Universität der Bundeswehr München Fakultät für Elektrotechnik Lehrstuhl für Hochspannungstechnik und Blitzforschung

# Teilentladungen in Isolierstoff-Hohlräumen bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung

Sven Zimmerath

Vorsitzender des Promotionsausschusses:	Prof. Dr.–Ing. K. Fastenmeier
1. Berichterstatter:	Prof. Dr.–Ing. K. Stimper
2. Berichterstatter:	Prof. Dr.–Ing. R. Marquardt

Tag der Prüfung: 12. März 2008

Mit der Promotion erlangter akademischer Grad: Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)

Neubiberg, den 18. März 2008

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Hochspannungstechnik und Blitzforschung des Institutes für Elektrische Energieversorgung der Universität der Bundeswehr München im Zeitraum von August 2003 bis Juli 2006.

Meinem Lehrer, Herrn Prof. Dr.–Ing. habil. K. Stimper, danke ich für die Aufnahme in sein Institut und die Möglichkeit, dieses interessante Thema zu bearbeiten. Von ihm erhielt ich viele richtungsweisende Ratschläge und

wertvolle Anregungen.

Herrn Prof. Dr.–Ing. R. Marquardt danke ich sehr herzlich für das Interesse an dieser Promotion und die Übernahme des Korreferats.

Ein herzliches Dankeschön an meine Kollegen Dr.-Ing. E.U. Landers, Dr.-Ing. U. Lang, Dr.-Ing. habil. F. Heidler und Dr.-Ing. W. Zischank für viele anregende Diskussionen, nützliche Ratschläge, für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die überaus gute Zusammenarbeit am Institut während der letzten Jahre.

Des Weiteren möchte ich Herrn Dr.-Ing. M. Kaufhold, Siemens AG Nürnberg, für die Bereitstellung der Sachmittel und die intensiven Diskussionen danken.

Außerdem danke ich allen weiteren Mitarbeitern aus dem Labor- und Werkstattbereich des Instituts, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

# Inhaltsverzeichnis

1	<b>Ein</b> ] 1.1	l <b>eitung</b> Motiva	<b>;</b> ation	<b>5</b> 5
	1.2	Gegen impuls	wärtiger Stand der Untersuchungen bei pulsförmiger und sförmiger Spannungsbeanspruchung	6
<b>2</b>	Phy	sikalis	che Grundlagen	10
	2.1	Entlac 2.1.1	lungen in Gasen	11
		2.1.2	genem und quasihomogenem Feldverlauf	12
			genem Feldverlauf	17
		2.1.3	Der Zündverzug bei transienter Spannungsbeanspruchung	19
	2.2	Teilen	tladungen in Feststoffen	22
		2.2.1	Bereitstellung von Ladungsträgern für Teilentladungen	
			in Isolierstoffen	23
		2.2.2	Beeinflussung der Gasentladung durch dielektrische	
			Grenzschichten	28
	2.3	Alteru	ngserscheinungen bei inneren Teilentladungen	30
3	Ver	suchste	echnik	34
	3.1	Verwe	ndete Anlagen	35
		3.1.1	Teilentladungsmessung bei 50 Hz Wechselspannung Teilentladungsmessung bei pulsförmiger Spannungsbe-	35
		0.1.4	rememoral and set presering of spannandsse	
		0.1.2	anspruchung	36
	3.2	Aufzei	anspruchung	$\frac{36}{42}$
	3.2	Aufzei 3.2.1	anspruchung	$\frac{36}{42}$
	3.2	Aufzei 3.2.1	anspruchung	36 42 42
	3.2	Aufzei 3.2.1 3.2.2	anspruchung	36 42 42
	3.2	Aufzei 3.2.1 3.2.2	anspruchung	36 42 42 42
	3.2 3.3	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei	anspruchung	36 42 42 42 44 47
	3.2 3.3	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei 3.3.1	anspruchung	<ul> <li>36</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>44</li> <li>47</li> <li>48</li> </ul>
	3.2 3.3	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei 3.3.1 3.3.2	anspruchung	36 42 42 44 47 48 55
4	3.2 3.3 Dar	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei 3.3.1 3.3.2 stellur	anspruchung	36 42 42 44 47 48 55 <b>57</b>
4	<ul> <li>3.2</li> <li>3.3</li> <li>Dar 4.1</li> </ul>	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei 3.3.1 3.3.2 stellur Statist	anspruchung	36 42 42 44 47 48 55 <b>57</b> 58
4	3.2 3.3 <b>Dar</b> 4.1	Aufzei 3.2.1 3.2.2 Verwei 3.3.1 3.3.2 stellur Statist 4.1.1	anspruchung	36 42 42 44 47 48 55 <b>57</b> 58 58 58

		4.1.2	Die Verteilungsfunktion		61
		4.1.3	Bereinigung von Stichproben		64
	4.2	Einflu	ssgrössen rechteckförmiger Puls- und Impulsspannung		65
		4.2.1	Teilentladungswahrscheinlichkeit und Teilentladungs-		
			verhalten bei Pulsspannung		65
		4.2.2	Einfluss von Teilentladungen auf die Teilentladungsein-		
			setzspannung		76
		4.2.3	Einfluss des Gleichanteils der Pulsspannung $U_{Offset}$		78
		4.2.4	Einfluss der Pulsbreite $t_P$		85
		4.2.5	Einfluss der Pulsfolgefrequenz $f_W$		90
		4.2.6	Einfluss der Anstiegszeit $t_R$	•	100
		4.2.7	Einfluss von Impulsen	•	103
	4.3	Vergle	ich des Teilentladungseinsatzes bei sinus- und rechteck-		
		förmig	ger Spannung	•	106
		4.3.1	Messergebnisse bei technischer Wechselspannung	•	106
		4.3.2	Messergebnisse bei rechteckförmiger Pulsspannung		108
		4.3.3	Interpretation der Ergebnisse	•	109
<b>5</b>	Zus	ammei	nfassung und Ausblick		110
	<b>-</b> -				
6	Ver	zeichni	is der Formelzeichen		116
7	Literaturverzeichnis 120				

# Kapitel 1

# Einleitung

# 1.1 Motivation

Die Teilentladungsmeßtechnik (TE- Meßtechnik) hat sich als zuverlässiges und aussagekräftiges Prüfmittel für Schwachstellen von Isolierungen in der Hochspannungstechnik durchgesetzt. Mit ihrer Hilfe lassen sich gezielt Ausfallwahrscheinlichkeiten voraussagen. Der wesentliche Vorteil dieser Messtechnik besteht in der schädigungsfreien Prüfung, da sehr kurzzeitig gemessen und nur eine kleine Anzahl von Teilentladungsimpulsen zugelassen wird.

Grundsätzlich existieren verschiedenste Möglichkeiten zur Detektion von Teilentladungen. Beispiele hierfür sind die optische, akustische und elektrische Erfassung, wobei sich letztere nach der DIN VDE 0434 durchgesetzt hat. Die Untersuchungen werden unter Beaufschlagung mit sinusförmiger Wechselspannung bei 50 Hz durchgeführt.

Mit Einzug der modernen Leistungselektronik in die Antriebstechnik und Energieversorgung veränderten sich die elektrischen Belastungen der Isoliersysteme.

Die typischen Ausgangsspannungen von Stromrichtern sind pulsweitenmodulierte Rechteckpulse. Die damit mögliche Variation von Frequenz und Amplitude der Ausgangsspannung erlaubt beispielsweise neue Regeldynamiken. Die dazu verwendeten Leistungshalbleiter arbeiten mit Taktfrequenzen bis 25 kHz. Typischerweise treten dabei Schaltzeiten herab bis zu 20 ns auf.

Beim Einsatz im Bereich der Antriebstechnik zeigte sich in der Praxis, dass die verwendeten Windungsisolierungen von Niederspannungsmaschinen für derartige Pulsspannungen speziell ausgelegt werden müssen. Die erzeugten Felder belasten offenbar die Isolierung stärker. Zudem erzeugen die grossen Steiheiten der Pulsspannungen starke Reflexionen auf dem beteiligten Ankoppelnetzwerk, was zu einer Erhöhung der Spannungsamplitude und zu mehr oder weniger starken Einschwingvorgängen führt [Kau93, Mel97].

Da sich die auftretenden Belastungen deutlich von denen der 50 Hz Sinusspannung unterscheiden, muss geklärt werden, inwiefern eine Anwendung der klassischen Teilentladungsmesstechnik möglich und sinnvoll ist.

Hierbei stellt sich die Frage, ob Prüfungen auf Teilentladungseinsatz mit Puls-

spannung durchgeführt werden müssen, oder ob ebenfalls mit der einfacher zu realisierenden sinusförmigen Wechselspannung aussagekräftige Ergebnisse ermittelt werden können. Daraus ergibt sich weiterführend die Problematik nach der Übertragbarkeit der gewonnenen Ergebnisse aus Teilentladungsmessungen bei technischen Wechselspannungen auf pulsförmige Belastungen.

An dieser Stelle soll der Begriff "Puls" verdeutlicht bzw. definiert werden. Ein Puls ist ein wiederkehrendes Ereignis, wogegen ein Impuls ein Einmalereignis darstellt. Da typischerweise die Ausgangsspannung eines Frequenzumrichters pulsweitenmoduliert und damit wiederkehrend geschaltet wird, spricht man demzufolge von Pulsen.

# 1.2 Gegenwärtiger Stand der Untersuchungen bei pulsförmiger und impulsförmiger Spannungsbeanspruchung

Für den Einsatz von Umrichtern in der Antriebstechnik fanden Grundlagenuntersuchungen zum elektrischen Verhalten von Isolieranordnungen bei verschiedenartigen, umrichtertypischen Spannungsformen statt. Dazu wurden grossteils spulenförmige Modellkörper, Twisten (verdrillte Lackdrähte) und Kunststofffolien verwendet. Der Grossteil der untersuchten Teilentladungen fand in Volumina statt, die nicht vollständig von Isolierstoff umhüllt waren. Im Folgenden werden die derzeitigen Erkenntnisse der jeweiligen Autoren zusammengefasst wiedergegeben. Zum Teil bestehen allerdings Widersprüche in den Aussagen der einzelnen Autoren.

#### Untersuchungen mit frequenzvariablen, sinusförmigen Spannungen

Am Anfang standen Untersuchungen zum Teilentladungsverhalten bei Beaufschlagung mit höherfrequenten Sinusspannungen. Vorteil dieser Technik ist die einfache Erzeugung der geforderten Spannung und die direkte Vergleichbarkeit zu den Erkenntnissen mit technischer Frequenzen. Sicher nachgewiesen wurde in diesen Untersuchungen, dass die Zeit bis zum Versagen eines Isolierstoffs frequenzabhängig ist [Ari00, Kau94, Poh01].

Darüber hinaus können folgende Aussagen zusammengefasst werden.

Die TE- Einsetzspannung sinkt zunächst und steigt anschliessend mit der Frequenz [Ple94, Wad03]. Nach Erreichen einer Grenzfrequenz fällt diese wieder (Untersuchung bis 4 MHz) [Hun90, Pfe99, Poh01]. Dieser Verlauf deutet auf einen Hochfrequenzdurchschlag hin [Gän53].

Die maximale TE- Intensität erhöht sich mit der Frequenz bei konstanter Amplitude [Ari00, Pfe91]. Des Weiteren steigt die Anzahl der Teilentladungsimpulse je Zeiteinheit mit der Frequenz [Ari00]. Für die Teilentladungsalterung des Isolierstoffs bis hin zum elektrischen Durchschlag des Isolierstoffs ist eine Sinusspannung belastender als eine Pulsspannung gleicher Amplitude und Frequenz, wenn der Tastgrad der Pulsspannung entsprechend klein gewählt wird [Har02].

#### Untersuchungen mit Stossspannungen

Bei Stossspannungsbeanspruchung wurde im Wesentlichen der Einfluss verschiedener Stirn- und Rückenhalbwertszeiten auf den Teilentladungseinsatz und das Durchschlagsverhalten untersucht. Darüber hinaus eignen sich oszillierende Stossspannungen Einschwingvorgänge nachzubilden, die auf elektrisch langen Leitungen mit ohmsch- induktivem Abschluss bei steilflankiger Spannungsbeanspruchung auftreten [Gue89, Kau94, Wer00].

Für Stossspannungsbeanspruchungen steigt die Durchschlags- und TE- Häufigkeit mit Erhöhung der Pulsspannungsamplitude. Dieses Verhalten kann für uni- und bipolare Spannungen festgestellt werden.

Im untersuchten Pulsfolgefrequenzbereich von 10 Hz bis 7 kHz konnte keine Frequenzabhängigkeit für die Anzahl an Spannungspulsen bis zum Durchschlag festgestellt werden. Dieser Effekt tritt vermutlich durch entstandene Oberflächenladungen auf [Kau94]. Darüber hinaus verringerte sich nach [Kau94] die TE- Einsetzspannung bei Verkürzen der Stirnzeit bzw. bei Verlängerung der Rückenhalbwertszeit. Bei Steigerung der Spannung bis hin zum Durchschlag wurde von [Wer00] ermittelt, dass eine Änderung der Stirnzeit keinen

signifikanten Einfluss auf die 50% Durchschlagsspannung von PE- Platten hat. Das Erhöhen der Spannungsamplitude führte zur Verlagerung der TE- Erscheinungen vom Rücken in die Stirn der Stossspannung [Kau94]. Wie [Gän53] zeigte, verkürzt sich durch die Zunahme der Amplitude die Entladeverzugszeit. Wird der Parameter Anstiegszeit bei konstanter Rückenhalbwertszeit vergrössert, erhöht sich die Zeit bis zum Versagen der Isolierung. Es verringert sich die Häufigkeit der TE- Ereignisse [Kau94]. Eine Vergrösserung der Rückenhalbwertszeit bei konstanter Anstiegszeit verkürzt die Zeit bis zum Versagen einer Isolierung.

Werden oszillierende Pulsspannungen verwendet, erhöht sich die Teilentladungshäufigkeit mit Erhöhung der Einschwingfrequenz und Verringerung der Dämpfung. Die Teilentladungen finden in den Extremwerten des Spannungsverlaufs statt [Kau94].

#### Untersuchungen mit Rechteckspannungen

Rechteckspannungen geben die betriebsrelevante Belastung für Isoliersysteme im Leistungsteil eines Frequenzumrichters in bester Näherung wieder. Zu den wesentlichsten Parametern einer Rechteckspannung gehören Amplitude, Anstiegzeit und Pulsfolgefrequenz. Deren Einfluss auf Teilentladungen wurde an isolierten Lackdrähten für die Anwendung in elektrischen Maschinen [Poh01] bzw. an PE- und PVC- Folien [Wad03] untersucht. Die Amplitude der TE- Einsetzspannung für monopolare Rechteckspannungen liegt über den Werten, die bei Beaufschlagung mit sinusförmiger Wechselspannung bei 50 Hz ermittelt wurden [Wad03].

Bei konstanter Isolierstoffdicke erhöht sich die TE- Häufigkeit mit Vergrösserung der Amplitude der Pulsspannung. Die Intensität der auftretenden Teilentladungen steigt linear mit der Spannungssteigerung [Poh01]. Die Lebensdauer der Isolierung nimmt mit steigender Spannung und Frequenz ab [Sto99a].

Die Anstiegszeit bestimmt die Lebensdauer eines Isoliersystems massgeblich [Cen00]. Höhere Lebensdauerwerte werden mit grösseren Anstiegszeiten erzielt [Poh01]. Dieser Effekt konnte in [Cen00, Leb98] nicht bestätigt werden.

Ein Einfluss der Frequenz der Pulsspannung auf das TE- Verhalten konnte nicht festgestellt werden [Poh01].

Wird die TE- Einsetzspannung einer Isolieranordnung überschritten, erhöht sich die TE- Häufigkeit nahezu linear mit Erhöhung der Pulsfrequenz und die Lebensdauer nimmt ab [Leb98, Poh01]. Die Einsetzspannung bleibt dabei praktisch unabhängig von der Pulsfrequenz.

#### Verwendete Messtechnik

Die konventionelle TE- Messung bei sinusförmiger Wechselspannung wird nach DIN VDE 0434 durchgeführt und zeichnet sich durch die einfache Bereitstellung der Prüfspannung aus. Die hochfrequenten TE- Ströme werden mittels Kondensator von der Spannungsquelle entkoppelt und fliessen ausschliesslich im Messkreis. Dort werden sie an einem Ankoppelvierpol in eine Spannung umgewandelt und zur Messwertaufnahme weitergeleitet.

Diese Messtechnik ist für die TE- Detektion bei pulsförmiger Beanspruchung nicht ohne weiteres anwendbar. Die steilen Flanken der Pulsspannungen erzeugen Verschiebungsströme, die dem eigentlichen Teilentladungssignal überlagert sind. Je nach Prüflingskapazität können die Verschiebungsströme um mehrere Grössenordnungen über den Teilentladungsströmen liegen. Für eine praktikable Detektion müssen diese periodischen Störer herausgefiltert werden.

Ein Nachweis von Teilentladungen ohne zusätzliche Massnahmen ist damit nicht möglich. Es kann darüber hinaus sinnvoll sein, von der elektrischen Auskopplung des TE- Signals abzugehen.

Für Sinusspannungen bis in den MHz- Bereich und Rechteckspannungen werden in [Bro99, Cen00] zur DIN VDE 0434 identische Aufbauten verwendet. Besonderheiten sind allerdings die Kompaktheit der Anordnung, sowie ein speziell entwickelter Koppelkondensator.

In [Mül00, Poh01] kommt ein Filtersystem zur TE- Detektion zum Einsatz, was die Möglichkeit eröffnet bei beliebigen Spannungsformen Teilentladungen zu detektieren. Mit diesem, auf UHF- Technik (Bandbreite 100- 150 MHz) basierendem Filter, soll eine scheinbare Ladung ab 5 pC feststellbar sein.

Ähnliche Wege werden in [Cam00, Sto92 - Sto00] beschritten. Ein kapazitiver Spannungsteiler mit hoher Bandbreite kombiniert mit einem Ultra- Breitbandfilter soll die TE- Impulse von den Pulsspannungen trennen. Hierzu existiert bereits ein fertiges Serienprodukt, das XTRAC von IRIS Power Engineering, welches allerdings speziell für den Einsatz an Niederspannungsmaschinen konzipiert ist.

Weitere Möglichkeiten bieten die optische Detektion [Kau94, Wad03] und die Erfassung mittels induktiver Auskopplung.

Untersuchungen zum TE- Verhalten von Isolierstoffen bei pulsförmigen Beanspruchungen gewinnen seit geraumer Zeit an Bedeutung. Ein besonderer Augenmerk liegt bis dato auf der Untersuchung des Teilentladungsverhaltens von Windungsisolierungen an Niederspannungsmaschinen. Dies gründet in den erhöhten Ausfallraten der elektrischen Maschinen seit der Einführung der Stromrichtertechnik in der Antriebstechnik. Nachweisbar treten erheblich erhöhte Feldbelastungen im Isoliersystem der elektrischen Maschine auf [Gue89, Kau94].

Diese elektrischen Belastungen wirken folglich ähnlich auf alle Isolierungen, die an der Potentialtrennung gepulster Ströme und Spannungen in Antriebssystemen beteiligt sind. Gegenstand dieser Arbeit ist es, die elektrischen Belastungen unter verschiedensten Einflussparametern an umrichtertypischen Isolieranordnungen zu ermitteln und in Relation zu Belastungen mit sinusförmiger Wechselspannung zu setzen.

Untersuchungen an derartigen Isolieranordnungen wurden bis dato noch nicht veröffentlicht. Arbeiten mit ähnlichen Aufgabenstellungen beschränken sich auf die Anwendung im Niederspannungsbereich. Problematisch gestaltet sich allerdings, dass diese Veröffentlichungen teilweise zueinander widersprüchliche Ergebnisse beinhalten.

Folgende Schwerpunkte wurden behandelt:

- Theoretische Grundlagen der Gasentladung
- Teilentladungen in Feststoffen und deren Schädigungswirkung
- Entwicklung und Aufbau einer Pulsspannungsquelle
- Entwicklung und Aufbau eines Teilentladungsmesssystems bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung
- Teilentladungsverhalten von umrichtertypischen Modellisolierungen bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung
- Vergleich des Teilentladungsverhaltens bei puls- und sinusförmiger Spannungsbeanspruchung

Die hierbei gewonnen Ergebnisse sollen zeigen, inwiefern Untersuchungen mit sinusförmiger Wechselspannung an Betriebsmitteln, die pulsförmig beansprucht werden, aussagekräftig sind und sich neue Grenzwerte für die elektrische Belastung von Isoliersystemen ergeben. Darüber hinaus ist ein Abgleich der Erkenntnisse mit früheren Arbeiten möglich.

# Kapitel 2 Physikalische Grundlagen

Wird eine Isolation zwischen zwei Elektroden mit unterschiedlichem Potential nur teilweise durch eine Entladung überbrückt, nennt man die Erscheinung Teilentladung. Diese Teilentladung kann in Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen stattfinden. Der signifikanteste Unterschied zum vollständigen Durchschlag besteht darin, dass die Isolation dabei zunächst im wesentlichen intakt bleibt. Langfristig gesehen schädigen Teilentladungen aber alle Isolierstoffe mit verschiedensten Auswirkungen. Ursachen für Teilentladungen sind lokale Feldstärkeüberhöhungen oder lokale Minderungen der elektrischen Festigkeit. In der Literatur unterscheidet man zwischen äusseren Teilentladungen bei inhomogenen Feldverläufen in Gasen, Oberflächenentladungen an Grenzflächen und inneren Teilentladungen an Fehlstellen innerhalb flüssiger oder fester Isolieranordnungen [Küc96].

Physikalische Grundlage für alle genannten Entladungsprozesse bildet die selbständige Gasentladung [Löb65, Mee78, Rät64]. In der Regel findet die innere Teilentladung in einem Entladungsraum statt, der von den spannungsführenden Metallelektroden ein- oder beidseitig getrennt ist. Man nennt sie deshalb auch ein- bzw. beidseitig dielektrisch behinderte Gasentladung [Har02]. Hierzu müssen neben den bekannten Emissions- bzw. Ionisationsprozessen zusätzliche bzw. modifizierte Sekundärprozesse berücksichtigt werden [Bru94, Hoo97].

Im Folgenden werden zunächst Entladungen in Gasen allgemein betrachtet und die wichtigsten Entlademechanismen für die spätere Anwendung auf innere Teilentladungen vorgestellt. Diese Betrachtungen gelten generell und werden an metallischen Elektroden mit stationären bzw. quasistationären Feldern erläutert.

Da eine Randbedingung der hier vorliegenden Arbeit die Untersuchung mit pulsförmigen Spannungen ist, wird auf die Besonderheiten bei transienten Feldbelastungen eingegangen. Im Anschluss daran werden die Modifizierungen der Gasentladungen durch dielektrische Grenzschichten, insbesondere die Bereitstellung der benötigten Ladungsträger, sowie die Auswirkungen der Gasentladung auf die dielektrischen Oberflächen näher betrachtet.

# 2.1 Entladungen in Gasen

Gase eignen sich gut als Isolierstoffe, da sie bei niedrigen Feldstärken nahezu keinen Strom leiten. Wird die Spannung zwischen den Elektroden allerdings über eine bestimmte Grenze hinaus gesteigert, treten charakteristische Entladungserscheinungen auf. Diese äussern sich in einem nichtlinearen Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und gemessenem Strom.

Zunächst verhält sich der Strom proportional zur Spannung, man spricht vom "ohmschen Bereich" der Gasentladungskennlinie (Abbildung 2.1). Die vorhandenen freien Ladungsträger sind durch eine gewisse Grundionisation (Photoionisation durch Höhenstrahlung bzw. natürliche radioaktive Strahlung) vorhanden oder entstehen durch Stossprozesse aufgrund thermischer Bewegung der Gasatome bzw. der Gasmoleküle [Küp73]. Es entstehen keine zusätzlichen Ladungsträger durch den Stromfluss im Gas selbst. Somit ergibt sich ein Gleichgewicht zwischen generierten und abtransportierenten Ladungsträgern. Eine derartige Entladung wird als *unselbständige Gasentladung* bezeichnet.

Mit wachsender Spannung erreicht der Strom einen Grenzwert, den Sättigungsstrom. Wird die Spannung darüber hinaus gesteigert, können Ladungsträger über die Gasstrecke soviel Energie aufnehmen, dass sie selbst neue Ladungsträger durch Stossionisation erzeugen. Die Entladung unterhält sich selbst – die so genannte *selbständige Gasentladung* [Küc96].



Abbildung 2.1: Gasentladungskennlinie nach [Küc96]

Die selbständige Gasentladung kann in Abhängigkeit des Verlaufs des elektrischen Grundfeldes  $E_G$ , des sogenannten Laplace- Feldes, und des Einflusses von Raum- bzw. Oberflächenladungen verschiedene Entladungsformen annehmen. Diese werden im folgenden vorgestellt.

## 2.1.1 Durchschlagmechanismen für Anordnungen mit homogenem und quasihomogenem Feldverlauf

Kann in einem homogenen Feld ein Startelektron genügend Energie aufnehmen, bildet sich eine Elektronenlawine (Abbildung 2.2: (1) Lawinenschwanz, (2) Lawinenkopf) aus.



Abbildung 2.2: Entladungslawine und Feldverlauf im Homogenfeld nach [Bey89]

Dabei führt das Erreichen der Zündbedingungen unmittelbar zum Durchschlag der Gasstrecke. Vorentladungen treten nicht auf. Im folgenden werden der *Generationendurchschlag* [Tow10] und der *Streamerdurchschlag* [Mee40, Rät64] als relevanteste Mechanismen beschrieben. In der Literatur findet man für den Generationendurchschlag zudem die Bezeichnungen Lawinen- bzw. Townsenddurchschlag. Der Streamerdurchschlag wird auch als Kanaldurchschlag bezeichnet.

Der Übergang zwischen beiden Entladungsformen liegt nach [Bey86] für Luft mit Normtemperatur und geringer Überspannung bei  $p \cdot s \leq 1, 3bar \cdot cm$ , wobei p den Druck und s die Schlagweite darstellt. Die ebenfalls in der Literatur beschriebene Leaderentladung hat aufgrund der geringen Schlagweiten der verwendeten Anordnungen keine Relevanz und soll nicht näher betrachtet werden.

#### 2.1.1.1 Generationendurchschlag

Betrachtet wird ein Startelektron in einem homogenen Grundfeld  $E_G$ . Steht eine entsprechend grosse Wegstrecke x zur Verfügung, akkumuliert das Elektron schliesslich die erforderliche Energie  $W_I$  um ein Molekül stufenweise bzw. vollständig zu ionisieren.

$$x = \frac{W_I}{q_e \cdot E} \tag{2.1}$$

Aufgrund des Impuls- und Energieerhaltungssatzes verliert das Elementarteilchen nun bei einem unelastischen Stoss mit einem schwereren Gasmolekül nahezu seine gesamte Energie. Die dabei entstehenden Elektronen nehmen im elektrischen Feld Energie auf und ionisieren selbst Moleküle. Bei gegebener mittlerer freier Weglänge führt das bei hinreichender Feldstärke zu einem lawinenartigen Anwachsen der Elektronen (Abbildung 2.3).



Abbildung 2.3: Physikalisches Modell zum Lawinendurchschlag nach [Küc96]

Die lokale Konzentration der Elektronen soll zunächst einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Grundfeld  $E_G$  haben, was nach [Bey86, Küc96] nur der Fall ist, wenn die Anzahl der Elektronen in der Raumladung den kritischen Wert von  $N_{cr} = 10^6$  unterschreitet. Wird der kritische Wert überschritten, kann die Feldverzerrung nicht mehr vernachlässigt werden und der Entlademechanismus ändert sich. Es akkumulieren sich im Kopf der Lawine (Abbildung 2.2: (2)) an der Stelle x

$$N_e(x) = N_{e0} \cdot e^{\int_0^x (\alpha - \eta) dx} = N_{e0} \cdot e^{(\alpha - \eta) \cdot x} = N_{e0} \cdot e^{(\alpha_{eff}) \cdot x}$$
(2.2)

Elektronen. Hierbei ist  $N_{e0}$  die Anzahl der zur Verfügung stehenden Startelektronen an der Stelle x= 0.  $\alpha$  ist der feldstärkeabhängige erste Townsendsche Stossionisierungskoeffizient und bestimmt die Anzahl der Ionisationsvorgänge je Längeneinheit, die von einem Elektron ausgelöst werden. Der Anlagerungskoeffizient  $\eta$  gibt die relative Abnahme der eine Längeneinheit durchlaufende Elektronen an und wird unter anderem von der Elektronenaffinität des beteiligten Gases und der Geschwindigkeit der Elektronen bestimmt.

Beide Parameter,  $\alpha$  und  $\eta$ , die von Gasdichte und Feldstärke abhängen, können zum effektiven Stossionisierungskoeffizienten  $\alpha_{eff}$  zusammengefasst werden.

$$\alpha_{eff} = \alpha - \eta \tag{2.3}$$

Somit ist direkt zu erkennen, ob Generation oder Rekombination überwiegt. Die bei dem Ionisierungsprozess entstehenden positiven Ionen

$$N_{+}(x) = \int_{0}^{x} (\alpha \cdot N_{e}(x)) dx = \frac{\alpha}{\alpha_{eff}} \cdot N_{e0} \cdot [e^{\alpha_{eff} \cdot x} - 1]$$
(2.4)

bleiben aufgrund ihrer Trägheit zurück und werden ihrerseits Richtung Kathode beschleunigt. Dort können sie nach dem  $\gamma$ - Ionisierungsprozess neue Sekundärelektronen auslösen.

Des Weiteren lösen Photonen Sekundärelektronen aus der Kathode heraus. Photonen entstehen bei der Rekombination von Ionen oder bei der Rückbildung angeregter Moleküle. Wahrscheinlich erscheint auch der Fall, dass hochenergetische Strahlungsquanten im Gasraum Atome ionisieren und dabei Elektronen abgegeben werden. Insgesamt werden

$$N_{eSek} = \gamma \cdot N_+ \tag{2.5}$$

Sekundärelektronen aus der Kathode emittiert. Hierbei ist  $\gamma$  der 2. Townsendsche Ionisationskoeffizient. Dieser Rückwirkungskoeffizient erfasst die Wirkung von Ionen und Photonen zur Bereitstellung von Sekundärelektronen aus der Kathodenoberfläche. Mit (2.4) erhält man

$$N_{eSek}(s) = \gamma \cdot \frac{\alpha}{\alpha_{eff}} \cdot N_{e0}[e^{\alpha_{eff} \cdot s} - 1]$$
(2.6)

die Anzahl der Elektronen für eine neue Lawine, wenn die erste Lawine die Schlagweite s durchlaufen hat. Wie leicht zu erkennen ist, wird die gesamte Gasstrecke zwischen den Elektroden und die Kathodenfläche selbst in den Entwicklungsprozess der Entladung eingebunden. Mit der Bedingung

$$N_{eSek} \ge N_{e0} \ge 1 \tag{2.7}$$

wird die Folgelawine stärker sein als die erste und der Lawinenprozess aufrecht erhalten. Die neu generierten Startelektronen erhalten dann die Entladungsentwicklung aufrecht und führen zu einer stufenartigen Stromentwicklung des Lawinenmechanismusses. Offensichtlich werden mehrere Lawinen bis zum Durchschlag benötigt. Aus (2.6) und (2.7) folgt das Kriterium  $K_G$  für den Lawinendurchschlag nach Townsend [Tow10].

$$\alpha_{eff} \cdot s = K_G \ge \ln \left[ \frac{\alpha_{eff}}{\alpha \cdot \gamma} + 1 \right]$$
(2.8)

Diese Zündbedingung wird bei Erhöhung der Feldstärke im Homogenfeld stets zuerst erfüllt. Wird die Spannung darüber hinaus gesteigert, setzt der Streamerdurchschlag ein.

Da der Ionisierungskoeffizient  $\alpha$  stark feldstärkeabkängig ist, vergrössert er sich mit Erhöhung der Spannung. Folglich wird eine grössere Anzahl Elektronen zur Verfügung gestellt, welche die kritische Zahl von  $N_{cr} = 10^6$  Elektronen schliesslich überschreitet. Auf diesen Mechanismus wird in 2.1.1.2 eingegangen.

Nach [Bey86] tritt der Lawinendurchschlag in zwei Varianten auf. Dabei ist die Sekundärelektronenemission der bestimmende Parameter. Überwiegt die Generation der Elektronen durch den  $\gamma$ - Prozess benötigt der Entlademechanismus eine sehr lange Aufbauzeit. Dieser tritt im wesentlichen bei metallischen Oberflächen auf, bei denen die Feldschwächung vernachlässigt werden kann. Werden Elektroden mit dielektrischen Grenzschichten verwendet, wird der Durchschlag stark durch die Photoemission beeinflusst. In diesem Fall sind die Aufbauzeiten wesentlich geringer.

#### 2.1.1.2 Streamerdurchschlag

Anders als beim Generationendurchschlag genügt bei dieser Art der Entladung bereits eine Lawine zur vollständigen Überbrückung der Gasstrecke. Dabei wächst die ausgelöste Lawine auf  $10^6$  bis  $10^8$  Elektronen an. Somit ist eine Verzerrung des Laplace- Feldes  $E_G$  nicht mehr zu vernachlässigen [Rät64, Küc96]. Ausgehend vom Lawinenbildungsprozess des Generationendurchschlags stehen an der Stelle x ebenfalls

$$N_e(x) = N_{e0} \cdot e^{\int_0^x (\alpha_{eff}) dx} = N_{e0} \cdot e^{(\alpha_{eff}) \cdot x}$$

Elektronen zur Verfügung. Ist das von aussen angelegte Laplacefeld  $E_G$  so stark, dass die kritische Anzahl von Elektronen  $N_{cr} = 10^6..10^8$  überschritten wird, kommt es zu einer starken Feldanhebung vor und hinter dem Lawinenkopf. Das Grundfeld  $E_G$  und das Raumladungsfeld  $E_L$ , auch Poisson- Feld genannt, überlagern sich lokal positiv, was zu einer erhöhten Ionisation und Vorwachsgeschwindigkeit führt. Des Weiteren führt die Feldanhebung zu einer verstärkten Emission von Photonen. Die unterstützende Photoemission stellt zusätzlich Sekundärelektronen bereit. Der damit enstehende Kanal, ein sogenannter Streamer, wächst gleichzeitig in Richtung Kathode und Anode vor. Man spricht auch von einem anoden- bzw. kathodengerichteten Streamer [Küc96, Har02]. Diese besitzen allerdings unterschiedliche Vorwachsgeschwindigkeiten, da der Lawinenschwanz vermehrt die Sekundärelektronen anlagert. Der Streamerdurchschlag wird entscheidend von der Photoemission beeinflusst, da Teilbereiche der Gasstrecke gleichzeitig überbrückt werden [Hoo97]. Der Entladungsaufbau vollzieht sich somit deutlich schneller als beim Generationendurchschlag. Breitet sich die Lawine bis zu den Elektroden aus, wird der Entladungskanal thermoionisiert und ein Plasmakanal entsteht.

Nach [Rät<br/>64, Bey86] kann die Durchschlagsbedingung, die kritische Elektronenzah<br/>l $N_{cr}$ im Kopf der Lawine, zu

$$N_{cr} = e^{\int_0^{x_{cr}} \alpha_{eff} \cdot dx} = e^{K_{St}} = 10^6 \dots 10^8$$
(2.9)

bestimmt werden. Mit  $N_{cr} = 10^6..10^8$  ergibt sich analog zur Zündbedingung nach Townsend das Streamerkriterium  $K_{St} = 13, 8..18, 4$ . Dabei ist die kritische Länge  $x_{cr}$  die Schlagweite, bei der die kritische Elektronenzahl  $N_{cr}$  erreicht wird.

Gelangt der Lawinenkopf zur Anode ohne das Streamerkriterium zu erfüllen, werden die Elektronen von der Elektrode aufgenommen. Liegt dabei das Townsendkriterium vor, wird ein Lawinendurchschlag eingeleitet. Folgende Parameter erhöhen die Wahrscheinlichkeit zur Erfüllung der Streamer- Zündbedingung [Bro98, Dev84, Mor93]:

- Grosse Schlagweite s
- Grosse Werte für  $\alpha$  und kleine Werte für  $\gamma$
- Hohe Überspannung durch geringe Anstiegszeit der Prüfspannung bzw. hohe Zündverzugszeit
- Geringe Sekundärelektronenemission aus der Kathode

# 2.1.2 Durchschlagmechanismen für Anordnungen mit inhomogenem Feldverlauf

Im Gegensatz zum Homogenfeld wird die Zündbedingung für eine Entladungserscheinung bei inhomogenem Feldverlauf zunächst nur in einem kleinen Bereich hoher Feldstärke erreicht. Entladungen können nur in diesem Bereich auftreten und nicht die gesamte Schlagweite überbrücken. Es können sich stabile Vorentladungen ausbilden.

Erst bei weiterer Spannungssteigerung kommt es zum vollständigen Ausbilden eines Entladungskanals. Das hochbelastete Volumen befindet sich direkt vor stark gekrümmten Elektroden.

Da für diese Arbeit Schlagweiten bis in den mm- Bereich relevant sind, sind die auftretenden Erscheinungen erneut mit dem *Generationen-* und *Streamerdurchschlag* beschreibbar. Die für grössere Schlagweiten einsetzende Leaderentladung soll hier nicht betrachtet werden.

Für Schlagweiten hinauf bis etwa 1 mm wurde in [Yah98] untersucht, dass die erste Lawine nicht unmittelbar zum Durchschlag führt, eine Entladung nach dem Townsend- Kriterium also wahrscheinlich ist. Nachgewiesen ist [Rät64, Bey86], dass für Schlagweiten oberhalb von 1mm ein Streamerdurchschlag stattfindet.

Im inhomogenen Feld ist der Entladungsaufbau grundsätzlich vergleichbar mit dem im homogenen Feld. Entscheidender Unterschied ist die Raumladungsbildung im Bereich der lokal erhöhten Feldbelastung. Die damit verbundenen Wechselwirkungen von Raumladungsfeld und -aufbau sowie die unterschiedlichen Beweglichkeiten der beteiligten Ladungsträger führen zu einem ausgeprägten Polaritätseffekt. Dieser soll anhand einer Spitze- Platte- Anordnung kurz skizziert werden.

### 2.1.2.1 Positive Spitze

Da nur unmittelbar im Nahbereich der Anode günstige Ionisierungsbedingungen herrschen ( $\alpha_{eff} > 0$ ), muss ein im Feldraum erzeugtes Startelektron dort zur Verfügung stehen, um eine Primärlawine auszulösen. Diese wächst in Richtung Anode und somit in einen Bereich mit zunehmender Feldstärke.

Da die Elektronen über die Anode abgeleitet werden, bleibt eine positive Raumladung unmittelbar vor der Anode zurück, die das Feld homogenisiert. Gleichzeitig wächst aber die Feldbelastung der restlichen Gasstrecke, da sich die Anode scheinbar in den Raum hinein schiebt.

Die damit verbundene Verlagerung des Ionisationsbereiches in Richtung Kathode führt schliesslich zum Erreichen der Zündbedingung im restlichen Gasraum und damit zum vollständigen Durchschlag.



Abbildung 2.4: Ladungsträgerbewegung und Feldverteilung mit (1) und ohne (2) Berücksichtigung der Raumladung nach [Bey86]

#### 2.1.2.2 Negative Spitze

Zur Verfügung stehende Startelektronen müssen unmittelbar an der Spitze der Kathode oder von der Kathode selbst generiert werden. Diese können z.B. durch Photoionisation und Feldemisson [Bey86] erzeugt werden. Allerdings schliesst [Bro98] aufgrund der meist geringen Feldstärken letzteres aus.

Wird die kritische Elektronenzahl im Nahbereich überschritten, werden vermehrt Photonen gebildet und die Vorentladung setzt ein. Die Startelektronen wandern in einen Bereich mit abnehmender Feldstärke und negativem effektiven Ionisierungskoeffizienten.

Im feldschwachen Gebiet werden sie an Moleküle angelagert und es entsteht eine negative Raumladung. Die Feldstärke unmittelbar vor der Kathode wird durch die zurückgebliebenen positiven Ionen stossionisierter Moleküle erhöht und durch die räumliche Ausweitung im weiteren Gasraum homogenisiert. Damit stellt sich eine stabile Vorentladung ein, der Durchschlag wird hinausgezögert und findet erst nach einer deutlichen Spannungssteigerung statt.



Abbildung 2.5: Ladungsträgerbewegung und Feldverteilung mit (1) und ohne (2) Berücksichtigung der Raumladung nach [Bey86]

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich der grundsätzliche Zusammenhang

$$U_{D(positiveSpitze)} < U_{D(negativeSpitze)}.$$
 (2.10)

Arbeiten von [Sti90, Har02] zeigen allerdings, dass sich dieser "Polaritätseffekt" bei sehr kleinen Abständen in der Nähe des Paschenminimums umkehrt.

Derzeit ist nachgewiesen, dass die Entladung in Hohlräumen mit dem Streamer- bzw. Kanaldurchschlag vergleichbar ist [Bar87, Gut95, Küc96, Nov00]. Fortschreitende Teilentladungen können jedoch die Leitfähigkeit der Fehlstellenoberflächen erhöhen, sodass der Entladungsmechanismus in den Generationendurchschlag umschlägt [Küc96].

## 2.1.3 Der Zündverzug bei transienter Spannungsbeanspruchung

Das in dieser Arbeit zu untersuchende Verhalten von Teilentladungen in Isolierungen unter pulsförmiger Spannungsbeanspruchung ist eng verbunden mit dem Verzug einer Entladungserscheinung. Im Allgemeinen wird von statischen Durchschlagsspannungen ausgegangen, die für langsame Spannungsänderungen gelten.



Abbildung 2.6: Zündverzug bei transienter Spannungsbeanspruchung Steigt die Spannung sehr schnell an, kann ein Durchschlag trotz Überschreiten

der statischen Ansprechspannung  $U_0$  verzögert eintreten (Abbildung 2.6). Man spricht vom Zündverzug [Bey86]. Dieser Zündverzug  $t_D$  setzt sich aus

- Verzug  $t_0$  bis zum Erreichen der statischen Ansprechspannung  $U_0$
- Statistischer Streuzeit  $t_S$
- Lawinenaufbauzeit  $t_A$
- Funkenaufbauzeit  $t_F$

zusammen.

$$t_D = t_0 + t_S + t_A + t_F \tag{2.11}$$

Die Summe aus statistischer Streuzeit  $t_S$  und Lawinenaufbauzeit  $t_A$  wird Entladeverzugszeit  $t_{EV}$  genannt [Küc96].

Bedingt durch die zeitliche Versetzung des Durchschlags, weicht die gemessene Durchschlagspannung von der statischen ab. Die relative Überspannung bzw. der Stossfaktor beträgt

$$u = \frac{U_{max}}{U_0}.$$
 (2.12)

Die statistische Streuzeit  $t_S$  ist die Zeitspanne vom Erreichen der Zündbedingungen bis zum Bereitstellen eines lawinenwirksamen Startelektrons.

Da alle Mechanismen zur Elektronenerzeugung Wahrscheinlichkeiten unterliegen, differiert diese Zeitspanne. Die statistische Streuzeit  $t_S$  nimmt mit der Zunahme des beanspruchten Gasvolumens ab (Volumen- Zeit- Gesetz).

Für Schlagweiten über 1 mm in Luft wird der Zündverzug  $t_D$  mit einigen 10 ns angegeben [Küc96]. Durch Verunreinigungen der Elektrodenoberfläche bzw. Erhöhen der Überspannung kann dieser signifikant verringert werden. Steht das Elektron zur Verfügung bedarf es noch der Zeit zum Aufbau der Lawine  $t_A$  und zur Bildung des Durchschlagkanals  $t_F$ . Sie variieren unter anderem stark in Abhängigkeit von Gasart und Elektrodengeometrie, sowie vom Durchschlagsmechanismus. Nach [Kin58] kann die Lawinenaufbauzeit  $t_A$  für einen Streamerdurchschlag nach dem Spannungs- Zeit- Flächenkriterium zu

$$\int_{t_0+t_S}^{t_0+t_S+t_A} [u(t) - U_0] dt = A \cdot s = F = const.$$
 (2.13)

bestimmt werden. A ist die bezogene Aufbaufläche und s die Schlagweite der Elektrodenanordnung. Die Spannungs- Zeit- Fläche F stellt für eine bestimmte Anordnung eine Konstante dar.

Für Elektrodenanordnungen mit homogenem Feldverlauf ergibt sich die Spannungs- Zeit- Fläche F nach [Kin58] zu

$$F \approx U_0 \cdot 10ns \tag{2.14}$$

und für inhomogene Feldverläufe zu

$$F \approx U_0 \cdot (0, 1...1 \mu s).$$
 (2.15)

Die Funkenaufbauzeit  $t_F$  lässt sich nach [Bey86] mit Hilfe des Funkengesetzes nach Toepler abschätzen. Sie beträgt

$$t_F = 4, 4 \cdot \frac{k_T}{E_D},\tag{2.16}$$

wobe<br/>i $E_D$  die mittlere Feldstärke in  $\frac{V}{m}$ zwischen den Elektro<br/>den beim Funkeneinsatz darstellt.

Somit ergeben sich mit einer Toeplerkonstante  $k_T = 5..6 \cdot 10^{-3} \frac{Vs}{m}$  für Luft und Schlagweiten bis 5 mm Aufbauzeiten im ns Bereich. Die Summe aus Lawinenaufbauzeit  $t_A$  und Funkenaufbauzeit  $t_F$  nimmt demnach Werte von einigen ns bis ms an.

In Summe ergibt sich so eine Verzögerung vom Erreichen der Zündbedingungen bis zum Zusammenbruch der Spannung von wenigen ns bis ms. Da bei Teilentladungen in Isolierstoffen zusätzliche Effekte auftreten, kann der Entladeverzug Werte bis in den Stunden Bereich annehmen. Dazu wird auf den Abschnitt 2.2 verwiesen.

# 2.2 Teilentladungen in Feststoffen

Teilentladungen in festen Isolierstoffen können als besondere Form der Gasentladung betrachtet werden [Bru94]. Nach [Bar87, Gut95, Nov00] wurden neben der Streamer- und Generationenentladung auch Glimmentladungen in Hohlräumen bzw. Einschlüssen, im Weiteren als Fehlstelle bezeichnet, identifiziert. Die Glimmentladung ist eine raumladungsbeschwerte Entladung und stellt oftmals die Vorstufe zum Streamerdurchschlag dar.



Abbildung 2.7: Modellabbildung zur inneren Teilentladung in Feststoffen

Der wesentlichste Unterschied der inneren Teilentladungen zu anderen Entladungserscheinungen besteht darin, dass die Entladungsstrecke ein- oder beidseitig durch ein Dielektrikum von den spannungsführenden Elektroden abgegrenzt wird (Abbildung 2.7).

Die beteiligten Ladungsträger werden durch das Dielektrikum behindert, über die Elektroden abzufliessen. Man nennt deshalb innere Teilentladungen auch "dielektrisch behinderte" Entladungen.

Somit bestehen für den Entladungsaufbau zusätzliche Randbedingungen im Vergleich zu den Gasentladungen aus Abschnitt 2.1. In [Mor93] wird gezeigt, dass dielektrischen Grenzschichten den Durchschlagmechanismus wesentlich mitbestimmen. Die bestimmenden Mechanismen werden im Folgenden erläutert. Dabei wird die Bereitstellung von lawinenfähigen Startelektronen und Sekundärelektronen besonders behandelt.

In der Literatur wird die innere Teilentladung mit konzentrierten Elementen nach [Gem32] vereinfacht dargestellt. Das Ersatzschaltbild ist in Abbildung 2.8 dargestellt und erlaubt die wesentlichsten Aussagen. Hierbei ist der Bereich (1) die Fehlstelle, in der die Teilentladung stattfindet, und der Bereich (2) ist das Restdielektrikum. Entwickelt man daraus das Ersatzschaltbild, stellen C die Kapazität des Restdielektrikums,  $C_1$  die Kapazität der Fehlstelle, die mit einer Funkenstrecke FS entladen werden kann und  $C_2$  die Kapazität des mit der Fehlstelle in Reihe liegende Restdielektrikum dar. Der Einfluss der Leitfähigkeiten von Dielektrikum und Fehlstellenfüllung wird vernachlässigt. Der prinzipielle Verlauf von Teilentladungen ist mit diesem Ersatzschaltbild



Abbildung 2.8: TE Ersatzschaltbild

zwar nachvollziehbar, eine befriedigende physikalische Analyse ist aber nicht möglich. Insbesondere kann keine Aussage zur Verteilung der Raum- und Oberflächenladungen in der Fehlstelle gemacht werden. Des Weiteren besteht die Schwierigkeit, dass weder Hohlraumkapazität noch die Kapazität des Restdielektrikums bekannt sind.

Der Versuch, die real ablaufenden physikalischen Vorgänge mathematisch zu beschreiben, wird in [Ped89, Ped91, Ped95a, Ped95b] dargestellt. Damit kann ein Zusammenhang zwischen den Prozessen in der Fehlstelle und extern messbarem TE- Verhalten angegeben werden. Hierbei besteht ebenfalls das Problem, die zeitliche und örtliche Verteilung der Raum- und Oberflächenladungen zu kennen. Eine praktische Anwendung ist deshalb in den wenigsten Fällen umsetzbar.

## 2.2.1 Bereitstellung von Ladungsträgern für Teilentladungen in Isolierstoffen

Die bereits angesprochenen Entlademechanismen laufen nur ab, wenn eine hinreichende Anzahl von Startelektronen zur Verfügung steht. Diese können sowohl aus dem Gas selbst, als auch aus der das Gas umgebenden Materie durch Ionisationsvorgänge herausgelöst werden. Neben dem Vorhandensein von Startelektronen ist zur Ausbildung einer Lawine die Emission von Sekundärelektronen von Bedeutung. Im folgenden werden die relevanten Mechanismen vorgestellt [Bey89, Bru91] und einige Teilaspekte näher betrachtet.

- 1. Elektronenauslösung durch Stossionisation
- 2. Photoemission

- 3. Elektronenablösung bei Annäherung von langlebigen metastabilen Molekülen und Atomen
- 4. Thermische Emission
- 5. Feldemission von Elektronen aus Oberflächen
- 6. Weitere Mechanismen

In Abhängigkeit den vorherrschenden Bedingungen (Fehlstellenoberfläche, Materialeigenschaften des Isoliermaterials) dominieren einige der oben genannten Mechanismen, wobei andere weniger Einfluss haben [Gut95].

#### 2.2.1.1 Elektronenauslösung durch Stossionisation

Die Stossionisation von neutralen Atomen und Gasmolekülen kann durch Elektronen ( $\alpha$ - Prozess) und Ionen ( $\gamma$ - Prozess) ausgelöst werden. Dabei stellt der Elektronenstoss den wichtigsten Stossionisierungsprozess im Gas dar [Bey89]. Sind Elektronen im Gas frei beweglich, driften sie auf Grund des elektrischen Feldes E in Richtung der Anode. Dabei durchlaufen sie zunächst ohne Zusammenstoss ihre mittlere freie Weglänge  $\lambda$  und können die Energie W aufnehmen

$$W = q_e \cdot E \cdot \frac{\lambda}{\delta}.$$
 (2.17)

Dabei gibt der Korrekturfaktor  $\delta$  das Verhältnis zwischen abgegebener und aufgenommener Energie an. Ist die kinetische Energie des Elektrons entsprechend gross, wird beim unelastischen Stoss Energie übertragen und metastabile Anregungsvorgänge oder Ionisationsprozesse eingeleitet.

Die Sekundärelektronenerzeugung durch Einfall von Elektronen auf Oberflächen wurde in [Kol54] näher untersucht. Dabei ergaben sich für Metalle und Isolatoren ähnliche Energieverteilungen der Sekundärelektronen. Die Lage der Maxima bei 2 eV stimmte für beide Materialien überein, der Abfall zu höheren Energien ist bei Metallen allerdings weniger stark ausgeprägt.

Positive Ionen werden aufgrund ihrer Ladung in Richtung Kathode beschleunigt. Beim Aufprall auf die Elektrode bzw. die kathodenseitige dielektrische Grenzschicht der Fehlstelle wird zunächst das Gasion neutralisiert und dessen Ionisierungsenergie  $W_I$  frei. Ist die Summe aus kinetischer Energie und Ionisierungsenergie  $W_I$  entsprechend gross, werden 2 Elektronen ausgelöst, wobei eines als Sekundärelektron zur Verfügung steht.

$$\frac{1}{2} \cdot m_{Ion} \cdot v^2 + W_I \ge 2W_a \tag{2.18}$$

Durch die geringen geometrischen Abmessungen von Fehlstellen im Isolierstoff ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ion mit der Feststoffoberfläche wechselwirkt grösser als die Energieabgabe an ein Gasmolekül. Damit kommt der Elektronenemission aus dem Feststoff nach dem  $\gamma$ - Prozess eine gesteigerte Bedeutung zu [Kur93, Nie93].

#### 2.2.1.2 Photoemission

Die Photoemision hat für die Sekundärelektronengeneration in Hohlräumen, die vollständig von einem Dielektrikum umschlossen werden, dominierende Bedeutung [Kur93]. Dabei wird einem Atom, Molekül oder Ion Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung zugeführt. Die Emission findet statt, wenn

$$W_I \le h \cdot f \tag{2.19}$$

ist, wobei h das Planksche Wirkungsquantum und f die Frequenz eines Photons ist. Geht man von der Ionisierungsenergie  $W_I = 12,1$  eV für ein Sauerstoffmolekül  $O_2$  aus, ergeben sich Wellenlängen unter 100 nm, was Licht im UV- Bereich entspricht [Mes02].

Untersuchungen von [Cos39, Schw40] zeigten, dass mehr als 90 % des ausgesendeten UV- Lichts einer unselbständigen Entladung Wellenlängen von  $\lambda \leq 100nm$  besitzen. Damit werden die erforderlichen Ionisierungs- bzw. Austrittsarbeiten sowohl für die Gasphase als auch für das umgebende Dielektrikum erreicht.

Soll ein Elektron aus einer Feststoffoberfläche herausgelöst werden, muss ihm eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit gegeben werden. Dann muss

$$\frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2 \le h \cdot f - W_a \tag{2.20}$$

gelten, wobei  $W_a$  die Austrittsarbeit eines Elektrons aus dem Feststoffmaterial ist. Nach [Bey89] genügt für die Emission aus Feststoffen eine wesentlich langwelligere Strahlung, da die Austrittsarbeiten  $W_a$  im Bereich von 4 - 5 eV liegen.

Für die Bereitstellung von Startelektronen wird in [Bey86] die Photoionisierung durch natürliche energiereiche Strahlung (kosmische und radioaktive Strahlung) angeführt. Dieser Mechanismus hat nach [Bru91, Nov95] für innere Teilentladungen keine Relevanz, da die Intensität sehr gering und das Volumen sehr klein ist. Im Wesentlichen wird ihr nur eine feldunterstützende Funktion, insbesondere an Metallelektroden, beigemessen.

#### 2.2.1.3 Elektronenablösung bei Annäherung von langlebigen metastabilen Molekülen und Atomen

Metastabile Moleküle bzw. Atome sind neutrale Teilchen, nehmen aber nicht das niedrigste Energieniveau ein. Eine Abgabe der Anregungsenergie  $W_A$  ist in Form von Strahlung oder bei Stössen in einigen Fällen nicht sofort möglich. Im Allgemeinen kann von einer Lebensdauer von einigen 10 ns ausgegangen werden, es treten aber auch Werte bis in den Sekundenbereich auf.

Wird die Energie in Form von Lichtquanten abgegeben, können Wellenlängen bis unter 100 nm auftreten, was für die Photoionisation ausreichend ist.

#### 2.2.1.4 Thermische Emission

Bei genügend hohen Temperaturen können Elektronen aus Feststoffen und Gasmolekülen freigesetzt werden. Nennenswerte Thermoionisation von Gasmolekülen benötigt Temperaturen von vielen 1000K im Gasraum und kann für innere Teilentladungen ausgeschlossen werden.

Wird einem Feststoff genügend thermische Energie zugeführt, treten Elektronen aus dem Leitungsband durch die Potentialbarriere. Untersuchungen an Metall- bzw. Metalloxidelektroden zeigten das hierfür Temperaturen im Bereich von 1000K notwendig sind [Mie72]. Durch die geringe Energietiefe der Haftstellen ist allerdings in hochpolymeren Isolierstoffen eine thermische Aktivierung und Emission wahrscheinlich [Kah89].

#### 2.2.1.5 Feldemission von Elektronen aus Oberflächen

Die für die Feldemission an Metallelektroden benötigten Feldstärken werden in [Bey86] mit 100 kV/mm angegeben. Elektronen können aus dem Leitungsband die Potentialbarriere durchtunneln, da die Austrittsarbeit nach dem Schottky-Effekt herabgesetzt ist. Durch Oberflächenrauhigkeiten kann lokal diese Grenzfeldstärke erreicht werden. Geht man von der geringen Energietiefe der Haftstellen in Isolierstoffen aus, werden geringere Feldstärken benötigt.

#### 2.2.1.6 Weitere Mechanismen

Für die Beschreibung weiterer Mechanismen zur Bereitstellung von Ladungsträgern in Isolierstoffen soll zunächst die Bandstruktur, damit die energetischen Zustände im Feststoff, betrachtet werden. Hochpolymere Isolierstoffe besitzen einen teilkristallinen Aufbau. Damit verbunden ist ein nicht durchgängiges Energieband mit einzelnen lokalen Niveaus nach Abbildung 2.9.



Abbildung 2.9: Bändermodell eines Hochpolymers nach [Bey86]

Es ergibt sich ein mittlerer Abstand W von Valenz (VB)- und Leitungsband (LB) bzw. Valenz (VN)- und Leitungsniveau (LN). Es wird davon ausgegangen [Bey86], dass sich Elektronenplätze (Haftstellen HS) in diesem Bandabstand befinden, deren Austrittsarbeit beim ungeschädigten Prüffing bei etwa 1 eV liegen.

Nach dem Ausbilden der ersten Gasentladung treffen die Elektronen auf die dielektrische Grenzschicht an der Anode und können dort in den Isolierstoff diffundieren oder sich in Haftstellen anlagern. In Anlehnung an die Halbleiterphysik heissen diese besetzten Haftstellen Donatoren (DZ).

Im bereits vorgeschädigten Isolierstoff kann davon ausgegangen werden, dass die mittlere Haftstellentiefe der Donatoren nur etwa 0,65 eV und weniger beträgt. In [Kah89] wird die Haftstellentiefe im Bereich von 0,01 bis 0,1 eV angegeben. Für ein unbelastetes, schädigungsfreies Dielektrikum liegt die Elektronenaustrittsarbeit  $W_a$  etwa im Bereich 4 - 5 eV. Diese stark herabgesetzten Austrittsarbeiten verbessern die Bereitstellung von Start- und Sekundärelektronen für folgende Entladungen erheblich und beeinflussen zudem den Entladeverzug  $t_{EV}$ .

Das Herauslösen von Elektronen aus Haftstellen mit niedrigem Energieniveau kann bei wesentlich geringeren Temperaturen und Feldstärken erfolgen. Die freigesetzten Ladungsträger stehen für Leitungsmechanismen im Feststoff zur Verfügung. Dieser Mechanismus wird Pool- Frenkel- Effekt genannt.

Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten zur Bereitstellung von Ladungsträgern an der Grenzschicht von Isolierstoff zur Elektrode. Bei ausreichender elektrischer bzw. thermischer Energiezufuhr können dem Isolierstoff Elektronen aus der Kathode injiziert und Raumladungen unmittelbar vor der Elektrode gebildet werden. Diese injizierten Elektronen werden ebenfalls in flachen Haftstellen angelagert [Mül03]. Beide Mechanismen, die

- felderleichternde thermische Injektion (Richardson- Schottky- Injektion) und die
- reine Feldinjektion (Fowler- Nordheim- Injektion)

laufen unter Feldstärken im Bereich von etwa 200 kV/mm ab. Für technische Oberflächenqualitäten werden nennenswerte Emissionsraten durch die reine Feldinjektion bereits bei weit geringeren Feldstärken erzielt [Bro98]. Eine exakte Begründung für dieses Phänomen ist bis dato noch nicht erbracht.

Zudem können Raumladungen in Bereichen unterschiedlicher Dielektrizitätszahlen bzw. Leitfähigkeiten ausgebildet werden. Die Ursache hierfür sind frei Ladungsträger, die sich in Abhängigkeit der Feldrichtung an den Korngrenzen ansammeln (Maxwell- Wagner- Effekt).

Eine weitere Möglichkeit steht mit dem Malter- Effekt zur Verfügung. Dünne, isolierende Fremdschichten auf Elektroden fördern die Auslösung von Elektronen. Hier können sich Oberflächenladungen absetzen und hohe Feldstärken erzeugen. In Fehlstellen die an Elektrode und Dielektrikum angrenzen, können isolierende Schichten durch Ablagerungen aus Alterungserscheinungen auf der Elektrode gebildet werden. Die nach [Bru91] wichtigsten Mechanismen zur Bereitstellung von Startelektronen sind die Auslösung bei Annäherung von metastabilen Molekülen bzw. Atomen, sowie die Feldemission aus Feststoffen.

Die relevantesten Möglichkeiten zur Sekundärelektronengeneration sind nach [Kur93] die Photoionisation von Gasmolekülen und das Auslösen von Elektronen aus dem Feststoff nach dem  $\gamma$ - Prozess.

## 2.2.2 Beeinflussung der Gasentladung durch dielektrische Grenzschichten

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben bilden sich während des Lawinenaufbaus bis zum Durchschlag Raumladungen im Gasraum aus. Liegt das elektrische Grundfeld  $E_G$  nach dem Ausbilden der ersten Lawine weiterhin an den Elektroden an und ist der effektive Ionisierungskoeffizient  $\alpha_{eff} > 0$ , driften die Elektronen und negativen Ionen in Richtung Anode. Da die Anode vom Entladungsraum durch eine dielektrische Grenzschicht getrennt ist, kann eine vollständige Rekombination bzw. Diffusion, bedingt durch die geringe Leitfähigkeit des Isolators, nicht stattfinden.

Ein Grossteil der Elektronen und negativen Ionen lagert sich als Oberflächenladung an, der geringere Teil diffundiert in das Dielektrikum, welches die Anode umschliesst bzw. rekombiniert mit positiven Ionen. Positive Ionen wandern ihrerseits in Richtung Kathode. Damit wird ein elektrisches Poisson- Feld  $E_L$ aufgebaut, welches das Grundfeld  $E_G$  schwächt. Wechselt das Grundfeld  $E_G$ nach dem Anlagern der Oberflächenladungen jedoch die Polarität, hat das Poisson- Feld  $E_L$  unterstützenden Charakter.

Zurückgebliebene Raumladungen im Gasraum rekombinieren oder werden selbst als Oberflächenladung angelagert. Ihr Einfluss auf Folgeentladungen ist als gering abzuschätzen, sie sind daher vernachlässigbar [Bru91].

Durch die Anlagerung und Injektion von Elektronen an bzw. in die fehlstellenseitigen Oberflächen des Dielektrikums nimmt die Leitfähigkeit im Bereich der Grenzschichten zu [Hod93] und begünstigt das Abfliessen der Ladungen in den Isolierstoff und somit den Abbau der Oberflächenladungen. Die generierten Oberflächenladungen verändern den TE- Einsatz massgeblich im Vergleich zu unbehinderten Entladungen an Metallelektroden. Das zeigt sich beispielsweise in pulsierendem TE- Einsatz mit zeitweiligem Aussetzen oder vollständigem Erlöschen, die so genannte Selbstlöschung [Kah89].

Der Einfluss der Oberflächenladung ist leicht an der TE- Messung mit 50 Hz nachzuvollziehen. Während die erste Teilentladung im zunächst raumladungsfreien Gasraum noch im Bereich der Amplitude detektierbar ist, begünstigen die neu generierten Ladungen den Entladungsaufbau durch eine positive Überlagerung des Grund- und Poisson- Feldes aufgrund des Polaritätswechsels der zweiten Halbwelle. Die TE- Impulse verschieben sich in Richtung des Nulldurchgangs.

Bedingt durch die geringen Leitfähigkeiten von Isolatoren, sind Oberflächenladungen meist sehr langlebig. Die Zeitkonstanten für den Ladungsabbau sind sehr gross gegenüber Periodendauern technischer Frequenzen. In [Das90] sind Ableitzeiten von Minuten bis in den Stunden Bereich ermittelt worden. Dieser Memory- Effekt [Bru91, Kog02] beeinflusst bei Wiederholungsmessungen der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  das Ergebnis und muss berücksichtigt werden.

Darüber hinaus ist der Zustand der Fehlstellenoberfläche in Verbindung mit angelagerten Ladungsträgern für den Entladeverzug bedeutend [Hoo97]. Die Entladeverzugszeit  $t_{EV} = t_S + t_A$  für den Einsatz der ersten Teilentladung im ungeschädigtem Epoxydharzprüfling mit einer kugelförmigen Fehlstelle ergibt sich nach [Gut95] zu

$$t_{EV} \approx t_S = \frac{1}{\dot{n}_{e0} \cdot V(1 - \frac{1}{u^2})}.$$
 (2.21)

Mit den Annahmen, dass die mittlere Startelektronenbildungsrate  $\dot{n}_{e0} \approx 2 \cdot 10^{-3}/(s \cdot mm^3)$ , die relative Überspannung  $u \gg 1$  und der Radius der kugelförmigen Fehlstelle  $r_{Fehl} = 0.5$  mm betragen, ergibt sich  $t_{EV} \approx 16$  min. Für einen Fehlstellenradius von  $r_{Fehl} = 0.1$  mm kann mit (2.21) ein Verzug von mehreren Stunden berechnet werden. Messungen in [Gut95] ergaben teilweise Werte, die über den berechneten lagen.

Für künstlich geschaffene Fehlstellen in Prüflingen ergeben sich meist deutlich geringere Entladeverzugszeiten  $t_{EV}$  [Bro98]. Es wird vermutet, dass Verunreinigungen, Elektronenablagerungen in den Haftstellen, elektrostatische Aufladungen oder Eindringen von Feuchtigkeit die Abweichung der Entladeverzugszeit  $t_{EV}$  bei künstlichen Fehlstellen hervorrufen.

Mit den oben gegebenen Werten für die Auslösearbeit von Elektronen aus den Haftstellen wurde in [Mor93] die Entladeverzugszeit  $t_{EV}$  berechnet. Es ergaben sich Zeiten von wenigen ns bis ms. Das verwendete Berechnungsmodell legte allerdings nur eine thermische Aktivierung der Oberflächenelektronen zu Grunde. Nach [Bru91] liefern feldunterstützende Emissionsprozesse einen wesentlichen Beitrag zur Elektronengeneration, die vollständig vernachlässigt wurden. Zieht man diesen Aspekt in Betracht, ergäben sich Entladeverzugszeiten  $t_{EV}$  im ns Bereich.

# 2.3 Alterungserscheinungen bei inneren Teilentladungen

Finden Teilentladungen dauerhaft in Isolierstoffen statt, kann davon ausgegangen werden, dass physikalische und chemische Prozesse die Umgebung verändern.

Quellen für Teilentladungen sind alle Inhomogenitäten des Isolierstoffs. Das können unter anderem Permittivitätsänderungen, Korngrenzen, amorphe Bereiche, Verunreinigungen, Einschlüsse und Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialien sein. In diesen Bereichen bilden sich örtlich überhöhte Feldstärken aus, welche Schädigungsmechanismen einleiten. Da sich im Festkörperim Gegensatz zu flüssigen oder gasförmigen Isolierstoffen- diese Inhomogenitäten nicht ausgleichen können, sind Feststoffisolieranordnungen besonders von Teilentladungen betroffen.

Die heute vielfach benutzten hochpolymeren Isolierstoffe sind besonders empfindlich gegenüber Entladungen an den Grenzflächen des Isolierstoffs und in Fehlstellen des Isolierstoffs [Sch85]. So verändern ständige Teilentladungen die Oberfläche des Dielektrikums, was sich in Änderungen der TE- Einsetzspannung, der Impulsabstände und der Folgefrequenz wiederspiegelt.

Wie in vielen Experimenten untersucht wurde, ist der Schädigungsprozess von Kunststoffen sehr komplex. Folgende Mechanismen können die Isolation degenerieren [Bey86, Göt92, Kah89, Mas78]:

- Lokale Erwärmung und thermisch bedingte Veränderung der Oberfläche
- Chemische Zersetzung an der Oberfläche
- Mechanische Erosion durch auftreffende Ladungsträger
- Erhöhen der Feldstärke durch Ladungsträgerinjektion
- Chemische Reaktionen und Erwärmung im Gasraum
- Radikalbildung und Kettenbruch im Isolierstoff.

Elektrische Alterungserscheinungen können nach [Kah89] in Feldalterung, Teilentladungsalterung, elektrothermische und elektrochemische Alterung eingeteilt werden. Eine strikte Trennung ist oftmals schwer möglich.

Für eine Aussage zur Schädigungswirksamkeit einer Teilentladung ist der Energieumsatz in der Fehlstelle ein relevanter Parameter [Cha62]. [Kah89] geht davon aus, dass nur 10% der umgesetzten Gesamtenergie einer Teilentladung zur Isolierstoffdegeneration direkt wirksam werden. Der Hauptteil wird in den Gasraum geleitet und erwärmt ihn [Gol95], womit auch das erhitzte Gas schädigungswirksam werden kann. In [Hoo97] wurde ein möglicher Energieumsatz bei Teilentladungen abgeschätzt. Für 100 Teilentladungen je Sekunde in einer kugelförmigen Fehlstelle mit dem Radius  $r_{Fehl}=0.5$  mm in Polyethylen wurde eine Erwärmung der Fehlstellenoberfläche von weniger als 1 K berechnet. Mit diesem Ergebnis kann eine thermische Belastung des Isolierstoffs ausgeschlossen werden.

Die mechanische Schädigung der Oberfläche wird in der Literatur der Belastung durch auftreffende Ladungsträger zugeschrieben. Elektronen können dabei kinetische Energien von einigen 10 eV besitzen [Bru94, Gol95, Hoo97, Kur93]. [Ize85, May76] untersuchten Alterungsprozesse an Polyethylen mit dem Ergebnis, dass eine signifikante Degeneration der Oberfläche erst ab Energien von mehr als 100 eV eintritt. In [Kah89] wird der Degradation des Isolierstoffs durch Elektronen deshalb nur eine thermische Unterstützung angedacht. Selbst unter Annahme eines zentralen Stosses eines Elektrons auf ein Atom sind die übertragbaren Energien zu gering um Polymerverbindungen aufzubrechen.

Bei Untersuchungen zur Glimmentladung wurden Energien von mehreren 10 eV für positive Ionen festgestellt [Gol95]. Sie verlieren sehr schnell ihre kinetische Energie und können deshalb nur bei chemischen und thermischen Prozessen unterstützen. Bei Streamerentladungen können positive Ionen allerdings kinetische Energien von mehr als 100 eV besitzen. Diese Energie ist ausreichend um chemische Bindungen zu zerstören und die mechanische Erosion zu unterstützen [Fou93, Ize85].

Schädigend für den Feststoff ist die Injektion und Extraktion von Elektronen in bzw. aus Haftstellen [Göt92, Sch85]. Das permanente Einlagern und Herauslösen führt zur Temperaturerhöhung, zum Auftreten elektromechanischer Kräfte und zur chemischen Schädigung.

[Bru91] stellte fest, dass die mittlere Energie der Elektronen grösser ist als die der Moleküle. Somit ist keine effektive Erwärmung der Umgebung durch Elektronen möglich [Kog02]. Es entstehen jedoch lokal stark begrenzte Bereiche mit erhöhter Temperatur auf der Isolierstoffoberfläche [Bro98]. Aus diesem Grund heissen innere Teilentladungen auch *kalte Entladungen*.

Wie bereits erwähnt, übertragen die auftreffenden Ladungsträger Teile ihrer Energie auf das Molekülgefüge des Isolierstoffs. Dort regen sie dieses zu thermischen Schwingungen an und die thermische Alterung setzt ein. Die morphologische Struktur des Feststoffs wird durch Ketten- und / oder Ringbrüche verändert und begünstigt die Oxidation des Isolators. Nach ersten Schädigungen stellte [Kra75] lokale Aufschmelzungen auf der Oberfläche fest, die er auf die thermische Alterung zurückführte. Bindungsbrüche treten zudem in der Gasphase der Fehlstelle auf und regen zur Bildung von Ionen und Molekülen an. Die Änderung der Zusammensetzung der Gasatmosphäre kann zum Druckanstieg im Einschluss führen, der aber im allgemeinen durch Diffusionsvorgänge wieder ausgeglichen wird.

Der Umbau der Bindungen und die mechanische Erosion bewirken eine Abgabe von flüchtigen Bestandteilen des Feststoffs in den Gasraum. Diese lagern sich zum Teil auf den Grenzschichten der Fehlstelle ab und verändern die Oberflächenleitfähigkeit. Messungen in [Bru94] zeigten, dass nach hinlänglicher Zeit für den Oberflächenladungsabbau der Oberflächenwiderstand mit zunehmender Teilentladungsbelastung zunimmt. Diese Zunahme ist auf Ablagerungen zurückzuführen, da nach der Entfernung dieser die Ausgangswerte erreicht wurden. In Verbindung mit Feuchtigkeit können diese Ablagerungen Elektrolyte auf den Oberflächen bilden, welche die Leitfähigkeit erhöhen können [Gol95].

Bei Teilentladungen in Hohlräumen laufen neben den physikalischen Prozessen chemische Reaktionen ab und schädigen den Isolierstoff. Der chemische Abbau der organischen Materialien kann hydrolytisch durch eindiffundierte Feuchtigkeit, strahleninduziert, thermisch oder thermooxidativ erfolgen. Durch die Vielzahl der beteiligten Stoffe und den damit verbundenen Reaktionsvarianten ist eine genaue Betrachtung sehr aufwendig. Einige Möglichkeiten sollen hier kurz skizziert werden.

Für Teilentladungen in Luft werden in [Eli91] ein Teil der beteiligten Reaktionspartner ermittelt. So entsteht durch Dissoziation von Sauerstoff durch UV-Strahlung oder energiereiche Elektronen Ozon, der mit der Luft zu Stickoxiden reagieren kann. Vermengt sich Wasser mit Stickoxid bildet sich Salpetersäure. Verbindet sich Ozon mit Wassermolekülen entstehen zunächst Hydroperoxide und daraus Carbonylgruppen, welche die funktionelle Gruppe der Carbonsäuren (z.B. Oxalsäure)ist. In [Hod91] wurden ebenfalls Alkansäuere (z.B. Methansäure) und Hydroxycarbonsäuren (z.B. Hydroxyessigsäure) in geschädigten Epoxydharzhohlräumen nachgewiesen, welche eine zersetzende Wirkung haben. Das zudem festgestellte Kristallwachstum ist auf einen oxidativen Abbau des Isolierstoffs zurückzuführen [Fou93]. Des Weiteren können sich organische Salze ablagern und  $H_2, CH_4, CO$  und  $CO_2$  entstehen, was auf einen Bindungsumbau rückschliessen lässt [Kah89].

Einen hohen Beitrag zur Degeneration des Feststoffs liefert die Bildung von atomarem Sauerstoff und angeregten bzw. ionisierten Sauerstoff [Kah89]. Ihm wird eine verstärkende Wirkung bei der Depolymerisation zugeschrieben. Die beschriebenen gasförmigen und flüssigen Reaktionsprodukte können nicht nur oberflächlich wirken, sondern auch in tiefere Schichten diffundieren und dort Molekülbindungen aufbrechen. In der Tiefe entstehende Radikale können bei entsprechend geringer Grösse ausdiffundieren und die Oberflächenerosion einleiten.

[Ize85] stellte fest, dass die chemische Schädigung die entscheidenste Rolle im Alterungsprozess einer Polyethylenisolierung darstellt.

In	Tabelle	$2.1 \mathrm{s}$	ind die Bi	ndungse	energien	$W_B$	einiger	wich	tiger	hoch	oolyı	me-
rer	Isolier	stoffe	beigefügt.	Wird d	liese Bir	ndung	gsenergi	e übe	$\operatorname{erschr}$	$\operatorname{itten}$	köni	nen
Biı	ndungsb	rüche	eingeleitet	werden	. Treten	Teile	entladur	igen j	perma	anent	auf,	de-

Isolierstoff	Mittlere molekulare				
	Bindungsenergie $W_B$ in eV				
Polyethylen	$3,\!62$				
Polyvinylchlorid	3,41				
Epoxydharz	3,72				
Polytetrafluorethylen	5,04				

Tabelle 2.1: Bindungsenergien hochpolymerer Isolierstoffe nach [Hoo97]

generiert der Isolierstoff unter den oben genannten Einflüssen. Überschreitet die elektrische Feldbelastung dann die maximale Festigkeit des verbleibenden Isolierstoffs erfolgt das Versagen der gesamten Isolieranordnung nach den Mechanismen des elektrischen Durchschlags bzw. des Erosionsdurchschlags. Die Zeit bis zum vollständigen Durchschlag kann dabei mit Hilfe des Lebensdauergesetzes nach [Bey86] abgeschätzt werden. Die dazu notwendigen Grössen, wie Lebensdauerexponent etc., müssen jedoch in den meisten Fällen experimentell bestimmt werden.

# Kapitel 3

# Versuchstechnik

Dieses Kapitel stellt die wesentlichen verwendeten Komponenten und Messaufbauten vor. Hierbei wird zunächst kurz auf die Baugruppen der Referenzanlage für technische Wechselspannungen eingegangen und anschliessend die Realisierung der entsprechenden Baugruppe für die Pulsspannungsprüfung detailliert erläutert.

Einen wesentlichen Teil dieses Kapitels nimmt die Charakterisierung der entwickelten Modellisolierungen ein. Es werden die 4 Typen der entstandenen Modellisolierungen und ihre Herstellungsverfahren erklärt.

## 3.1 Verwendete Anlagen

## 3.1.1 Teilentladungsmessung bei 50 Hz Wechselspannung

Die derzeitigen Normen sehen für die Prüfung von Isolieranordnungen auf Teilentladungen eine Belastung mit sinusförmigen Wechselspannungen mit

f=50 Hz vor. Die entsprechenden Versuchsaufbauten und Prüfbedingungen sind in der DIN VDE 0434 festgelegt.

Für die Ermittelung von normgerechten Referenzwerten zur späteren Korrelation mit den Ergebnissen aus der Pulsspannungsuntersuchung stand eine kommerzielle TE- Messanlage von LEMKE DIAGNOSTICS GmbH zur Verfügung. Die Prinzipskizze 3.1 zeigt den verwendeten Aufbau. Die praktische Realisierung des Messkreises und der Spannungserzeugung wird in Abbildung 3.2 dargestellt.



Abbildung 3.1: Prinzipskizze zum 50 Hz TE- Messsystem

Alle hochspannungsführenden Baugruppen wurden in einer geschirmten Kabine mit einer frequenzabhängigen Schirmdämpfung von wenigstens 80 dB aufgebaut. Der TE- Grundstörpegel beträgt in der Anordnung ca. 0,3 pC.

Die Spannungserzeugung wurde zum Teil mit Elementen des MWB- Hochspannungsbaukastens erstellt und über ein Steuerpult bedient. Ein netzseitiger, motorgetriebener Einphasen- Stelltransformator speist einen 100 kV-Hochspannungstransformator. Dessen Primärwicklungen können nach Bedarf parallel bzw. seriell geschaltet werden, sodass nach Bedarf eine maximale Ausgangsspannung von 100 kV bzw. 50 kV erreicht wird. Da die Versuche nur eine Spannung bis ca. 30 kV benötigen, wird der Hochspannungstransformator mit verminderter Maximalspannung betrieben.

Sekundärseitig wurden am Hochspannungstransformator ein Schutzwiderstand mit  $R_{Schutz} = 50k\Omega$  und ein Messkondensator mit  $C_{Mess} = 100pF$  nachgeschaltet. Mit dem an den Messkondensator  $C_{Mess}$  angeschlossenen Drehspulinstrument in der Schaltung nach Chubb und Fortescue wird der Scheitelwert der Ausgangspannung angezeigt.



Abbildung 3.2: Versuchsaufbau für 50 Hz Messung

Der Spannungserzeugung und - anzeige ist der eigentliche TE- Messkreis nachgeschaltet. Er besteht aus dem Prüfling, zu dem die Serienschaltung aus Koppelkondensator  $C_K = 1nF$  und Messimpedanz LDM - 5 von LEMKE DIA-GNOSTICS GmbH parallel geschaltet ist.

Der Messvierpol ist breitbandig mit einer oberen Grenzfrequenz von ca. 30 MHz ausgelegt. Die grosse Induktivität des Hochspannungstransformators bedingt, dass die hochfrequenten TE- Ströme nahezu vollständig im Messkreis fliessen. Dort erzeugen sie einen Spannungsabfall an der Messimpedanz LDM - 5, der mit dem Messsystem LDS - 6 weiterverarbeitet wird. Somit steht eine Referenzanlage zur Verfügung, die Teilentladungen von < 1 pC bis 100 nC normgerecht erfassen kann. Der verwendete Aufbau ist bis zu einer Effektivausgangsspannung von 100 kV teilentladungsfrei.

# 3.1.2 Teilentladungsmessung bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung

Für die Untersuchung von Isolieranordnungen unter pulsförmigen Spannungsbelastungen sollten umrichtertypische Ausgangsspannungen erzeugt werden. Die Versuchstechnik wurde nach folgenden Parametern ausgelegt:

- Rechteckförmige Ausgangsspannung bis 10 kV
- Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bis 10 kHz
- Anstiegszeiten  $t_R$  ab ca. 200 ns
### 3.1.2.1 Die Pulsspannungserzeugung

Die Erzeugung der oben spezifizierten Pulsspannung erfolgte mit einer Anlage aus mehreren Komponenten. Abbildung 3.3 zeigt die Prinzipskizze, Abbildung 3.4 die praktische Realisierung.



Abbildung 3.3: Übersichtsskizze der Pulsspannungsanlage



Abbildung 3.4: Pulsspannungsanlage

Zunächst wird eine Gleichspannung mit dem Hochspannungsnetzteil Heinzinger HNC 10000- 180 erzeugt. Diese kann im Bereich 0 - 10 kV stufenlos eingestellt werden. Über ein koaxiales Hochspannungskabel wird die Spannung dem Pulsgenerator PVX- 4110 von DIRECTED ENERGY zugeführt und in einem Transistorarray ein- bzw. ausgeschaltet, wodurch eine rechteckförmige Pulsspannung entsteht. Mit diesem Generator sind Anstiegszeiten  $t_R$  von ca. 20 ns für Prüflinge mit kleiner Kapazität möglich. Für die hier untersuchten Anordnungen waren, begrenzt durch die Impulsstromstärke, allerdings nur Steilheiten von ca. 200 ns über den untersuchten Spannungs- und Frequenzbereich erzeugbar.

Gesteuert wird der Pulsgenerator mittels eines Frequenzgenerators, bei dem die Pulsfolgefrequenz  $f_W$  und der Tastgrad a in einem grossen Bereich frei wählbar sind. Der Frequenzgenerator bietet neben der automatischen Triggerung (Pulsfolgen) die Möglichkeit der manuellen Triggerung. Somit können auch gezielt Impulse geforderter Breite erzeugt werden.

Da Stromrichter oftmals pulsweitenmodulierte Rechteckspannungen überlagert mit einem Gleichspannungsanteil erzeugen, wurde eine zweite Gleichspannungsquelle verwendet. Diese wurde potentialgetrennt betrieben und die Gleichspannung kapazitiv in den Erzeugerkreis eingekoppelt. Somit ist eine Untersuchung des Teilentladungseinsatzes bei beliebigem Gleichspannungsanteil möglich.

### 3.1.2.2 Der Messkreis

Für die Detektion des Teilentladungsstroms  $I_{PD}$  wurde ein Messkreis verwendet, der dem 50 Hz- Messkreis ähnlich ist (Abbildung 3.5).



Abbildung 3.5: Messkreis schematisch

Über einen Vorwiderstand  $R_V$  wird die Pulsspannung an den Koppelkondensator  $C_K = 500pF$  und den Prüfling  $C_P$  gelegt. Vorwiderstand  $R_V$  und Koppelkondensator  $C_K$  bilden einen Tiefpass 1. Ordnung, mit dem die Anstiegszeit  $t_R$  der Eingangsspannung  $U_{Puls}$  verändert werden kann.

Widerstandswert $R_V$ in $\Omega$	Anstiegszeit $t_R$ in ns
120	350 - 450
220	550 - 650
900	950 - 1100
1750	1500 - 1700
2460	3000 - 3300
10030	12500 - 13000

Folgende Widerstandswerte wurden für die Untersuchungen verwendet:

Tabelle 3.1: Verwendete Widerstandswerte für den Vorwiderstand

Der hochfrequente Teilentladungsstrom  $I_{PD}$  fliesst über Hochpass, Messwiderstand  $R_M$  und Koppelkondensator  $C_K$  zurück zum Prüfling  $C_P$  und ist dabei als Spannungsabfall  $u_M$  am Messwiderstand  $R_M$  abgreifbar. Dieser kann mit einem Oszillographen sichtbar gemacht werden.

Zum Schutz der Messtechnik bei einem vollständigen Durchschlag des Prüflings dienen 2 Transzorbdioden. Sie begrenzen die Messspannung  $u_M$  im ps-Bereich auf ca. 160 V. Zusätzlich wurde ein Tastkopf 10:1 verwendet, der den Schutz der Messtechnik nochmals erhöht.

Um die Streuinduktivitäten klein zu halten, wurde der Messkreis möglichst kompakt aufgebaut. Die relativ geringe Amplitude der Rechteckspannung von bis zu 10 kV ermöglicht den räumlich gedrängten Aufbau, der in Abbildung 3.6 dargestellt ist.



Abbildung 3.6: Messkreis bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung

Mit der Annahme von Streukapazitäten  $C_{Streu} = 100 pF$  ergibt sich die Messkreiszeitkonstante  $\tau_M$  nach [Schw81] bei den verwendeten Modellisolierungen zu

$$\tau_M = \frac{R_M}{2} \cdot \frac{C_P \cdot (C_K + C_{Streu})}{C_P + C_K + C_{Streu}} = 0,8ns$$
(3.1)

Da für einen typischen TE- Impuls die Anstiegszeit  $\tau_{A/PD} = 3ns$  beträgt [Hoo97], sind sowohl  $\hat{I}_{PD}$  als auch  $i_{PD}(t)$  weitestgehend proportional zur Messspannung  $u_M$ , falls Zuleitungs- und Bauelementeinduktivitäten vernachlässigt werden. Der räumlich gedrängte Aufbau des Messkreises begünstigt diese Annahme, es treten in der Praxis jedoch Streukapazitäten und induktivitäten auf. Diese beeinträchtigen den zeitlichen Verlauf der Messspannung  $u_M$ , sodass zum Teil schwingende Verläufe des Signals aufgezeichnet werden. Aus der sich ergebenden Spannungszeitfläche kann nach [Schw81] auch bei oszillierenden Verläufen die scheinbare Ladung  $Q_S$  bestimmt werden.

Die Pulsspannungsbelastung unterscheidet sich von der 50 Hz - Belastung unter anderem durch wesentlich geringere Anstiegszeiten. Will man Teilentladungen bei Pulsspannungen sinnvoll detektieren, ist ein zusätzliches Filtersystem notwendig. Die zeitliche Änderung der Pulseingangsspannung

$$\frac{dU_{Puls}}{dt} = i \cdot \frac{1}{C_P} \tag{3.2}$$

hat den Ladestrom i zur Folge, der über den Messwiderstand  $R_M$  messbar und dem TE- Strom  $I_{PD}$  überlagert ist. Da sich die Spektren der beiden Ströme voneinander unterscheiden, sind sie mittels Filtern trennbar.

Nach [Mül03] sind Teilentladungen bis in den Gigahertzbereich nachweisbar. Frequenzen von Pulsspannungen wie sie an Frequenzumrichtern entstehen, erstrecken sich im Wesentlichen unter 200 MHz. Eingesetzt wurde ein analoges Butterworth- Hochpassfilter 5. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von  $f_{Grenz} \approx 200 MHz$ .

In Abbildung 3.7 ist das Ubertragungsverhalten des Filters, in Abbildung 3.8 die praktische Realisierung dargestellt. Für eine gute hochfrequenztechnische Eignung des Filters wurde ein sehr kompakter Aufbau in SMD- Technik realisiert.



Abbildung 3.7: Übertragungsverhalten des Hochpassfilters



Abbildung 3.8: Hochpassfilter

# 3.2 Aufzeichnung und Darstellung der Messdaten

## 3.2.1 Messsystem für Teilentladungen bei 50 Hz Wechselspannung

Kernstück der TE- Messanlage ist das TE- Messgerät LDS - 6, welches die Abbildung 3.9 zeigt. Hiermit können Teilentladungen zusammen mit dem Phasenverlauf der Sinusspannung aufgezeichnet und analysiert werden. Die dafür benötigten Signale, Netzspannung und TE- Spannung, werden über die Messimpedanz LDM - 5 gemessen und zum Messgerät über BNC- Kabel übertragen.



Abbildung 3.9: Teilentladungsmesssystem LDIC LDS - 6

Die Eingangssignale werden im TE- Messgerät zunächst verstärkt und an die nachfolgenden Schaltungen angepasst. Hiernach detektiert die Impulsverarbeitungseinheit aus den Teilentladungssignalen die eigentlichen Teilentladungen und reduziert das Rauschen des Signals. Im Anschluss werden Prüfspannung und TE- Signal digitalisiert und stehen der eigentlichen rechnergestützten Auswertung zur Darstellung, Analyse und Diagnose zur Verfügung.

Grundsätzlich wird bei dem TE- Messsystem die Teilentladung als scheinbare Ladung  $Q_S$  in pC angegeben und über einer Sinusperiode dargestellt (Abbildung 3.10). Die scheinbare Ladung ist die Antwort des elektrischen Netzwerks (Ersatzschaltbild des Prüflings) auf den Ladungsumsatz in der Fehlstelle und kann an den Klemmen des Prüflings erfasste werden. Sie korreliert in nicht erfassbarer Weise mit der tatsächlich umgesetzten Ladung in der Fehlstelle, da ein Teil des Teilentladungstroms nur im Prüfling selbst fliesst. Man verwendet Eichgeneratoren, die Ladungen fester Grösse in den Messkreis einspeisen, um Einflüsse des angeschlossenen Messkreises abzugleichen. Die scheinbare Ladung  $Q_S$  hat sich als quantitative Kenngrösse in der TE-Messtechnik durchgesetzt. Durch die Aufzeichnungsmöglichkeit des LDS - 6



Abbildung 3.10: TE- Aufzeichnung bei 50 Hz über eine Periode

über einen frei wählbaren Zeitbereich stehen Daten zur Verfügung, mit denen der zu untersuchende Prüfling umfangreich analysiert, statistisch und diagnostisch bewertet werden kann. Abbildung 3.11 zeigt das Ergebnis der Aufzeichnung über ein 10 s Intervall.



Abbildung 3.11: TE- Aufzeichnung bei 50 Hz über 10 s

## 3.2.2 Messsystem für Teilentladungen bei Puls- und Impulsspannungen

Für die Analyse der Teilentladungen unter Pulsspannungen können folgende Parameter unmittelbar aus dem Oszillogramm ermittelt werden:

- TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$
- TE- Amplitude  $U_{PD}$
- Relative Lage der Teilentladungen
- zeitliche Verlauf der Teilentladungen

Aus dem zeitlichen Verlauf der Teilentladungsspannung  $U_{PD}$  kann darüber hinaus durch Rechnung (Faltungsintegral) die scheinbare Ladung  $Q_S$  abgeschätzt werden.

Die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  ist direkt über die Eingangsspannung  $U_{Puls}$ bestimmbar, welche mit einem Hochspannungstastkopf direkt am Koppelkondensator  $C_K$  gemessen wird. Zur Visualisierung der Eingangsspannung  $U_{Puls}$ und der Teilentladungen über das Messsignal  $u_M$  vom Messwiderstand  $R_M$ werden beide Signale auf einem 2 Kanal Oszilloskop dargestellt. Da Eingangsund Teilentladungsspannung über mehrere Perioden der Pulsspannung aufgezeichnet werden sollen, muss das Oszilloskop über eine grosse Speichertiefe verfügen.

Für die weitere Datenverarbeitung werden die Messdaten über den IEEE 488-2 Bus (GPIB) ausgelesen und im Binärformat auf einem PC gespeichert (siehe Abbildung 3.12). Die dafür notwendigen Steuerungsaufgaben sind in LAB-VIEW realisiert. Diese Software dient zudem für die Analyse der Messdaten.



Abbildung 3.12: Mess- und Aufzeichnungseinrichtung für Teilentladungen bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung

Somit steht ein Gesamtsystem zur Verfügung, mit dem Pulsspannungen erzeugt und Teilentladungen unter diesen Bedingungen gemessen werden können. Abbildung 3.13 zeigt ein typisches Messergebnis für eine Teilentladungsmessung unter Pulsspannung.

Will man die Messungen der Teilentladungen bei Wechselspannung und Pulsspannung miteinander vergleichen, muss eine Vergleichsgrösse festgelegt werden. Hierzu bietet sich die scheinbare Ladung  $Q_S$  an. Da es sich im Wesentlichen bei der vorliegenden Arbeit um die Detektion von Teilentladungen handelte, soll auf die Ermittlung der scheinbaren Ladung  $Q_S$  nur am Rande eingegangen werden.

Hierzu wird der TE- Messkreis ohne Hochpassfilter und Schutzdioden betrachtet, bei dem der Messwiderstand  $R_M$  in Serie zur Prüflingskapazität  $C_P$  liegt. Die scheinbare Ladung  $Q_S$  ergibt sich aus der Integration der Messspannung  $u_M = u_{PD} + u_0$ .

$$Q_S = \frac{C_P + C_K}{C_K} \cdot \frac{1}{R_M} \cdot \int_{t=t_0}^{t=t_1} \left[ u_M(t) - u_0(t) \right] \cdot dt$$
(3.3)

Die Differenz innerhalb des Integrals beschreibt den Offset des Teilentladungssignals  $u_{PD}$ . Das Teilentladungssignal  $u_{PD}$  ist auf die Spannung  $u_0$  aufgesetzt, welche sich durch den Ladestrom i bei Spannungsänderung der Pulsspannung  $U_{Puls}$  an der Kapazität  $C_P$  ergibt.

Der Korrekturfaktor  $\delta = \frac{C_P + C_K}{C_K}$  berücksichtigt, dass bei kleinen Koppelkapazitäten  $C_K$  der TE- Strom  $I_{PD}$  und damit die scheinbare Ladung  $Q_S$  abnimmt. Praktisch ergibt sich für den Messkreis  $\delta = 1,05$ .

Vergleichsmessungen des Messsystems bei technischer Wechselspannung zeigten auch bei schwach ausgeprägten Teilentladungen im pC Bereich identische Teilentladungseinsetzspannungen wie das LEMKE-Messsystem. Folglich besitzen beide Systeme vergleichbare Messempfindlichkeiten.



Abbildung 3.13: Teilentladungsmessung bei pulsförmiger Spannungsbelastung

## 3.3 Verwendete Isolieranordnungen

Im Rahmen dieser Arbeit sollten neben umrichtertypischen Spannungsbelastungen auch umrichtertypische Isolieranordnungen untersucht werden. Bei Untersuchungen an vakuumverklebten Verschienungen diverser Stromrichter zeigte sich jedoch, dass konstruktionsbedingt zunächst nur Korona- bzw. Gleitentladungen (äussere TE) auftreten. Innere Teilentladungen konnten nicht festgestellt werden.

Diese Verschienungen sind somit für die gewünschten Untersuchungen prinzipiell ungeeignet. Ausserdem würden die grossen Kapazitäten der Anordnungen die Leistungsfähigkeit der Pulsspannungsanlage aus 3.1.2.1 übersteigen.

Ausgehend von diesen Erfahrungen wurden reproduzierbare Isolieranordnungen mit verschiedenen Elektroden- und Fehlstellengeometrien entwickelt, die innere Teilentladungen bei Einsetzspannungen bis 10 kV aufweisen. Die sich dabei ergebenden zwei Arten von Prüflingen wurden eingeteilt in:

- Prüflinge mit quasihomogenem Grundfeldverlauf
  - Fehlstelle allseitig von Epoxydharz umhüllt (P1 und P4)
  - Fehlstelle an Elektrode angrenzend (P2)
- Prüflinge mit inhomogenem Grundfeldverlauf (P3)

Ziel war es, realitätsnähere Prüflinge, als die der bisher veröffentlichten Untersuchungen zu verwenden.

Wie bereits in der Einführung erwähnt, wurden bisher Windungsisolierungen auf ihr Teilentladungsverhalten bei pulsförmigen Spannungsbeanspruchungen untersucht. Ein Modell dafür sind isolierte Lackdrähte, welche verdrillt oder in Form von Spulen verwendet wurden. Es ist fraglich, ob diese Modellisolierungen auch geeignet sind, umrichtertypische Isolieranordnungen nachzubilden.

Die Fehlstelle, und damit das Teilentladungsvolumen, befindet sich zwischen den Lackschichten und ist nicht von der Umwelt getrennt. Verunreinigungen, aber auch Ladungsträger, können aus der umgebenden Atmosphäre in den Entladungsraum gelangen. Damit sind grundsätzlich andere Bedingungen für Gasentladungen möglich.

Durch die Länge des verwendeten Drahtes sind Teilentladungen prinzipiell überall möglich, was die Schädigungsuntersuchung erschwert. Für die verwendeten Modellisolierungen sind Teilentladungen nur in einem lokal begrenzten Raum möglich.

Des Weiteren beeinflusst der offene Entladungsraum die Folgeteilentladungen. Teilentladungen rufen Druck- und Temperaturveränderungen hervor, die bei vollständig umschlossenen Fehlstellen eine gewisse Zeit erhalten bleiben.

Durch Gasentladungen werden Ladungsträger gebildet, die sich anschliessend auf den dielektrischen Grenzschichten abgelagern. Bei vollständig umschlossenen Fehlstellen können diese durch Ladungsträger von ausserhalb des Entladungsvolumens nicht abgebaut werden.

## 3.3.1 Prüflinge mit quasihomogenem Grundfeldverlauf P1, P2 und P4

Eine typische Topologie für Stromrichterverschienungen sind grossflächige Elektroden mit kleinem Abstand, die durch Isoliermaterial voneinander getrennt sind. In erster Näherung ergibt sich, zumindest räumlich begrenzt, ein homogenes elektrisches Grundfeld. In diesem Homogenfeld können sich Fehlstellen befinden, die vollständig von Isoliermaterial umschlossen sind bzw. an einer Elektrode anliegen.

Ausgangspunkt für Prüflinge mit quasihomogenem Grundfeldverlauf sind zwei Kugelelektroden mit dem Durchmesser d=20 mm, die aus Messing gefertigt sind.



Abbildung 3.14: Übersichtsskizze Prüffingsart P1

Bei einem Elektrodenabstand s= 1,0 mm von Pol zu Pol ergibt sich der Schwaigersche Ausnutzungsfaktor nach [Gän53] zu  $\eta_S \approx 0,967$ . Für s= 1,5 mm beträgt  $\eta_S \approx 0,951$ .

Als typischer Isolierstoff wurde für diese Untersuchung ein ungefülltes 2 Komponentenepoxydharz von VANTICO verwendet, das Harz CW 1301 und der Härter HY 1300 aus der ARALDITE Linie.

Zunächst wurden die beiden polierten Elektroden in einem ausreichend grossen Gehäuse vollständig mit Isolierstoff vergossen und im Vakuumschrank bei p=0,3 bar unter Umgebungstemperatur  $\vartheta = 25^{\circ}$ C mindestens 24 Stunden ausgehärtet. Das Vakuum soll verhindern, dass Lufteinschlüsse im Isolierstoff verbleiben und damit ungewollt Fehlstellen entstehen.

Nach der Aushärtephase wurde die Isolieranordnung zwischen den beiden Elektroden mit einem HSS- Kreissägeblatt aufgetrennt und mittels Drehbank auf das geforderte Mass abgedreht. Die Fertigungsgenauigkeit der verwendeten Werkzeugmaschinen liegt hierbei im Bereich von 5  $\mu m$ .

### 3.3.1.1 Die Prüflingsart P1

Die erste Prüflingsart mit quasihomogenem Feldverlauf und allseitiger Umhüllung der Fehlstelle stellt die Prüflingsart P1 dar (siehe Abbildung 3.14). Dazu wurde die oben beschriebene Isolieranordnung mittig aufgeschnitten und asymmetrisch gemäss Abbildung 3.15 abgedreht. In die Prüflingshälfte mit dem Abstand x = 0.6 mm von Elektrodenpol zur Schnittfläche wurde daraufhin eine Fehlstelle auf der Symmetrieachse der Kugelelektrode eingebracht. Dazu wurde ein 0,8 mm 3- Schneiden- Fräser verwendet. Es entstand eine zylinderförmige Fehlstelle mit einem Radius  $r_{Fehl} = 0.4$  mm und einer Fehlstellenhöhe  $h_{Fehl} = 0.2$  mm. Beide Prüflingshälften wurden im Anschluss ausserhalb der Schnittfläche verklebt und zusätzlich mit Silikon abgedichtet.



Abbildung 3.15: Vergrösserter Ausschnitt der Fehlstelle von P1

Näherungsweise ergibt sich nach [Kor98] die Kapazität der Anordnung zu

$$C_P \approx \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon}{\frac{1}{r_{Kugel}} - \frac{1}{2 \cdot r_{Kugel} + s}} = 4,04pF.$$
(3.4)

Messtechnisch bei einer Frequenz von 1 kHz wurde für den Stichprobenumfang jedoch  $C_P \approx 3, 1pF - 3, 3pF$  ermittelt.

Mit Hilfe der verwendeten Geometriedaten besteht die Möglichkeit, die minimale Einsetzfeldstärke der Fehlstelle  $E_Z$  bzw. die minimale Einsetzspannung  $U_Z$  der gesamten Prüflingsanordnung zu berechnen.

Der Zusammenhang zwischen dem äusseren, homogenen Feld  $E_A$  und dem Feld im Zylindereinschluss  $E_I$  wurde in [Hal54] untersucht und formuliert durch:

$$\frac{E_I}{E_A} = grad\varphi_0 \cdot s = \frac{\left[\left(\frac{\epsilon_{r/A}}{\epsilon_{r/I}} - 1\right) \cdot \frac{h_{Fehl}}{s} + 1\right] \cdot \frac{\epsilon_{r/A}}{\epsilon_{r/I}} \cdot \left(\frac{d}{h_{Fehl}}\right)^{3/2} + \left(\frac{\epsilon_{r/A}}{\epsilon_{r/I}}\right)^{1,6}}{\left[\left(\frac{\epsilon_{r/A}}{\epsilon_{r/I}} - 1\right) \cdot \frac{h_{Fehl}}{s} + 1\right]^2 \cdot \left(\frac{d}{h_{Fehl}}\right)^{3/2} + \left(\frac{\epsilon_{r/A}}{\epsilon_{r/I}}\right)^{1,6}}.$$
(3.5)

Dabei ist s der Elektrodenabstand, d der Zylinderdurchmesser,  $h_{Fehl}$  die Zylinderhöhe,  $r_{Fehl}$  der Zylinderradius,  $\epsilon_{r/I}$  die relative Dielektrizitätszahl des Füllmaterials der Fehlstelle (Luft) und  $\epsilon_{r/A}$  die relative Dielektrizitätszahl des umgebenden Dielektrikums.

Werden für die geometrischen Abmessungen die Werte der Abbildung 3.15 und eine relative Dielektrizitätszahl  $\epsilon_{r/A} = 3.8$  für das verwendete Epoxydharz bzw.  $\epsilon_{r/I} = 1$  für Luft zugrunde gelegt, ergibt sich das Verhältnis der Feldstärken zu

$$\frac{E_I}{E_A} \approx 2. \tag{3.6}$$

Da das äussere Feld nur näherungsweise homogen ist, muss der Feldausnutzungsfaktor  $\eta_S \approx 0,967$  korrigierend eingebracht werden. Die Gleichung 3.5 ist das Ergebniss einer Regressionsrechnung bei der relative Abweichungen von bis zu 10 % auftreten können. Um das Ergebnis zu bekräftigen, wurden zusätzlich Simulationen mit den FEM- Programmen ANSYS und Maxwell 3D durchgeführt. Hiermit wurde ein Feldstärkeverhältnis von 2,3 erzielt und somit das Ergebnis verifiziert.

Die Bestimmung der minimalen Einsetzfeldstärke  $E_Z$  der zylinderförmigen Fehlstelle lässt sich aus der Bedingung für die Entstehung von Sekundärelektronen herleiten. Ausgangsort für ein Startelektron soll die dielektrische Grenzschicht an der Kathode sein. Für die minimale Einsetzfeldstärke muss das Elektron die grösstmögliche Entfernung  $h_{Fehl}$  zurücklegen, eine kleinere Entfernung bedingt eine Zunahme der Einsetzfeldstärke. Wie bereits im Kapitel "Grundlagen" beschrieben, dominiert in Hohlräumen, die vom Dielektrikum vollständig umschlossen sind, die Photoemission die Sekundärelektronenerzeugung [Bey86]. Sollen ausreichend Sekundärelektronen  $N_{eSek}$  erzeugt werden, muss im Homogenfeld der Ansatz

$$N_{eSek} = \eta_{Ph} \cdot \delta \cdot \delta_{UV} \cdot \int_{z=0}^{z=h_{Fehl}} e^{\alpha_{eff} \cdot z} dz > 1$$
(3.7)

mit

- $\eta_{Ph}$  Photoionisationskoeffizient
- $\delta$  Korrekturfakor
- $\delta_{UV}$  Anregungskoeffizient
- $\alpha_{eff}$  Effektiver Ionisierungskoeffizient

nach [Kur92b] gelten. Der Anregungskoeffizient beträgt nach [Tei67]  $\delta_{UV} = 0,06$  für Luft unter Umgebungsdruck.

Da sich Photonen statistisch gleichverteilt in alle Raumrichtungen ausbreiten, muss der Korrekturfaktor  $\delta$  eingebracht werden, der den Anteil der tatsächlich wirkenden Photonen auf die dielektrische Grenzschicht zur Kathode beschreibt. Unter der Voraussetzung, dass ein Grossteil der Photonen erst unmittelbar am Ende der Driftstrecke  $h_{Fehl}$  entstehen, kann der Korrekturfakor über die beteiligten Flächen zu

$$\delta \approx \frac{\sqrt{r_{Fehl}^2 + h_{Fehl}^2 - h_{Fehl}}}{2 \cdot \sqrt{r_{Fehl}^2 + h_{Fehl}^2}} = 0,28$$
(3.8)

abgeschätzt werden. Nach [Kur92a] kann  $\eta_{Ph} = 0,1$  für Polyethylen angenommen werden. Ein Koeffizient für Epoxydharze konnte in der Literatur nicht ermittelt werden. Zur groben Ermittlung wurde mit dem oben genannten Wert gerechnet. Somit ergibt sich aus Gleichung 3.7 der effektive Ionisierungskoeffizient zu

$$\alpha_{eff} = 89.533 \frac{1}{m}.$$
(3.9)

Nach [Fro<br/>64] kann der Anlagerungskoeffizient  $\eta$ unter Umgebungsbeding<br/>ungen bestimmt werden zu

$$\eta = 7, 5 \cdot 10^{-3} \frac{Pa}{m} \cdot 1,013 \cdot 10^5 Pa = 759,75 \frac{1}{m}.$$
(3.10)

Damit lässt sich nach [Gän53] die minimale Einsetzfeldstärke  $E_Z$  der Fehlstelle bestimmen.

$$E_Z = -\frac{C_1}{\ln\left(\frac{\alpha_{eff} + \eta}{C_2}\right)} = -\frac{19, 3 \cdot 10^6 \frac{V}{m}}{\ln\left(\frac{\alpha_{eff} + \eta}{0,654 \cdot 10^6}\right)} = 9,75\frac{kV}{mm}$$
(3.11)

Dabei gelten die beiden Koeffizienten  $C_1$  und  $C_2$  für den Feldstärkebereich 2,74 $kV/mm \leq E \leq 13,7kV/mm$ . Mit Berücksichtigung des Feldausnutzungsfaktors  $\eta_S \approx 0.967$  ergibt sich für die minimale Einsetzspannung  $U_Z$ 

$$4, 1kV \le U_Z \le 4, 7kV \tag{3.12}$$

falls das Feldstärkeverhältnis von 2 bis 2,3 angenommen wird. Da die Einsetzspannung selbst einer Furry- Verteilung unterliegt [Bru91], streut sie um den ermittelten Bereich. Die berechneten und gemessenen Einsetzspannungen decken sich und werden im nächsten Kapitel näher betrachtet.

Eine zweite, vergleichende Möglichkeit ergibt aus [Kur93]. Die Paschen- Kurve soll hier nicht zur Anwendung kommen, da sie massgeblich durch den 2. Townsendschen Ionisationskoeffizienten  $\gamma$  bestimmt wird. Dieser kann nach [Mor93] jedoch für Kunststoffoberflächen von den Werten für Metalloberflächen abweichen. Es bietet sich an, die Einsetzfeldstärke  $E_Z$  aus dem Streamer-Kriterium abzuleiten. Demnach können regelmässige Entladungen innerhalb der Fehlstelle nur auftreten, wenn sich entlang der Fehlstellenhöhe  $h_{Fehl}$  eine Elektronenlawine von mindestens 10<sup>6</sup> Elektronen ausbilden kann. Mit dem Ansatz

$$10^6 = e^{\alpha \cdot h_{Fehl}} \tag{3.13}$$

und der Gleichung 3.11 ergibt sich eine Einsetzfeldstärke von  $E_Z = 8, 6 \frac{kV}{mm}$ , was eine Abweichnung von ca. 10% zum Ergebnis aus Gleichung 3.11 darstellt.

### 3.3.1.2 Die Prüflingsart P2

Für die Prüflingsarten P2 und P4 wurde die gleiche Elektrodengrundanordnung verwendet. Abbildung 3.16 zeigt die geometrischen Abmessungen beider Prüflingsarten.



Abbildung 3.16: Übersichtsskizze Prüflingsart P2 und P4

Für den Prüfling mit an die Elektrode angrenzender Fehlstelle wurde die Isolieranordnung mittig aufgeschnitten und asymmetrisch gemäss Abbildung 3.17 abgedreht. Hiernach wurde eine Sacklochbohrung von 0,4 mm Tiefe auf der Symmetrieachse einer Kugelelektrode eingebracht, welche den Elektrodenpol punktuell berührt. Nach dem Verkleben der zuvor getrennten Isolieranordnung ausserhalb der Schnittflächen unter Umgebungsbedingungen entstand ein zylinderförmiger Einschluss mit einer planen Deckfläche und einem kegelförmigen Abschluss mit einem Öffnungswinkel von 120°. Der Kegel hat ebenfalls einen kugeligen Abschluss.



Abbildung 3.17: Vergrösserter Ausschnitt der Fehlstelle von P2



Abbildung 3.18: Realisierung der Prüflingsarten P1, P2 und P4

Nach [Kor89] ergibt sich für die Kapazität der Anordnung näherungsweise

$$C \approx \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon}{\frac{1}{r_{Kugel}} - \frac{1}{2 \cdot r_{Kugel} + s}} = 3,95pF,$$
(3.14)

gemessen wurden ebenfalls kleinere Werte $C\approx 2,8pF-3,1pF$ bei einer Frequenz von 1 kHz.

Eine geschlossene mathematische Lösung zur Berechnung der minimalen Einsetzfeldstärke  $E_Z$ , vergleichbar mit dem Ergebnis für die Prüflingsart P1, schliesst sich aufgrund des inhomogenen Feldverlaufs in der Fehlstelle aus. Möglichkeiten liefern hier die bereits angesprochenen FEM Simulationsprogramme.

### 3.3.1.3 Die Prüflingsart P4

Eine weitere Prüflingsanordnung mit quasihomogenem Feldverlauf und allseitiger Umhüllung der Fehlstelle stellt die Prüflingsart P4 dar (siehe Abbildung 3.19).



Abbildung 3.19: Vergrösserter Ausschnitt der Fehlstelle von P4

Hierfür wurde die Isolieranordnung der Abbildung 3.16 symmetrisch aufgetrennt und beidseitig auf den halben Elektrodenabstand s = 0.75 mm abgedreht. Im Anschluss wurden 2 Fehlstellen (Sacklochbohrungen) mit einem 0.8 mm Spiralbohrer auf jeder Seite der Schnittfläche eingebracht. Hierbei wurden die Fehlstellen mit einem Versatz mit ca. 0,1 mm bis 0,2 mm zur Symmetrieachse der Kugelelektrode gebohrt. Durch die geringe Eintauchtiefe von 0,2 mm entstanden kegelförmige Fehlstellen mit einem Radius  $r_{Fehl} = 0.35$  mm am Kegelfuss. Der Öffnungswinkel des Kegels beträgt 120°. Des Weiteren formt sich durch die beiden Schneiden des Bohrers ein kugeliger Abschluss an der Spitze des Öffnungswinkel. Nach dem Verkleben der beiden Hälften der Isolieranordnung ausserhalb der Schnittflächen und zusätzlicher Abdichtung mit Silikon unter Umgebungsbedingungen beträgt die gesamten Fehlstellenhöhe  $h_{Fehl} = 0,4$  mm.

Für diese Anordnung ergibt sich ebenfalls nach [Kor89] die Kapazität näherungsweise zu

$$C \approx \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon}{\frac{1}{r_{Kugel}} - \frac{1}{2 \cdot r_{Kugel} + s}} = 3,95pF.$$
(3.15)

Bei einer Messfrequenz von 1 kHz wurden Werte im Bereich  $C \approx 2, 8pF - 3, 0pF$  ermittelt.

### 3.3.2 Prüfling mit inhomogenem Grundfeldverlauf P3

Da stets auch inhomogene elektrische Felder an Stromrichterverschienungen auftreten, muss auch dieser Fall untersucht werden. Dabei handelt es sich um eine Anordnung mit Spitzenelektrode gegenüber einer Kugelelektrode (Abbildung 3.20).



Abbildung 3.20: Übersichtsskizze P3

Bei Annahme einer Hyperboloidspitze gegenüber einer Ebene mit einem Elektrodenabstand von s= 1,25mm und einem Spitzenwinkel  $\gamma_S$ = 24,2° ergibt sich nach [Pri69] ein Ausnutzungsfaktor von

$$\eta_S = \sin\frac{\gamma_S}{2} \cdot \tan\frac{\gamma_S}{2} \cdot \ln\left(\cot\frac{\gamma_S}{4}\right) \approx 0, 1.$$
(3.16)

Beide Elektroden wurden ebenfalls in einem hinlänglich grossen Gehäuse (Abbildung 3.20) mit Epoxydharzgemisch aus Harz CW 1301 und Härter HY 1301 vergossen und im Vakuumschrank ausgehärtet. Der Elektrodenabstand betrug



Abbildung 3.21: Vergrösserter Ausschnitt der Fehlstelle von P3

hierbei s= 1 mm. Während der Gelierphase wurde die Spitzenelektrode um 0,25 mm nach aussen versetzt, sodass der Elektrodenabstand s= 1,25 mm betrug. Es entstand eine spitzwinklige Fehlstelle direkt im Bereich des hochbelasteten Feldraumes (Abbildung 3.21).

# Kapitel 4

# Darstellung und Interpretation der Messergebnisse

Dieses Kapitel legt die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen dar. Zunächst wird gezeigt, mit welchen Mitteln der Statistik die Versuchsreihen ausgewertet werden, wobei der Begriff der Teilentladungswahrscheinlichkeit erklärt wird. Anschliessend wird allgemein des Teilentladungsverhalten und der Einfluss kontinuierlicher Teilentladungen diskutiert.

Den wesentlichen Teil nimmt die Untersuchung mit Pulsspannung mit den Parametern Gleichanteil der Pulsspannung, Pulsbreite, Pulsfolgefrequenz und Anstiegszeit ein, wobei jeweils im Anschluss die Ergebnisse interpretiert werden. Daneben wird auch der Einfluss von einzelnen Impulsen aufgezeigt.

Abschliessend wird das Teilentladungsverhalten bei sinusförmiger Wechselspannung herausgearbeitet und ins Verhältnis zu den gewonnenen Erkenntnissen aus der Pulsspannungsuntersuchung gesetzt.

## 4.1 Statistische Versuchsauswertung

Um das Teilentladungsverhalten der Modellisolierungen bei den zu untersuchenden Parametern zu beschreiben, wurde die Teilentladungseinsetzspannung  $U_{PD/inc}$  als stetige Zufallsgröße statistisch ausgewertet. Da für die jeweiligen Messserien die äusseren Einflussparameter, bis auf die Spannungshöhe, konstant gehalten wurden, sind die mehr oder weniger grossen Streuungen der Teilentladungseinsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zufälliger Natur und damit ein Kennzeichen des zufälligen Charakters des Gasentladungsprozesses. Somit ist für die Versuchsauswertung die Anwendung statistischer Methoden möglich.

### 4.1.1 Unabhängigkeit von Messwerten

Eine statistische Auswertung einer Messreihe, welche als eine Stichprobe aufzufassen ist, ist nur zulässig, wenn die einzelnen Messwerte voneinander unabhängige Ergebnisse darstellen [Hau84]. Beeinflussen sich beispielsweise Versuchsergebnisse untereinander, besteht die Wahrscheinlichkeit einer Fehlinterpretation einer Messreihe.

Prinzipbedingt besteht beim mehrfachen Untersuchen eines Prüflings auf Teilentladungen das Problem der Abhängigkeit der Einzelversuche. Trotz des schädigungsarmen Prüfverfahrens, verursacht dieses kurzfristige und dauerhafte physikalische Veränderungen im Isolierstoff, welche teilweise nicht rückgebildet werden können. Neben den mechanischen und chemischen Einwirkungen auf die Fehlstellengrenzflächen beeinflussen zurückbleibende Raum- und Oberflächenladungen die Feldverteilung innerhalb der Fehlstelle. Genügend große Pausenzeiten zur möglichst identischen Wiederherstellung der Ausgangsbedingungen und ein Test auf Unabhängigkeit sind somit unerlässlich.

Positiv auf die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Messergebnisse wirken sich die durchgeführten Spannungssteigerungsversuchen aus [Hau84]. Es werden zumindest für die beanspruchende Spannung identische Ausgangsbedingungen geschaffen, da sie stets nach Teilentladungseinsatz auf Null abgesenkt wurde.

Für die Prüfung auf Unabhängigkeit sind grafische und rechnerische Verfahren möglich [Hau84, Sac78]. Für das grafische Verfahren wird die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  (Zufallsgröße) mehrfach für einen Prüfling bei identischen Ausgangsbedingungen ermittelt und in der Reihenfolge ihres Auftretens grafisch dargestellt.

Schwanken die Messwerte um einen Mittelwert  $U_{PD/inc/50}$ , besteht kein Bedenken gegen die Annahme der Unabhängigkeit. In Abbildung 4.1 wird die Stichprobe eines Prüflings der Prüflingsart P1 grafisch dargestellt. Die Messwerte schwanken zufällig um den Mittelwert  $U_{PD/inc/50}$  in einem Bereich von etwa  $\pm 2$ s, wobei s die Standardabweichung ist.



Abbildung 4.1: Grafische Darstellung der Unabhängigkeit anhand einer Stichprobe der Prüflingsart P1

Um die grafische Kontrolle zu untermauern, empfiehlt sich ein Iterationstest nach [Sac74]. Hierzu werden die Differenzen des jeweiligen Messergebnisses in der Reihenfolge ihres Auftretens mit dem Mittelwert gebildet. Anschliessend wird das Vorzeichen dieser Differenz bewertet. In diesem Fall wird mit jedem Auftreten eines positiven Vorzeichens k inkrementiert. Jede Gruppierung eines gleichartigen Vorzeichens entspricht einem Iterationsschritt.

Nr.	TE- Einsetzspannung	Vorzeichen von	Anzahl pos.	Iterationen
ν	$U_{PD/inc/ u}/{ m kV}$	$U_{PD/inc/\nu} - U_{PD/inc/50}$	Vorzeichen	
		$U_{PD/inc/50}$ =4,92kV	k	r
1	4,91	-		1
2	$5,\!00$	+	1	2
3	4,89	-		3
4	4,81	-		
5	4,83	-		
6	4,81	-		
7	4,83	-		
8	$5,\!00$	+	2	4
9	$5,\!03$	+	3	
10	4,87	-		5
11	$5,\!00$	+	4	6
$\overline{12}$	4,88	-		7

Nr.	TE- Einsetzspannung	Vorzeichen von	Anzahl pos.	Iterationen
ν	$U_{PD/inc/ u}/{ m kV}$	$U_{PD/inc/\nu} - U_{PD/inc/50}$	Vorzeichen	
		$U_{PD/inc/50}$ =4,92kV	k	r
13	5,00	+	5	8
14	4,81	-		9
15	4,81	-		
16	4,75	-		
17	5,00	+	6	10
18	4,88	-		11
19	5,00	+	7	12
20	4,88	-		13
21	4,81	-		
22	5,08	+	8	14
23	5,10	+	9	
24	4,88	-		15
25	5,00	+	10	16
26	4,88	-		17
27	5,06	+	11	18
28	4,81	-		19
29	4,97	+	12	20
30	5,07	+	13	
31	5,00	+	14	

Tabelle 4.1: Anwendung des Iterationstests auf eine Stichprobe der Prüflingsart P1

Für einen gegebenen Stichprobenumfang n deutet eine kleine Anzahl an Iterationen r auf Klumpungen hin. Große r - Werte zeigen häufige Wechsel auf. Beide Extremale weisen auf Abhängigkeiten hin.

Soll bei diesem zweiseitigen Test die Hypothese auf Unabhängigkeit überprüft werden, muss die Anzahl der Iterationen r zwischen einer unteren und oberen Grenze liegen. Die entsprechenden Schranken können für kleine Stichprobenumfänge aus Tabellen in [Sac74] nachgeschlagen werden. Im oben aufgeführten Beispiel ergeben sich die Schranken bei einer statistischen Aussagesicherheit von 95% auf Unabhängigkeit zu

$$r_u = 10 \le r \le r_o = 23$$

Die Stichprobe darf damit als zufällig angesehen werden.

## 4.1.2 Die Verteilungsfunktion

Will man Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Teilentladungen bei verschiedenen Spannungswerten ermitteln, können diese aus der empirischen Verteilungsfunktion - der relativen Summenhäufigkeit der einzelnen Messwerte einer Stichprobe - geschätzt werden.

Für eine genauere mathematische Betrachtung wird die empirische Verteilungsfunktion mit einer theoretischen Verteilungsfunktion approximiert. Die Anpassung und die Bestimmung der entsprechenden Parameter der theoretischen Verteilungsfunktion kann aus der grafischen Darstellung im Wahrscheinlichkeitspapier entnommen, mittels rechnerischer Verteilungsprüfungen oder durch Schätzung ermittelt werden [Car90, Hau84, Sac78].

Eine geeignete Möglichkeit bietet die grafische Darstellung im Wahrscheinlichkeitsnetz. Dazu werden den einzelnen Messwerten einer Stichprobe Summenhäufigkeiten zugewiesen und diese in das Wahrscheinlichkeitspapier übertragen. Für Stichprobengrössen von n=6 bis n=30 wurden die benötigten Häufigkeiten [Joh70] entnommen. Größere Stichprobengrössen erforderten die Ermittlung der relativen Summenhäufigkeiten über die primäre Verteilungstafel [Hau84, Sac78].

Die Approximation der empirischen Verteilungsfunktion erscheint im Wahrscheinlichkeitspapier als Gerade, siehe Abbildung 4.2. In Zusammenhang mit dem 95% Vertrauensbereich nach [Joh70] kann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% bestimmt werden, ob die empirische Verteilungsfunktion die theoretischen Verteilungsfunktion hinreichend abbildet.



Abbildung 4.2: Prüfung auf Normalverteilung im Wahrscheinlichkeitspapier der Prüflingsart P1

Für die Anpassung der empirischen an die theoretische Verteilungsfunktion gelten nach [Hau84] folgende Grundsätze:

- eine ausreichend genaue Näherung, aber keine unnötig komplizierte Approximation
- inhaltliche Zuordnung der Verteilungsfunktion zu der physikalischen Modellvorstellung

Eine vorteilhafte Anwendung für Gasentladungen stellt die Gauss'sche Normalverteilung dar [Hau84, Kah89], welche durch die theoretische Verteilungsfunktion

$$\Phi = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}dt}$$
(4.1)

mit den Parametern  $\mu$  Mittelwert  $\sigma$  Standardabweichung

beschrieben wird. Eine Möglichkeit der Bestimmung der Parameter  $\mu$  und  $\sigma$ aus der empirischen Verteilungsfunktion kann über die Schätzung aus den Gleichungen 4.2 und 4.3 erfolgen. Der arithmetische Mittelwert der Spannungswerte  $U_{50}$  und die Standardabweichung s einer Stichprobe mit dem Umfang von k Elementen ergeben sich zu

$$U_{50} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{n=1}^{k} U_n \tag{4.2}$$

bzw.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{n=1}^{k} (U_n - U_{50})^2}.$$
(4.3)

Mit der Bedingung  $n \to \infty$  gehen die beiden Parameter  $U_{50}$  und s in die Parameter  $\mu$  und  $\sigma$  der theoretischen Verteilungsfunktion über.

Da immer nur eine begrenzte Anzahl n an Stichproben zur Verfügung steht, kann die Bestimmung des Mittelwertes und der Standardabweichung über die Gleichungen 4.2 und 4.3 fehlerbehaftet sein. Eine genauere Methode arbeitet mit der Ermittlung einer Regressionsfunktion nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Sie liefert damit eine Prüfmöglichkeit für die ermittelten Werte von Mittelwert  $U_{50}$  und Standardabweichung s aus den Gleichungen 4.2 und 4.3. Die lineare Regressionsfunktion wird durch

$$z = b \cdot U + a \tag{4.4}$$

beschrieben. Die beiden Regressionskoeffizienten a und b berechnen sich nach [Sac78] zu

$$a = \frac{\sum z_n - b \cdot \sum U_n}{n} \tag{4.5}$$

bzw.

$$b = \frac{n \cdot \sum (U_n \cdot z_n) - \sum U_n \cdot \sum z_n}{n \cdot \sum U_n^2 - (\sum U_n)^2}.$$
(4.6)

wobei <br/>n der Stichprobenumfang ist und  $z_n$ aus der Invertierung der Normalverteilungsfunktion ableit<br/>bar ist. In der Polynomapproximation nach [Abr72] ist

$$z_n = t - \frac{2,515517 + 0,802853 \cdot t + 0,010328 \cdot t^2}{1 + 1,432788 \cdot t + 0,189269 \cdot t^2 + 0,001308 \cdot t^3} + \epsilon$$
(4.7)

 $\operatorname{mit}$ 

$$t = \sqrt{\ln \frac{1}{(\Phi(z_n))^2}}.$$
(4.8)

Der Fehler $\epsilon$ ist betragsmässig <br/>  $5\cdot10^{-4}$ und kann daher vernachlässigt werden. Der Mittelwer<br/>t $U_{50}$ ergibt sich für z=0zu

$$U_{50} = -\frac{a}{b}.$$
 (4.9)

Für die Standardabweichung <br/>s muss die Bedingung z $=\pm$ 1 gelten. Daraus folgt

$$s = U_{z=0} - U_{z=-1} = \frac{1}{b} \tag{4.10}$$

Eine Möglichkeit die Güte der Anpassung zu prüfen bietet das Bestimmtheitsmass  $r^2$ .

$$r^{2} = \frac{(\sum (U_{n} \cdot z_{n}) - \frac{1}{n} \cdot \sum U_{n} \cdot \sum z_{n})^{2}}{(\sum U_{n}^{2} - \frac{1}{n} \cdot (\sum U_{n})^{2}) \cdot (\sum z_{n}^{2} - \frac{1}{n} \cdot (\sum z_{n})^{2})}$$
(4.11)

Je näher  $r^2$  an 1 liegt, desto besser ist die Anpassung. In der vorliegenden Arbeit wurde mit  $r^2 > 0.9$  eine befriedigende Anpassung der empirischen an die theoretische Verteilungsfunktion erzielt.

### 4.1.3 Bereinigung von Stichproben

Gelegentlich treten Stichprobenwerte auf, die scheinbar nicht zur Grundgesamtheit dieser Stichprobe gehören. Diese fehlerhaften und somit abhängigen Spannungswerte  $U_F$ , sogenannte Ausreisser, müssen aus der Stichprobe eliminiert werden und stehen für die weitere statistische Auswertung nicht mehr zur Verfügung [Hau84].

In einer empirischen Verteilungsfunktion, die der Normalverteilung gehorcht, muss jeder Wert die Bedingung

$$W_{n;\alpha} > \left| \frac{U_F - U_{50}}{s} \right| \tag{4.12}$$

erfüllen. Dieser Grenzwert  $W_{n;\alpha}$  kann in Abhängigkeit des Signifikanzniveaus  $\alpha$  und der Stichprobenmenge n aus [Mue73] entnommen werden.

# 4.2 Einflussgrössen rechteckförmiger Puls- und Impulsspannung

Alle Darstellungen der Teilentladungseinsetzspannung  $U_{PD/inc}$  über die zu untersuchenden Parameter werden in der vorliegenden Arbeit identisch ausgeführt. Die Diagramme besitzen einen unterdrückten Nullpunkt und stellen die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  im Bereich von 3 kV bis 10,5 kV dar. Hierbei ist allerdings bei 10,3 kV die technische Grenze der Spannungsversorgung erreicht, sie stellt die obere Schranke dar. Allen Graphen ist die Darstellung des arithmetischen Mittelwertes  $U_{PD/inc/50}$  gemein, welche um den beidseitigen Streubereich der Standardabweichung s ergänzt sind.

## 4.2.1 Teilentladungswahrscheinlichkeit und Teilentladungsverhalten bei Pulsspannung

### 4.2.1.1 Teilentladungswahrscheinlichkeit

Charakteristisch für den Teilentladungseinsatz bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung ist, dass nicht unmittelbar jede Pulsbelastung zur Entwicklung einer Teilentladung führt. Die Abbildungen 4.3 bis 4.6 zeigen die Verhaltensfunktionen der einzelnen Prüflingsarten P1 bis P4 bei monopolarer Spannungsbeanspruchung.



Abbildung 4.3: TE- Häufigkeiten und Verhaltensfunktion der TE- Wahrscheinlichkeit der Prüflingsart P1 (20 Prüflinge) bei  $f_W = 2000$  Hz,  $t_R \approx 950$  ns und a = 0.5

Erkennbar ist, dass bei Steigerung der Amplitude der Pulsspannung die relative Häufigkeit der Teilentladungen zunimmt. Darüber hinaus konnte bei den Spannungssteigerungsversuchen festgestellt werden, dass die Zündzeitpunkte sich mit Spannungssteigerung in Richtung des Stirnbereiches der Pulsspannung verschieben.



Abbildung 4.4: TE- Häufigkeiten und Verhaltensfunktion der TE- Wahrscheinlichkeit der Prüflingsart P4 (15 Prüflinge) bei  $f_W = 2000$  Hz,  $t_R \approx 950$  ns und a = 0.5

Bereits in [Gän53] wurde dieses Phänomen bei Gasentladungen beschrieben und mit dem Zündverzug  $t_D$  erklärt. Anhand der Verhaltensfunktionen lassen sich nach [Kau94] 3 Spannungsbereiche einteilen.

Unterhalb einer unteren Grenze führt keine Pulsbelastung zur Ausprägung einer Teilentladung. Überschreitet die Amplitude der Pulsspannung eine obere Grenze findet mindestens eine Teilentladung je Pulsbelastung statt. Innerhalb der beiden Schranken beträgt die relative Häufigkeit des Teilentladungsereignisses zwischen 0 % und 100 %. Dieser mittlere Bereich charakterisiert die Prüflingsart.

Die Neigung der Verhaltensfunktion kennzeichnet die statistische Streuung des Gasentladeprozesses jedes Einzelindividuums. Hinzu kommt die Streuung des Fertigungsprozesses was eine Parallelverschiebung der Verhaltensfunktion bewirkt. Hierbei überlagern sich beide Grössen nicht äquivalent. Die Prozessstreuung ist ca. um den Faktor 2 grösser, als die Streuung des Entladeprozesses.



Abbildung 4.5: TE- Häufigkeiten und Verhaltensfunktion der TE- Wahrscheinlichkeit der Prüflingsart P2 (15 Prüflinge) (P2+ oben, P2- unten) bei $f_W = 2000$  Hz,  $t_R \approx 950$ ns und a<br/>=0.5



Abbildung 4.6: TE- Häufigkeiten und Verhaltensfunktion der TE- Wahrscheinlichkeit der Prüflingsart P3 (6 Prüflinge) (P3+ oben, P3- unten) bei $f_W = 2000$  Hz,  $t_R \approx 950$ ns und a= 0,5

#### 4.2.1.2 Teilentladungsverhalten

Belastet man eine Isolieranordnung mit dielektrischen Grenzschichten an den Elektroden mit Pulsen, wird ausgehend vom zunächst raumladungsfreien Laplace- Feld in der Fehlstelle, entsprechend der kapazitiven Verhältnisse, die elektrische Feldstärke  $E_I$  in der Fehlstelle der aussen an die Modellisolierung angelegten Spannung  $U_A$  (siehe Abbildung 4.7 linkes Bild) folgen.

Nach [Bru91] kann vernachlässigt werden, dass Ladungsträger aus Ionisationsvorgängen durch natürliche Strahlung generiert werden. Somit kann zunächst für eine bis dato unbelastete Anordnung von einer verschwindend geringen Anzahl freier Ladungsträger im Volumen der Fehlstelle ausgegangen werden.



Positive Ladungsträger

Abbildung 4.7: Oberflächenladungsaufbau an den Grenzflächen der Fehlstelle

Mit Steigerung der angelegten Spannung  $U_A$  driften diese wenigen Ladungsträger entsprechend ihrer Polarität zu den Grenzflächen. Überschreitet die Feldstärke  $E_I$  die Grenze

$$E_I > 2,44 \frac{kV}{mm \cdot bar} \cdot p = E_{Ion} \tag{4.13}$$

überwiegt der Stossionisierungskoeffizient  $\alpha$  gegenüber dem Anlagerungskoeffizienten  $\eta$  und es werden per saldo Ladungsträger, Elektronen und Ionen, durch Stossionisierung gebildet [Bey86]. Wie aus der Gasentladungskennlinie ablesbar ist, werden bereits unterhalb der Ionisierungsfeldstärke  $E_{Ion}$  Ladungsträger erzeugt, die bei Metallelektroden aus dem Feldraum entzogen werden. Da dieser Vorgang in der Fehlstelle nicht stattfinden kann, stehen diese Ladungsträger zusätzlich zur Verfügung.

Des Weiteren besteht nach [Kau94] die Möglichkeit, dass Ladungsträger aus dem Feststoff zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls unterstützend wirken Mikroentladungen an Oberflächen von Dielektrika [Fic03, Fuj89, Kae76]. Fertigungsbedingt ergeben sich an der Fehlstellenoberfläche Inhomogenitäten, welche lokal die Feldstärke erhöhen und die Generation von Ladungsträgern begünstigen. Eine geringfügige Feldentlastung in der Fehlstelle wird durch die Zuführung von Elektronen durch Injektion aus der Kathode sowie die Anlagerung von freien Ladungsträgern aus dem Gasraum der Fehlstelle erzielt. Beide Vorgänge sind nur ungenügend ergiebig bzw. die Injektion läuft langsam ab [Bru91, Sjö00]. Da bei all diesen Vorgängen nur eine geringe Anzahl von Ladungsträgern erzeugt bzw. bewegt werden, sind sie mit der zur Verfügung stehenden Messtechnik nicht detektierbar. Diese Präsumtion wurde bereits in [Kau94] geäussert.

Die bereits vorhandenen bzw. erzeugten Ladungsträger wandern aufgrund der Kraftwirkung des elektrischen Feldes zur jeweiligen Grenzfläche der Fehlstelle und lagern sich dort ab. Der hohe spezifische Widerstand (bei  $\vartheta = 20^{\circ}$ C beträgt  $\rho \approx 10^{12} - 10^{14}\Omega m$ ) des Epoxydharzes verhindert ein sofortiges Abfliessen der Ladungsträger und führt zur Akkumulation auf den Grenzflächen. Das entstandene Poisson- Feld der Raumladungen wirkt dem Laplace- Feld entgegen und setzt die Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  herab. Gleichzeitig erhöht sich die elektrische Feldstärke in den Feststoffdielektrika.

Für statische und langsam veränderliche Felder findet dieser Vorgang mindestens solange statt, bis der Grenzwert von  $E_I < 2,44$  kV/mm unterschritten wird und alle freien Raumladungen an den dielektrischen Grenzflächen abgelagert sind. Der Anlagerungskoeffizient  $\eta$  überwiegt und die Ladungsträgergeneration erlischt (siehe Abbildung 4.7 rechtes Bild). Der gesamte Vorgang bedarf aufgrund der endlichen Geschwindigkeit der Ladungsträger entsprechend Zeit.

Die akkumulierten Ladungen auf der Epoxydharzoberfläche verteilen sich inhomogen [Koe81] und bleiben auch nach Abgeschalten der Elektrodenspannung eine Zeit lang erhalten [Cav05, Fan96, Fuj89, Nev96]. Das Aufladen von Kunststoffen ist ein bekannter Vorgang und für verschiedene Spannungsformen nachgewiesen [Ble00, Fan96, Fuj89, Schm89, Sjö01, Win03]. Die physikalisch Theorie zur Aufladung von Kunststoffoberflächen wird in diversen Literaturstellen beschrieben [Bla91, Cav05, Caz96, Fan96, Mue99, Nem03, Win03], ist aber in Gänze noch nicht geklärt. [Bla91, Caz96, Fan96] gehen davon aus, dass elektrische Ladungsträger nach Entladungen im Bereich der Isolierstoffoberfläche aufgrund ihrer hohen thermischen Energie an Isolierstoffmoleküle gebunden werden. Ladungen gelangen so bei starker Anregung, z.B. durch Durchschläge und Gleitentladungen, in tiefe Haftstellen, bei Koronaentladungen in flache Haftstellen. Folglich bedarf das Herauslösen dieser Ladungen Energien bis in den eV- Bereich (geometrische Eindringtiefe bis ca. 9  $\mu$ m [Bla91]). Es wirken demnach Bindungskräfte auf Ladungen an Isolierstoffoberflächen.

Berücksichtigt man diesen Aufladevorgang ergeben sich schematisch folgende Verläufe für einen Spannungssteigerungsversuch mit monopolarer Pulsspannung  $U_A = U_{Puls}$ .



Abbildung 4.8: Zeitabhängigkeit des Aufladevorganges bei monopolarer Pulsspannung (schematisch)

Ohne eine genügende Zahl freier Ladungsträger folgt die Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  zunächst der Spannung an den Elektroden  $U_A$ . Überschreitet  $E_I$  die Ionisierungsfeldstärke  $E_{Ion}$  mindestens lokal, werden Ladungsträger gebildet. Durch die Feldstärkeabhängigkeit des Stossionisierungskoeffizient  $\alpha$  werden um so mehr Ladungsträger gebildet, je grösser die Feldstärke  $E_I$  ist. Die angelagerten Ladungsträger entlasten das Feld durch eine entgegengesetzte Überlagerung von Laplace- und Poisson-Feld.

Die Feldschwächung durch Ionisation bedarf einer endlichen Zeit, da in den ersten Perioden des Spannungssteigerungsversuchs relativ geringe Feldstärken in der Fehlstelle erreicht werden. Eine grosse Anzahl von Ladungsträgern durch Stossionisation wird nach dem exponentiellen Ansatz für den Streamerdurchschlag erst im Bereich der Durchschlagfeldstärke erzeugt. Gleichzeitig beginnt ein kontinuierlicher Ladungsabbau über das Epoxydharz, welcher bedingt durch den grossen Isolationswiderstand erst im Stundenbereich abgeklungen sein kann. Sowohl die Ladungsträgergeneration durch Ionisierungsvorgänge, als auch der Ladungsabbau über den Isolierstoff war mit der eingesetzten Messtechnik nicht detektierbar.

Sinkt die Spannung an den Elektroden auf Null ab, werden die Oberflächenladungen gehalten. Das Verbleiben der Oberflächenladungen q auf den dielektrischen Grenzflächen ohne merklichen Verlust dauert nach eigenen Messungen mindestens bis in den Bereich einer Stunde. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle Ladungen q an den Grenzflächen haften bzw. in den Isolierstoff diffundieren, sondern rekombinieren bzw. in den Gasraum der Fehlstelle abwandern. Durch die Trägheit und der damit verbundenen geringeren Beweglichkeit der Ionen findet ein Grossteil der Rekombinationen unmittelbar an der positiv geladenen Grenzfläche statt. Nach [Bey86] kann abgeschätzt werden, dass die Elektronen die Fehlstellenhöhe  $h_{Fehl}$  im ns- Bereich zurücklegen. Ionen benötigen dafür etwa 250 bis 500 mal so lange, sodass deren Bewegung vernachlässigt werden kann. Dieser Rekombinationsvorgang war mit der zur Verfügung stehenden Messtechnik nicht detektierbar.

Im Verlauf des Spannungssteigerungsversuchs wird schliesslich das Poisson-Feld die Ionisationsfeldstärke in der Fehlstelle in entgegengesetzter Richtung überschreiten, wenn die äussere Spannung  $U_A$  abgeschaltet ist. Es werden entsprechend dem oben beschriebenen Vorgang Ladungsträger durch Ionisation erzeugt, die ihrerseits das bereits existierende Poisson-Feld schwächen. Es entsteht ein eingeschwungener Zustand.

Das theoretische Modell des Aufladevorgangs konnte durch eigene Messungen verifiziert werden. Zunächst sollten Ladungsmessungen mittels einer Kapazitätssonde an den Schnittflächen nicht verfügter Modellisolierungen zeigen, dass während einer Spannungsbelastung Ladungsträger an den Grenzflächen akkumuliert werden. Von diesen Grenzflächen wird angenommen, dass sie ähnliches Verhalten zeigen wie die Fehlstellengrenzflächen selbst.

Analog zu den Messungen mit den verfügten Modellisolierungen wurden die beiden unverklebten Hälften der Isolieranordnung im Messkreis mit Gleichund Pulsspannung beaufschlagt. Durch die Zugänglichkeit der Epoxydgrenzflächen besteht die Möglichkeit, im Anschluss an die Belastung, den Aufladevorgang qualitativ zu erfassen. Die Messungen zeigten eine heteropolare Aufladung der Isolierstoffflächen bei Gleich- und Pulsspannung, da die Ionisationsfeldstärke  $E_{Ion}$  in der Fehlstelle überschritten wurde. Die Amplituden waren unterhalb der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  gewählt, da die Ladungsträgergeneration von Teilentladungen ausgeschlossen werden sollte.

Die Fragestellung, inwiefern diese Oberflächenladungen auf den Grenzflächen haften, konnte mit der vorgenannten Anordnung ebenfalls qualitativ untersucht werden. Bei geringen Haftkräften wäre keine bzw. eine geringe Gegenspannung ausreichend, die Ladungsträger von den Oberflächen zu lösen und somit den Abbau des Poisson-Feldes einzuleiten.

Mit Impulsen variabler Impulsbreite, die in Richtung des Poisson-Feldes der Oberflächenladungen wirkten, sollte der Abbau bzw. heteropolare Umbau dieses Feldes eingeleitet werden. Es zeigte sich, dass erst ab einer Feldstärke von  $E \approx 2..2, 5kV/mm$  zwischen den Isolierstoffgrenzflächen, hervorgerufen durch das Laplace- Feld, eine entgegengesetzte Aufladung detektiert werden konnte. Kleinere Feldstärken führten zu schwachen, detektierbaren Teilentladungsströmen, ergaben jedoch keine signifikante qualitative Veränderung des Poisson- Feldes. Ohne angelegte Spannung verbleiben die Ladungen an den Oberflächen und werden aufgrund der geringen Leitfähigkeit des Epoxydharzes erst im Stundenbereich abgebaut. Auch ohne vorhergehende Entladungserscheinung binden sich demzufolge Ladungsträger an die Isolierstoff-
grenzfläche. Finden darüber hinaus Mikroentladungen statt, muss die Feldstärke zum Ablösen der Oberflächenladungen nach [Caz96] entsprechend grössere Werte annehmen.

Darauf aufbauend wurde an Individuen der Prüflingsart P1 der Akkumulationsvorgang bei Pulsspannungen experimentell untersucht. Zunächst wurden die Prüflinge mit Pulsspannung im Bereich von 1 kV  $\leq U_{Puls} < U_{PD/inc}$  für ca. 30 s beaufschlagt und folglich innerhalb der Fehlstelle aufgeladen. Anschliessend wurde mit Impulsen gleicher Polarität der Teilentladungseinsatz ermittelt.

Es konnte festgestellt werden, dass unabhängig von der zuvor angelegten Pulsspannungsamplitude  $U_{Puls}$  eine relativ konstante Impulsspannungsamplitude  $U_{Impuls}$  - und damit TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  - gemessen wurde, um Teilentladungen einzuleiten.

Wurde der Teilentladungseinsatz mit Impulsen ohne vorherigen Aufladevorgang ermittelt, ergaben sich stets um ca. 500 V - 800 V kleinere Amplituden. Dieses Ergebnis deutet auf eine annähernd identische Oberflächenladung q in der Fehlstelle und einen stationären Zustand hin.

Bei Variation der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  der aufladenden Pulsspannung konnte des Weiteren festgestellt werden, dass die Oberflächenladungsdichte  $\sigma$  eine gewisse Abhängigkeit von der Pulsbreite  $t_P$  besitzt. So wurden bei grösseren Pulsbreiten  $t_P$  eine grössere Anzahl Oberflächenladungen q angelagert, was sich in einer höheren TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bemerkbar machte.

Bei weiterer Steigerung der Pulsspannung  $U_{Puls}$  ist die resultierende Feldschwächung aus der Ladungsträgererzeugung nicht mehr ausreichend und die Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  überschreitet die Festigkeit der Luftstrecke der Fehlstelle  $E_D$ . Nach einer gewissen Zeit, dem Entladeverzug  $t_{EV}$ , bildet sich eine lawinenartige Entladung nach dem Mechanismus des Streamerdurchschlags aus [Bar87, Gut95, Küc96, Nov00]. Diese Teilentladung führt gemeinsam mit dem zuvor beschriebenen Aufladevorgang zu einer weiteren Ladungsträgerakkumulation an den Grenzflächen der Fehlstelle und damit zu einer Reduktion der Feldstärke  $E_I$ . Dies stellt schematisch Abbildung 4.9 dar.

Während der ersten beiden Perioden beim dargestellten Verlauf soll zunächst nur eine geringe Überspannung anliegen und damit eine schwache Teilentladung stattfinden. Die daraus resultierende Feldschwächung in der Fehlstelle ist demzufolge relativ gering, sodass weiterhin Ionisationsvorgänge stattfinden und Ladungsträger erzeugt werden.

Die Feldschwächung bleibt somit erhalten und führt zum Verlöschen der Teilentladung. Werden die akkumulierten Oberflächenladungen durch den kontinuierlichen Entladeprozess über den Isolierstoff abgebaut, kann bei gleichbleibender Amplitude der Pulsspannung eine Folgeteilentladung zünden [Kau94].



Abbildung 4.9: Zeitabhängigkeit des Entladevorganges bei monopolarer Pulsspannug (schematisch)

Mit der darauf folgenden Spannungserhöhung der letzten beiden Perioden wird erneut die Durchschlagfeldstärke  $E_D$  überschritten und Lawinen generiert. Es findet eine starke Teilentladung statt, welche die Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  nahezu vollständig kompensiert. Demzufolge können keine Folgeentladungen während des Anstehens der Spannung auftreten, was sich messtechnisch bestätigte.

Mit der anschliessenden negativen Flanke erreicht die Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  aufgrund des Raumladungsfeldes  $E_L$  das Durchschlagkriterium in der Gegenrichtung des bis dahin wirkenden äusseren Feldes  $E_G$ . Es treten Entladungen auf, obwohl die äussere Spannung an den Elektroden  $U_A$  abgeschaltet ist. Mit dem abgebildeten Verlauf in Abbildung 4.9 ist auch nachvollziehbar, dass nicht jeder Puls, trotz Überschreiten der Durchschlagfeldstärke  $E_D$ , zu einer Entladung führt. Darin spiegelt sich der statistische Charakter der Gasentladung wieder. Dieser theoretische Ansatz kann mit eigenen Messergebnissen bestätigt werden.

Im Gegensatz zu [Ble99, Kau94, Sjö01] wurden die Rückentladungen nach negativem dU/dt nicht in Form mehrerer stossartiger Entladungen mit einem Zeitverzug von einigen 10  $\mu s$  bis mehreren hundert ms gemessen.

[Kau94] geht davon aus, dass diese stossartigen "Rückentladungen" die gespeicherten Oberflächenladungen nicht vollständig abbauen und somit mehrfach Umladevorgänge stattfinden bis die Durchschlagfeldstärke unterschritten wird. Eigene Untersuchungen zeigten nur eine Entladung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang, meist einige  $\mu s$ , zum Flankenwechsel. Weitere Folgeentladungen traten nicht auf, obwohl die Pausenzeiten ausreichend gewesen wären (siehe Abbildung 4.10 unteres Bild).



Abbildung 4.10: Beispiel für die Ausprägung der Teilentladungen bei Pulsspannung

Auszuschliessen sind Abtastfehler, da hierbei wenigstens gelegentlich aufeinanderfolgende "Rückentladungen" erkennbar hätten sein müssen.

Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass bereits bei einer "Rückentladung" eine Mindestzahl von Oberflächenladungen rekombiniert und damit die Feldstärke durch das Raumladungsfeld unter die Durchschlagfeldstärke sinkt. Die Ausprägung der "Rückentladung" bei der hier verwendeten Modellisolierung ist somit ein Unterschied zu den bisher verwendeten Lackdrähten.

Des Weiteren ist ersichtlich, dass bei Überschreiten der TE- Einsetzspannung Teilentladungen ausschliesslich im zeitlichen Zusammenhang zu den Flanken stattfinden. Daraus folgt, dass die TE- Häufigkeit mit steigender Pulsfolgefrequenz steigt. Das bestätigten ebenso [Leb98, Poh01].

# 4.2.2 Einfluss von Teilentladungen auf die Teilentladungseinsetzspannung

Bei wiederholender Beanspruchung einer Stichprobe einer Modellisolierung besteht die Möglichkeit, dass die ermittelte TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  erheblichen Streuungen unterliegt. Diese Schwankungen sind bedingt durch den zufälligen Charakter des Gasentladungsprozesses und durch die ständigen Änderungen der Ausgangsbedingungen im Gasraum der Fehlstelle.

Eventuell zurückbleibende Ladungsträger, Oberflächenerosionen, sowie gegebenenfalls Druck- und Temperaturveränderungen infolge kontinuierlicher Gasentladungen können stets verschiedenartige Zündbedingungen in den Fehlstellen zu schaffen.



Abbildung 4.11: TE- Einsetzspannung bei verschiedenen Messzeiten bei  $f_W = 1000$  Hz,  $t_R \approx 950$  ns und a = 0.5 an zwei Individuen der Prüflingsart P1

Für den Nachweis dieses Einflusses wurden 4 Messreihen an 2 Modellisolierungen der Prüflingsart P1 bei monopolarer Rechteckspannung mit Pulsfolgefrequenz  $f_W = 1000$  Hz, Anstiegszeit  $t_R \approx 950$  ns und einem Tastgrad a = 0.5 durchgeführt. Dabei wurde die Pausenzeit des Prüflings variiert. Abbildung 4.11 zeigt die jeweiligen Verläufe der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bei Messabständen von t= 10 s, 30 s, 120 s und > 24 h. Für den Zeitpunkt t > 24 h kann angenommen werden, dass sowohl alle Ladungsträger [Das90] als auch eventuelle Druckerhöhungen ausgeglichen wurden.

Beide Grafiken zeigen ähnliches Verhalten. Die TE- Einsetzspannungen liegen für alle Zeitpunkte t = 10 s, 30 s 120 s und t > 24 h dicht beieinander. Das verdeutlichen zudem die Mittelwerte aller Messungen des jeweiligen Zeitpunkts. So liegen die Mittelwerte für t > 24 h ca. 350 V bis 550 V unter denen für t = 10 s, 30 s und 120 s. Die Messwerte für die Zeitpunkte t = 10 s, 30 s und 120 s unterscheiden sich nahezu nicht.

Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob dieser Unterschied durch die statistische Streuung des Gasentladungsprozesses oder durch Änderungen der Zündbedingungen in der Fehlstelle hervorgerufen werden. Nachweisbar verändert sich die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  jedoch nur gering durch die Wahl des Messzeitpunktes. Somit spricht zunächst nichts gegen eine Verwendung der Prüflinge für Reihenuntersuchungen.

Im Folgenden wurden mit 25 Individuen der Prüflingsart P1, 15 Individuen der Prüflingsarten P2 und P4, sowie 6 Individuen der Prüflingsart P3 die Einflüsse der unterschiedlichen Parameter untersucht. Alle Messungen fanden an diesen Individuen statt. Für die Bestätigung der Messergebnisse stand eine zweite Stichprobe mit 25 Prüflingen der Prüflingsart P1 zur Verfügung.

# 4.2.3 Einfluss des Gleichanteils der Pulsspannung $U_{Offset}$

Ausgangspunkt der Untersuchung zum Einfluss des Gleichanteils der Pulsspannung ist die Anwendung von Mehrpunktumrichtern in der Antriebstechnik. Hierfür wurde die Spannung mit der im Kapitel "Versuchstechnik" beschriebenen Pulsspannungsanlage erzeugt. Der Gleichanteil wurde mit einer zusätzlichen Gleichspannungsquelle generiert und kapazitiv eingekoppelt.

Untersucht wurde der Einfluss bei einer Pulsfolgefrequenz von  $f_W = 1000 Hz$ , einer Anstiegszeit von  $t_R \approx 1200 ns$  und einem Tastgrad a= 0,5. Der Gleichanteil wurde von -4 kV bis +4 kV variiert.

Der Vergleich der Diagramme zeigt, dass bei keiner der 4 Prüflingsarten ein nennenswerter Einfluss des Gleichanteils der Pulsspannung nachweisbar ist. Die Höhe der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  wird allein durch den Wechselanteil der Pulsspannung bestimmt.



Abbildung 4.12: TE- Einsetzspannungshub über der Spannungshöhe des Gleichanteils für die Prüflingsarten P1 (oben) und P4 (unten) bei  $f_W = 1000Hz, t_R \approx 1200ns$  und a = 0.5



Abbildung 4.13: TE- Einsetzspannungshub über der Spannungshöhe des Gleichanteils für die Prüflingsart P2 (P2+ oben, P2- unten) bei  $f_W = 1000 Hz$ ,  $t_R \approx 1200 ns$  und a = 0.5



Abbildung 4.14: TE- Einsetzspannungshub über der Spannungshöhe des Gleichanteils für die Prüflingsart P3 (P3+ oben, P3- unten) bei  $f_W = 1000 Hz$ ,  $t_R \approx 1200 ns$  und a = 0.5

#### 4.2.3.1 Interpretation der Messergebnisse

Die Spannungsverteilung in der Modellisolierung ist beeinflusst von der Geometrie der Anordnung, sowie von den spezifischen Leitfähigkeiten  $\kappa$  und den Dielektrizitätszahlen  $\epsilon$ .



Abbildung 4.15: Vereinfachtes Ersatzschaltbild nach [Küc96]

Zur Abschätzung der Spannungsverteilung im quasistationären dielektrischen Verschiebungsfeld und im stationären Strömungsfeld soll das vereinfachte Modell nach Abbildung 4.15 genutzt werden. Dazu soll nur der Bereich um die Fehlstelle zwischen den Elektroden betrachtet und als homogen angenommen werden. Aus den gegebenen Geometrien, sowie den spezifischen Leitfähigkeiten  $\kappa$  und den Dielektrizitätszahlen  $\epsilon$  für Luft bzw. Epoxydharz berechnen sich die Widerstands- und Kapazitätswerte in der Abbildung 4.15.

Somit ergibt sich für eine kapazitive Sofortverteilung im Einschaltzustand

$$\frac{U_{C2}}{U_{Ges}} = \frac{C_1}{C_1 + 2C_2} = 0,49 \tag{4.14}$$

bzw. für die Verteilung im stationären Strömungsfeld

$$\frac{U_{R2}}{U_{Ges}} = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} = 0,91. \tag{4.15}$$

Nach den FEM Simulationen fallen an  $C_2$  etwa 40% der Gesamtspannung ab, für eine qualitative Betrachtung ist die Genauigkeit des Modells hinreichend. Die entsprechenden Zeitkonstanten

$$\tau_1 = C_1 R_1 \approx 33,7s$$
  $bzw.$   $\tau_2 = C_2 R_2 \approx 354,2s$  (4.16)

zeigen, dass für die Spannungsverteilung bei pulsförmiger Beanspruchung nur die Kapazitäten betrachtet werden müssen.

Die kapazitive Verteilung erklärt nicht den konstanten Teilentladungseinsatz bei grundsätzlich verschiedenen äusseren Spannungen.

Dieser Effekt wird erst durch die Bildung und Anlagerung von Ladungsträgern innerhalb der Fehlstelle sinnvoll erklärbar, welcher ähnliche Feldverhältnisse hervorrufen muss, wie sie bereits im Abschnitt 4.2.1.2 beschrieben wurden. Der dort beschriebene Feldverlauf stellt den Spezialfall für einen Gleichanteil von  $U_{Offset} = 0$  V dar. Bereits in [Kau94] wurden ähnliche Messergebnisse vorgestellt. Bestimmend für den Teilentladungseinsatz war der Spitze-Spitze-Wert bei mono- und bipolaren Pulsspannungen. Die Pulsfolgefrequenz  $f_W$  hatte keinen Einfluss auf diese Verhalten.

Die vorliegenden Messungen wurden durchgeführt, indem zunächst der Gleichanteil eingestellt und hiernach der Wechselanteil der Pulsspannung aufgesetzt wurde. Die Abbildung 4.16 zeigt schematisch die Verläufe der Elektrodenspannung und der Feldstärke in der Fehlstelle für die Fälle positiver Gleichanteil (Abbildung 4.16 a) und negativer Gleichanteil unterschiedlicher Grösse (Abbildungen 4.16 b und c).

Zunächst soll die Modellvorstellung bei Pulsspannung mit positivem Gleichanteil aus Abbildung 4.16 a beschrieben werden. Die Grösse des Gleichanteils ist so gewählt, dass die Ionisationsfeldstärke  $E_{Ion}$  mindestens lokal in der Fehlstelle überschritten wird und die Ladungsträgergeneration durch Stossionisation einsetzt.

Mit der sukzessiven Erhöhung des Wechselanteils -damit verbunden die Erhöhung der Feldstärke  $E_I$  in der potentialfreien Fehlstelle - werden verstärkt Ladungsträger generiert und ein Raumladungsfeld aufgebaut, welches entgegen der Feldstärke  $E_I$  in der Fehlstelle wirkt und diese herabgesetzt.

Steht ausreichend Zeit zur Verfügung findet dieser Vorgang solange statt, bis die Feldstärke  $E_I$  in der Fehlstelle kleiner als die Ionisierungsfeldstärke  $E_{Ion}$  ist und keine zusätzlichen Ladungsträger generiert werden können. Die endliche Geschwindigkeit des Generationsprozesses führt dazu, dass diese Grenze erst nach einer Vielzahl von Pulsen unterschritten werden kann, falls die Pulsspannung  $U_{Puls}$  nicht das Durchschlagskriterium überschreitet. Bei jeder negativen Flanke der Pulsspannung wird der Ionisationsprozess zunächst unterbrochen. Für grössere Amplituden der Pulsspannung  $U_{Puls}$  wird durch die Überlagerung mit dem Poisson- Feld die Ionisierungsfeldstärke in negativer Richtung überschritten und die ursprünglichen Ladungsträger teilweise abgebaut. Es entsteht ein eingeschwungener Zustand um die Ionisationsfeldstärke  $-E_{Ion}$ .

Analog zum beschriebenen Vorgang läuft der Aufladevorgang bei negativem Gleichanteil, wie aus den Abbildungen 4.16 b und c erkennbar ist. Da sich die Fehlstelle potentialfrei im Isolierstoff befindet ist nur die Potentaldifferenz von praktischer Bedeutung. In jedem Fall können den beiden Grenzflächen der Fehlstelle verschiedene Potentiale zugeordnet werden, wobei eine feste Grenzfläche stets das höhere Potential annimmt. Dieser Sachverhalt bleibt in allen drei Fällen identisch.



Abbildung 4.16: Zeitabhängigkeit des Aufladevorganges bei Pulsspannung mit Gleichanteil (schematisch)

Messtechisch kann der Aufladevorgang mit beliebigem Gleichanteil  $U_{Offset}$  bestätigt werden. Schaltet man den Gleich- und Wechselanteil während eines Aufladevorgangs ab, muss ein heteropolares Raumladungsfeld verbleiben.

Die Beanspruchung mit Impulsen entgegengesetzter Polarität zu der vorherigen Pulsspannung ergibt eine positive Überlagerung beider Felder und somit eine reduzierte Amplitude der Impulsspannung  $U_{Impuls}$  für den Teilentladungseinsatz. Dieses Ergebnis ist bereits in [Kau94] gezeigt.

Durch die qualitativ gleichartigen Verläufe der Feldstärke in der Fehlstelle  $E_I$  kann folglich kein Einfluss des Gleichanteils nachweisbar sein.

Somit ist die folgende Untersuchung mit monopolarer Pulsspannung hinreichend.

## 4.2.4 Einfluss der Pulsbreite $t_P$

Der Einfluss der Pulsbreite auf die TE-Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  wurde mit monopolarer Rechteckspannung mit einer Pulsfolgefrequenz  $f_W = 1000$  Hz und einer Anstiegszeit  $t_R \approx 950$  ns ermittelt. Die Pulsbreite wurde im Bereich von  $t_P = 10 \ \mu s$  bis 700  $\mu s$  variiert.



Abbildung 4.17: TE- Einsetzspannung über der Pulsbreite für die Prüflingsarten P1 (oben) und P4 (unten) bei bei  $f_W = 1000Hz$  und  $t_R \approx 950$  ns

Der Verlauf der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zeigt für alle 4 Prüflingsarten ähnlichen Verlauf. So treten bei sehr kurzen Pulsen die höchsten TE- Einsetzspannungen auf. Diese sinkt dann um ca. 20 % und stabilisiert sich im Bereich von  $t_P = 150 \ \mu$ s bis 300  $\mu$ s.

Die Messungen deuten darauf hin, dass ab einer Grenzpulsbreite  $t_{Grenz}$  praktisch keine Abhängigkeit der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  von der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bei konstanter Pulsbreite  $t_P$  auftritt und damit konstante Entladebedingungen herrschen. In [Kah89, Leb98] wird bereits darauf hingewiesen, dass die Pulsbreite  $t_P$  bei Rechteckspanungen eine Mindestdauer haben muss, um Teilentladungen zu initiieren.



Abbildung 4.18: TE- Einsetzspannung über der Pulsbreite für die Prüflingsart P2 (P2+ oben, P2- unten) bei  $f_W = 1000Hz$  und  $t_R \approx 950$  ns



Abbildung 4.19: TE- Einsetzspannung über der Pulsbreite für die Prüflingsart P3 (P3+ oben, P3- unten) bei  $f_W = 1000Hz$  und  $t_R \approx 950$  ns

#### 4.2.4.1 Interpretation der Messergebnisse

Alle Abbildungen zeigen qualitativ gleiches Verhalten und deuten auf ein ähnliches Spannungs-Zeit-Flächen Kriterium hin, welches schon bei [Kin58] mit Blitzstossspannungen untersucht wurde. Die sich dabei ergebenden Spannungs-Zeit-Kennlinien sind jedoch für Spannungsverläufe mit identischen Stirn- und Rückenhalbwertszeiten ermittelt. Allein die Amplitude wird variiert. Für die Abhängigkeit der Pulsbreite ergibt sich sowohl eine Variation der Amplitude als auch eine Variation der Signalbreite, bei der jedoch Anstieg- und Abfallzeit konstant bleiben. Es können ebenfalls Informationen zur Stossfestigkeit des Feldraumes, im untersuchten Fall der der Fehlstelle, abgeleitet werden.



Abbildung 4.20: Ermittlung des Spannungs-Zeit-Flächen-Kriteriums bei Pulsspannung (Funkenaufbauzeit  $t_F$  wird vernachlässigt)

Für die Interpretation ist es sinnvoll, die statische Ansprechspannung gleich der Amplitude der TE- Einsetzspannung  $\hat{U}_{PD/inc}$  bei 50 Hz- sinusförmiger Wechselspannung zu setzen. Wie im Kapitel "Versuchstechnik" beschrieben wurde, deckt sich die minimale Zündspannung  $U_Z$  der Fehlstelle mit dem Wert der Amplitude bei sinusförmiger Wechselspannung. Der üblicherweise verwendete Ansatz, die statische Ansprechspannung der Fehlstelle mittels Gleichspannung zu ermitteln, führt aufgrund eines sich stark ausprägenden Poisson- Feldes in der Fehlstelle zu falschen Ergebnissen. Abbildung 4.20 zeigt schematisch die Ermittlung der Spannungs-Zeitfläche.

Der Spannungsverlauf kann aufgrund des vorgeschalteten RC- Gliedes mit einer Exponentialfunktion beschrieben werden, was die Berechnung der Verzugszeit  $t_0$  bis zum Erreichen der statischen Ansprechspannung vereinfacht. Die statistische Streuzeit  $t_S$  wird durch die Bereitstellung eines lawinenwirksamen Elektrons bestimmt und konnte in den Untersuchungen nicht explizit ermittelt werden. Da nach [Gän53] sich die statistische Streuzeit  $t_S$  jedoch für grosse Stossfaktoren u zu einem Minimum ergibt, soll die Aufbauzeit  $t_A$  abgeschätzt werden. Sie stellt eine Konstante für eine gleichbleibende Anordnung dar. Für kleine Volumina nimmt die statistischen Streuzeit  $t_S$  zu, jedoch wird aufgrund der Oberflächenrauhigkeiten der Fehlstellen diese wieder verkürzt [Küc96]. Des Weiteren stehen durch vorhergehende Teilentladungen ständig Ladungsträger in der Fehlstelle zur Verfügung, sodass anzunehmen ist, dass die statistische Streuzeit  $t_S$  vernachlässigbar klein sein muss.

Für die Modellisolierung P1 konnten auch für grosse Stossfaktoren u keine Zündverzugszeiten  $t_D < 800$  ns gemessen werden. Ähnlich kleine Zündverzugszeiten  $t_D$  wurden bei Folgeteilentladungen bei geringer Überspannung festgestellt. Hierbei wirkt offenbar das Vorhandensein von Ladungsträgern von vorangegangenen Teilentladungen in der Fehlstelle förderlich für den Lawinen-aufbau.

Die Spannungs-Zeit-Fläche wurde unter der Annahme, dass Streuzeit  $t_S$  und Funkenaufbauzeit  $t_F$  minimal bzw. vernachlässigbar sind, ermittelt. Sie ergab sich zu  $F \approx 0, 3...0, 5kV \cdot \mu s$ . F liegt damit im Bereich der Angaben von [Kin58] für Elektrodenanordnungen mit inhomogenem Feldverlauf.

Da die zylinderförmige Fehlstelle nur in erster Näherung eine homogene Anordnung ist, erscheinen diese Werte plausibel. Betrachtet man die Spannungs-Zeit-Fläche inklusive dem Bereich der statistische Streuzeit  $t_S$ , ergeben sich Werte von  $F \approx 0, 5...5kV \cdot \mu s$ .

Für die übrigen Arten der Modellisolierung ergaben sich Spannung-Zeit-Flächen F, welche Werte in ähnlicher Grössenordnung annahmen.

# 4.2.5 Einfluss der Pulsfolgefrequenz $f_W$

## 4.2.5.1 Konstante Pulsbreite $t_P$

Das Herausarbeiten des Einflusses der Pulsfolgefrequenz bei konstanter Pulsbreite wurde mit einer monopolaren Rechteckspannung mit einer Pulsbreite  $t_P = 125 \ \mu$ s und einer Anstiegszeit  $t_R \approx 950$  ns durchgeführt. Die Pulsfolgefrequenz wurde von  $f_W = 100 \ \text{Hz}$  bis  $f_W = 7500 \ \text{Hz}$  verändert.



Abbildung 4.21: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsarten P1 (oben) und P4 (unten) bei  $t_P = 125 \mu s$  und  $t_R \approx 950$  ns

Hier zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Einfluss des untersuchten Parameters. Für alle 4 Prüflingsarten verläuft die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  ähnlich. Zunächst verläuft die TE- Einsetzspannung relativ konstant, um dann ab der Pulsfolgefrequenz  $f_W \approx 2000$  Hz - 3000 Hz bis  $f_W = 7500$  Hz um ca. 20 % anzusteigen.



Abbildung 4.22: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsart P2 (P2+ oben, P2- unten) bei  $t_P = 125 \mu s$  und  $t_R \approx 950$  ns

Der charateristische Anstieg der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bei Erhöhen der Pulsfolgefrequenz  $f_P$  konnte für unbelastete Prüflinge ebenso festgestellt werden, wie während eines Durchgangs, bei dem bereits mehrere Messpunkte durchlaufen worden sind. Somit kann ein Ansteigen durch Druckerhöhung durch vorhergehende Entladungen entsprechend der Paschenkurve nahezu vollständig ausgeschlossen werden.



Abbildung 4.23: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsart P3 (P3+ oben, P3- unten) bei  $t_P = 125 \mu s$  und  $t_R \approx 950$  ns

#### 4.2.5.2 Konstanter Tastgrad a

Wie im vorhergehenden Abschnitt kam eine monopolare Rechteckspannung zum Einsatz, die im Bereich von  $f_W = 50$  Hz bis  $f_W = 10000$  Hz variiert wurde. Die Anstiegszeit betrug  $t_R \approx 400$  ns. Der Tastgrad wurde mit a = 0.5 konstant gehalten.



Abbildung 4.24: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsarten P1 (oben) und P4 (unten) bei  $t_R \approx 400ns$  und a = 0.5

Im Gegensatz zum Abschnitt 4.2.5.1 verändert sich durch die Variation der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bei konstantem Tastgrad a= 0,5 die Pulsbreite  $t_P$  für jeden Messpunkt.



Abbildung 4.25: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsart P2 (P2+ oben, P2- unten) bei  $t_R \approx 400ns$  und a = 0.5

Alle 4 Prüflingsarten zeigen ähnliches Verhalten. Die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  scheint bei Steigerung der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  konstante Werte einzunehmen. Eine Abhängigkeit beider Parameter kann somit nicht festgestellt werden.

Ein interessanter Aspekt ergab sich jeweils gegen Ende der Messreihe. Die Teilentladungsamplitude  $U_{PD}$  nahm ab ca. 4 kHz deutlich ab.



Abbildung 4.26: TE- Einsetzspannung über der Pulsfolgefrequenz für die Prüflingsart P3 (P3+ oben, P3- unten) bei  $t_R\approx 400ns$  und a= 0,5

#### 4.2.5.3 Interpretation der Messergebnisse

Der Einfluss der Pulsfolgefrequenz bei konstanter Pulsbreite kann unter Zuhilfenahme der Interpretation aus dem Abschnitt 4.2.4 erklärt werden.

Bei Wahl einer konstanten Pulsbreite  $t_P$  verläuft die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zunächst konstant. Das Steigern der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  führte schliesslich zum Anstieg der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$ . Es wurden identische TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  erzielt, wie sie bereits im Abschnitt 4.2.4 gemessen wurden. Dazu muss die Pausenzeit der dort betrachteten Pulsbreite entsprechen. In der Pulspause findet die "Rückentladung" nach vorangegangener Teilentladung und damit die Überschreitung der negativen Durchschlagfeldstärke  $-E_D$  statt.

Der Anstieg der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  kann entsprechend Abschnitt 4.2.4 mit dem Spannungs-Zeit-Flächen Kriterium erklärt werden, wobei die Pausenzeit  $T_W - t_P$  der dort betrachteten Pulsbreite  $t_P$  und der Spannungshub der negativen Flanke dem dort betrachteten Spannungshub  $\Delta U_{Puls}$  entspricht. Die Gasentladung wird in diesem Fall durch das Abschalten der Pulsspannung  $U_{Puls}$  eingeleitet. Während des Abschaltvorgangs wird die Durchschlagfeldstärke  $-E_D$  überschritten, wenn in der Fehlstelle im Vorfeld genügend Ladungsträger akkumuliert wurden. Diese Durchschlagfeldstärke  $E_D$  muss dem Spannungs-Zeit-Flächen Kriterium entsprechend eine bestimmte Mindestzeit anstehen, da sonst keine Gasentladung ausgebildet werden kann.

Es ergaben sich ebenfalls Spannungs-Zeit-Flächen F wie sie bereits in Abschnitt 4.2.4 ermittelt wurden.



Abbildung 4.27: Zur Interpretation des Teilentladungsverhaltens für den Parameter Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bei konstanter Pulsbreite  $t_P$ 

Wird folglich eine Modellisolierung mit der Pulsbreite  $t_{P1}$  des linken Zeitverlaufs der Abbildung 4.27 untersucht, führt das zu identischen TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  wie bei Beanspruchungen mit

$$t_{P2} = T_W - t_{P1} \tag{4.17}$$

des rechten Zeitverlaufs.  $T_W$  ist hierbei die Periodendauer der Pulsspannung der Verläufe (1) und (2).

Für die Modellisolierung liegen demzufolge trotz unterschiedlicher zeitlicher Verläufe betragsmässig gleichartige Maximalfeldbelastungen in der Fehlstelle vor, was sich in identischen TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  widerspiegelt. Aus diesen Überlegungen muss die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  für variable Pulsbreiten  $t_P$  bei konstanten Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  den schematischen Verlauf in Abbildung 4.28 zeigen.



Abbildung 4.28: Schematischer Verlauf der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  für variable Pulsbreiten  $t_P$  bei verschiedenen Pulsfolgefrequenzen  $f_W$ , Abszisse: logarithmische Darstellung

Die Verhältnisse

$$\frac{t_p}{T_W - t_P} = \frac{a}{1 - a} \approx 0,12 \qquad bzw. \qquad \frac{t_p}{T_W - t_P} = \frac{a}{1 - a} \approx 8,3 \qquad (4.18)$$

für den Bereich  $U_{PD/inc} = \text{const.}$  sind für die Prüflingsart P1 bei einer Pulsfolgefrequenz  $f_{W1} = 1000$  Hz gewählt. Aus Abschnitt 4.2.4 kann hierfür die Pulsbreite  $t_{Grenz} \approx 110 \ \mu \text{s}$  ermittelt werden. Für kleinere Pulsbreiten  $t_P$  als die Grenzpulsbreite  $t_{Grenz}$  steigt die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  an.

Kleinere Pulsfolgefrequenzen  $f_{W2}$  bei konstanter Pulsbreite  $t_P$  führen zu einer Verbreiterung des konstanten Bereiches, der bei  $\frac{t_P}{T_W - t_P} = 1$  für verschiedene Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  nahezu identische Werte einnimmt.

Die Ergebnisse aus [Kau94] zeigten hier ebenfalls eine Unabhängigkeit der TE-Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  von der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bei konstanter Pulsbreite  $t_P$  in einem Bereich von  $f_W = 0,1$  Hz bis  $f_W = 5000$  Hz. Wird die Pulsfolgefrequenz  $f_W$  so gewählt, dass  $f_W \ge f_{Grenz} = \frac{1}{2 \cdot t_{Grenz}}$  erreicht bzw. überschritten wird, wird der konstante Bereich der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zu Null. Die Spannungspulse bei konstanter Pulsspannung  $U_{Puls}$  genügen dem Spannungs- Zeit- Flächen- Kriterium nicht mehr und die Teilentladungen erliegen.

Für Pulsspannungen  $U_{Puls}$  mit variablen Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  bei konstanter Pulsbreite  $t_P$  ergibt sich insofern kein Einfluss auf die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$ , solange die Pulspause die Bedingung

$$T_W - t_P \ge t_{Grenz}$$

und der Puls die Bedingung

$$t_P \ge t_{Grenz}$$

erfüllen. Überschreitet man diese Grenzen, steigt die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$ .

In den Ausführungen von [Kau94] konnte dieser Anstieg vermutlich nicht aufgezeigt werden, da die obere Grenze der Pulsfolgefrequenz bei  $f_W = 5$  kHz bei einer Pulsbreite  $t_P \approx 20 \mu s$  festgelegt war.

Die Ergebnisse zum Einfluss der Pulsfolgefrequenz  $f_W$  bei konstantem Tastgrad a auf die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zeigen keine ausgeprägte Abhängigkeit, wie sie bei konstanter Pulsbreite  $t_P$  erkennbar ist. Vielmehr verläuft sie nahezu konstant über den gesamten Bereich. Mit der Anwendung der bisher erarbeiteten Erkenntnisse kann dieses Verhalten zumindest teilweise geklärt werden.

Die Interpretation, die zu Abbildung 4.28 geführt hat, kann den Verlauf der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  nur teilweise erklären. Der konstante Tastgrad a = 0,5 bedeutet, dass sich das Verhältnis  $\frac{t_p}{T_W - t_P} = 1$  ergibt. Somit ergibt sich für die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bis zur Grenzpulsbreite  $t_{Grenz}$  ein konstanter Wert.

Für kleinere Pulsbreiten  $t_P$  sollte sich anhand der vorhergehenden Interpretationen die Amplitude der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  erhöhen. Zieht man die Messwerte für die Prüflingsart P1 aus Abschnitt 4.2.4 in Betracht, müsste dieser Anstieg ab einer Pulsfolgefrequenz  $f_W \approx 4.5$  kHz $=\frac{1}{2 \cdot t_{Grenz}}$  zu verzeichnen sein und bis  $f_W = 10$  kHz etwa 10% betragen. Dieses Ansteigen der TE-Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  stellte sich allerdings bei den Messungen nicht ein. Denkbar wäre ein Effekt, welcher dem Anstieg der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  durch die Verkürzung der Pulsbreite  $t_P$  entgegenwirkt. In der Literatur wird bestätigt, dass bei der Verwendung von hochfrequenten elekrischen Belastungen ein Absinken der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zu verzeichnen ist. Dieses Phänomen kommt bei dieser Applikation jedoch nicht in Betracht, da nach [Gän53] eine Pulsfolgefrequenz von  $f_W \approx 1,3$  MHz für die gegebene Geometrie benötigt würde.

Des Weiteren lässt sich im untersuchten Bereich eine signifikante Frequenzabhängigkeit der relativen Dielektrizitätszahl  $\epsilon_r$  ausschliessen. Dagegen ist die

relative Dielektrizitätszahl  $\epsilon_r$  für Epoxydharze temperaturabhängig. Sie steigt mit Erhöhung der Temperatur. Andauernde TE- Aktivität führt zur lokalen Erwärmung des Isolierstoffs, woraus eine erhöhte Feldbelastung in der Fehlstelle folgt.

In Betracht zu ziehen ist die in [Kur93] bestätigte zunehmende Oberflächenleitfähigkeit der Fehlstellenoberfläche bei zunehmender Dauer der TE- Aktivität. Eine erhöhte Leitfähigkeit an der Oberfläche begünstigt das Abfliessen der Ladungen und damit den Abbau des Poisson- Feldes, woraus eine geringe Feldschwächung folgt. Bei energietechnischen Frequenzen werden ca. 10 min benötigt, um die Leitfähigkeit nachweislich zu erhöhen. Demzufolge könnten sich ähnliche Verhältnisse bereits nach kürzeren Zeiträumen bei Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  im kHz- Bereich einstellen. Die Messpunkte mit hohen Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  wurden stets gegen Ende einer Messreihe untersucht, was eine Vielzahl von bereits stattgefundenen Teilentladungen und damit eine Erhöhung der Oberflächenleitfähigkeit mit sich führte.

Eine umfassende Erklärung konnte nicht gefunden werden, sodass hier weitere Untersuchungen notwendig sind.

## 4.2.6 Einfluss der Anstiegszeit $t_R$

In der modernen Leistungselektronik setzt sich zunehmend der Trend zu immer größeren Spannungssteilheiten durch, um beispielsweise die Ein- und Ausschaltverluste der Halbleiter zu minimieren. Infolge dessen liegt die elektrische Feldstärke schneller an den potentialführenden Komponenten des Antriebssystems und belastet den Isolierstoff zusätzlich.

Um den Einfluss von verschiedensten Anstiegszeiten  $t_R$  auf die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  zu ermitteln, wurden durch Variation des Vorwiderstands  $R_V$  die gewünschten Anstiegszeiten im Bereich von  $t_R \approx 400$  ns .. 13  $\mu$ s erzeugt (siehe Kapitel "Versuchstechnik"). Alle Messungen wurden mit einem Tastgrad a= 0,5 durchgeführt. Die Abbildung 4.29 zeigt den Verlauf der Amplitudenmittelwerte der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  der 4 Prüflingsarten für die untersuchten Anstiegszeiten  $t_R$  für die Pulsfolgefrequenz  $f_W = 1000$  Hz und  $f_W = 10000$  Hz.



Abbildung 4.29: TE- Einsetzspannung über der Anstiegszeit für alle Prüflingsarten bei  $f_W = 1000Hz$  bzw.  $f_W = 10000Hz$  und a = 0.5

Der Verlauf der Mittelwerte der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  für alle Prüflingsarten zeigt keinen ausgeprägten Einfluss der Anstiegszeit. Auch wenn die

Vertrauensbereiche zusätzlich einzeichnet (der besseren Übersichtlichkeit wegen weggelassen) kann keine eindeutige Tendenz im untersuchten Bereich nachgewiesen werden.

Um den tatsächlich existenten Einfluss [Cen00, Gue89, Kau94, Poh01] der Anstiegszeit nachzuweisen, wurde die Anstiegszeit  $t_R$  in einem grösseren Bereich variiert und die Pulsfolgefrequenz auf  $f_W = 50Hz$  veringert und an ausgewählten Individuuen untersucht. Die Abbildung 4.30 zeigt den Verlauf der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bei Anstiegszeiten  $t_R = 150$ ns....2ms eines Individuums der Prüflingsart P3.



Abbildung 4.30: TE- Einsetzspannung über der Anstiegszeit für ein Individuum der Prüflingsart P3 bei  $f_W = 50Hz$  und a = 0.5

Hierbei ist eine deutliche Abhängigkeit der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  von der Anstiegszeit  $t_R$  erkennbar. Erst für Anstiegszeiten im ms- Bereich konvergiert die TE- Einsetzspannung und nimmt den Wertebereich ein, welcher mit dem Spitze-Spitze-Wert bei sinusförmiger Wechselspannung identisch ist. Die Zusammenstellung aller Individuen der Prüflingsart P3 ergibt analoges Verhalten, wobei der Mittelwert  $U_{PD/inc/50}$  ca. 0,2 kV kleiner als in Abbildung 4.30 ist. Die Standardabweichung beträgt s $\approx$  0,47 kV.

## 4.2.6.1 Interpretation der Messergebnisse

Wie bereits in Abschnitt 4.2.1.2 beschrieben, finden im Volumen und an den Grenzschichten der Fehlstelle Generation und Bewegung von Ladungsträgern statt, was einen heteropolaren Aufladevorgang der dielektrischen Grenzflächen mit sich führt. Damit verbunden ist eine Reduktion der elektrischen Feldstärke  $E_I$  in der Fehlstelle auf einen Bereich, in dem die Ladungsträgererzeugung gehemmt wird oder eventuell nicht mehr stattfindet.

Aufgrund der begrenzten Beweglichkeit der Ladungsträger bedarf der Akkumulationsvorgang an den Grenzflächen Zeit und soll hier durch die Zeitkonstante  $\tau_{\sigma}$  ausgedrückt werden.



Abbildung 4.31: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Spannung an den Elektroden und Feldstärke in der Fehlstelle bei unterschiedlichen Anstiegszeiten  $t_R$  nach [Kau94]

Abbildung 4.31 stellt schematisch den Aufladevorgang für zwei verschieden grosse Anstiegsgeschwindigkeiten  $t_R$  dar.

Die linke Spalte zeigt den Fall, dass die Anstiegszeit  $t_R$  kleiner ist als die Zeitkonstante  $\tau_{\sigma}$ . Somit beginnt die Ausbildung eines Poisson-Feldes  $E_L$  erst nachdem die Feldstärke des Laplace-Feldes  $E_G$  der Pulsspannung mit ihrer vollständigen Amplitude in der Fehlstelle wirkt.

Ist die Anstiegszeit  $t_R$  grösser als die Zeitkonstante des Akkumulationsvorganges  $\tau_{\sigma}$  (rechte Spalte), schwächt das Poisson- Feld  $E_L$  schon während des Anstiegs der Pulsspannung das Laplace- Feld  $E_G$ .

Trotz identischer Amplituden der Elektrodenspannungen  $U_A$  werden unterschiedliche Feldstärkeamplituden in der Fehlstelle  $E_I$  erreicht. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$ , damit eine Abhängigkeit von der Anstiegszeit  $t_R$ . Es deutet sich somit an, dass nicht die Signalform, sinus- bzw. rechteckförmig, die Höhe der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$ bestimmt, sondern die Anstiegszeit  $t_R$  der jeweiligen Spannung.

## 4.2.7 Einfluss von Impulsen

Der Einfluss von Impulsen variabler Impulsbreite  $t_P = 5\mu s...2ms$  (Prüflingsart P3) bzw.  $t_P = 5\mu s...20ms$  (Prüflingsart P1) wurde mit monopolaren Rechteckimpulsen der Anstiegszeit  $t_R = 950$  ns ermittelt. Die Prüflingsarten P2 und P4 wurden nicht untersucht, da die zur Verfügung stehende Pulsspannungsanlage bei kleinen Impulsbreiten  $t_P$  keine hinreichende Spannungsamplitude lieferte.

Definitionsgemäss ist ein Impuls ein einmaliger Vorgang. Demzufolge muss eine unendlich grosse Zeit zwischen zwei einzelnen Impulsen liegen. Für eine praktikable Untersuchung wurde dieser Zeitraum auf ca. 60 s festgelegt.



Abbildung 4.32: TE- Einsetzspannung über der Impulsbreite für die Prüflingsart P1 bei  $t_R = 950ns$ 

Die Abbildungen zeigen ähnlichen Einfluss, wie bereits in Abschnitt 4.2.4 festgestellt wurde. Die TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  sinkt mit Vergrösserung der Impulsbreite  $t_P$  und stabilisiert sich etwa im Bereich  $t_P \approx 200 \ \mu s$  bis 300  $\mu s$ . Die ermittelten TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  liegen hierbei unterhalb der Werte aus Abschnitt 4.2.4. So wurden bei der Prüflingsart P3 TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  gemessen, die durchschnittlich 200 V - 300 V kleiner als die zuvor genannten waren. Dieser Abstand verbleibt relativ konstant bis über die Stabilisierungsphase hinaus. Für die Prüflingsart P1 wichen die TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  ca. 300 V - 500 V voneinander ab.



Abbildung 4.33: TE- Einsetzspannung über der Impulsbreite für die Prüflingsart P3 (P3+ oben, P3- unten) bei  $t_R = 950 ns$ 

## 4.2.7.1 Interpretation der Messergebnisse

Die impulsförmige Belastung soll durch Pulse mit einer Pulsfolgefrequenz  $f_W \rightarrow 0$  nachgebildet werden. Nach diesem unendlich langen Zeitraum wird nur eine verschwindend geringe Zahl an Ladungsträger im Fehlstellenvolumen vorhanden sein. Ein stationärer raumladungsfreier Zustand stellt sich ein.

Es wurde bereits im Abschnitt 4.2.1.2 gezeigt, dass die Steigerung von Pulsspannungen mit endlichen Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  eine Ladungsträgerakkumulation an den Grenzflächen zur Folge hat. Dieses heteropolare Poisson-Feld reduziert die Feldstärke  $E_I$  in der Fehlstelle und erhöht somit die elektrische Festigkeit. Es stellt sich für Pulsspannungen mit endlichen Pulsfolgefrequenzen  $f_W$  ein raumladungsbehafteter Zustand ein.

Sind Oberflächenladungen vorhanden, verbleiben diese zunächst. Der hohe Volumen- und Oberflächenwiderstand des Epoxydharzes führt zum Ladungsträgererhalt an den dielektrischen Grenzflächen der Fehlstelle für mehrere 10 Minuten.

Für Impulse tritt kein vorangehender heteropolarer Akkumulationsvorgang und somit keine Feldentlastung in der Fehlstelle auf, da für jeden Impuls die Durchschlagsfeldstärke  $E_D$  erreicht wird. Demzufolge müssen die TE- Einsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  für impulsförmige Belastung unter den Werten für pulsförmige Belastungen liegen.

Die praktische Ausführung der Messungen mit einem schrittweisen Herantasten an die Durchschlagsspannung  $U_D$  führt jedoch nach Abschnitt 4.2.1.2 zwangsläufig zu einer gewissen Aufladung, sodass die tatsächlichen Spannungswerte wahrscheinlich noch deutlicher differieren. Des Weiteren verbleiben Reste von Oberflächen- und Raumladungen in der Fehlstelle von vorhergehenden Teilentladungen trotz "Rückentladungen", was ebenfalls eine Feldschwächung mit sich bringt.

# 4.3 Vergleich des Teilentladungseinsatzes bei sinus- und rechteckförmiger Spannung

Ein wichtiger Teil der Fragestellung ist die Anwendbarkeit der bisher verwendeten konventionellen Messtechnik für technische Wechselspannungen und der damit gewonnene Ergebnisse auf Pulsspannungen. Besonders interessant ist hierbei das Verhalten des Parameters TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  bei sinusförmiger und rechteckförmiger Belastung gleicher Frequenz.

# 4.3.1 Messergebnisse bei technischer Wechselspannung

Die Teilentladungseinsetzspannungen  $U_{PD/inc}$  bei sinusförmiger Wechselspannung wurden mit der im Kapitel "Versuchstechnik" beschriebenen Anlage an allen 4 Prüflingsarten ermittelt. In Abbildung 4.34 sind die Mittelwerte  $U_{PD/inc/50}$  der Amplituden und die zugehörigen Streuungen der einzelnen Prüflingsarten dargestellt.



Abbildung 4.34: Teilentladungseinsetzspannung bei sinusförmiger Wechselspannung der 4 Prüflingsarten

Für die Prüflingsart P1 wurde ein Amplitudenmittelwert von

 $\hat{U}_{PD/inc/50} = 4,14$  kV bei einer Standardabweichung von s= 0,42 kV gemessen. Minimal traten dabei  $\hat{U}_{PD/inc} = 3,55$  kV und maximal  $\hat{U}_{PD/inc} = 4,86$  kV auf. Die Messwerte decken sich mit den im Kapitel "Versuchstechnik" berechneten Werten. Die scheinbare Ladung  $Q_S$  häufte sich dabei um Werte von ca. 40 pC bis 150 pC. Vereinzelt wurden aber auch Teilentladungsimpulse bis 300 pC gemessen. Geringfügig höher fielen die Messwerte der Prüflingsart P2 aus. Es wurde ein Amplitudenmittelwert  $U_{PD/inc/50} = 4,61$  kV bei einer Standardabweichung von s= 0,28 kV ermittelt. Gemessen wurde eine minimale Einsetzspannung  $\hat{U}_{PD/inc} = 4,08$  kV und eine maximale Einsetzspannung von  $\hat{U}_{PD/inc} = 5,2$  kV. Die bei den ermittelten TE- Einsetzspannungen umgesetzte scheinbare Ladung  $Q_S$  lag grossteils im Bereich 20 pC bis 50 pC, singulär bis 100 pC.

Der Amplitudenmittelwert der Prüflingsart P3 beträgt  $U_{PD/inc/50} = 2,47$  kV bei einer Standardabweichung von s= 0,15 kV. Hierbei wurde eine relativ geringe Spannweite der Messungen festgestellt. Die minimale TE- Einsetzspannung betrug  $\hat{U}_{PD/inc} = 2,24$  kV, die maximale TE- Einsetzspannung  $\hat{U}_{PD/inc} = 2,62$  kV.

Die scheinbare Ladung  $Q_S$  nahm einen Wertebereich von 40 pC bis 150 pC ein.

Die größten Werte wurden für die Prüflingsart P4 ermittelt. Der Amplitudenmittelwert ergibt sich zu  $U_{PD/inc/50} = 5,01$  kV mit einer Standardabweichung von s= 0,53 kV. Minimal wurden  $\hat{U}_{PD/inc} = 4,2$  kV, maximal  $\hat{U}_{PD/inc} = 6,2$  kV gemessen.

Hierbei wurde scheinbare Ladungen  $Q_S$  im Bereich von 10 pC bis 100 pC gemessen, wobei teilweise auch deutlich stärkere Entladungen bis 500 pC auftraten.

Die oben angegebenen Messwerte zeigen deutlich die grosse Spannweite der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  der identisch gefertigten Stichproben einer Modellisolierungsart. Das gründet einerseits im statistischen Charakter der Gasentladung als physikalischer Prozess der Teilentladung.

Den wesentlichsten Anteil daran liefert allerdings die Prozessstreuung mit den Fertigungstoleranzen bei der mechanischen Bearbeitung der Modellisolierungen. Insbesondere das Einbringen der Fehlstelle in den Isolierstoff beeinflusst das Mikrofeld und somit die Durchschlagsbedingungen der Fehlstelle. Zusätzlich kann in Betracht gezogen werden, dass hochpolymeren Isolierstoffe aus einem nichtreproduzierbaren, teilkristallinen Aufbau mit amorphen Übergangsstrukturen bestehen. Diese Bereiche, sowie die Korngrenzen zwischen diesen Bereichen weisen meist unterschiedliche Dielektrizitätszahlen auf, was die Feldverteilung innerhalb der Modellisolierung bestimmt. Als weitere beeinflussende Parameter seien hier nur die Elektrodengeometrie, Mischungsverhältnis und Aushärtephase des Epoxydharzes genannt, welche nur im Rahmen gewisser Fertigungsgenauigkeiten reproduziert werden konnten.

## 4.3.2 Messergebnisse bei rechteckförmiger Pulsspannung

Für die Erfassung des Teilentladungseinsatzes bei Pulsspannungen wurde die im Kapitel "Versuchstechnik" vorgestellte Anlage verwendet. Für die Erzeugung der bipolaren Rechteckspannung wurde wie beschrieben eine zweite Gleichspannungsquelle verwendet. Für die monopolare Rechteckspannung kam diese weitere Gleichspannungsquelle nicht zum Einsatz.

Die Messungen wurden durchgeführt mit einer Anstiegszeit  $t_R \approx 950$  ns bei monopolarer Pulsspannung bzw.  $t_R \approx 1200$  ns bei bipolarer Pulsspannung bei einer Pulsfolgefrequenz  $f_W = 50$  Hz. Die Abbildung 4.35 zeigt den Wert des Spannungshubs  $\Delta U_{PD/inc}$ , also den Spitze-Spitze-Wert, bei dem Teilentladungseinsatz gemessen wurde für eine Stichprobenmenge n= 25 der Prüflingsart P1.



Abbildung 4.35: TE- Einsetzspannungshub  $\Delta U_{PD/inc}$  bei (1) Sinusspannung, (2) Bipolarer Rechteckspannung und (3) Monopolarer Rechteckspannung bei  $f_W = 50$  Hz,  $t_R \approx 1200$  ns (bipolar) bzw.  $t_R \approx 950$  ns (monopolar) und a = 0.5an der Prüflingsart P1

Bei sinusförmiger Spannungsbeanspruchung wurde ein Spannungshub-Mittelwert  $U_{PD/inc/50} = 7,64$  kV mit einer Standardabweichung von s= 1,23 kV ermittelt. Für den Teilentladungseinsatz bei pulsförmigen Belastungen wurden geringere Spannungshübe  $\Delta U_{PD/inc}$  gemessen. Hier ergab sich für bipolare und monopolare Rechteckspannung ein Mittelwert von  $U_{PD/inc/50} = 6,38$  kV bei Standardabweichungen von S= 0,93 kV bzw. s= 0,98 kV. Ein Vergleich der jeweiligen Mittelwerte ergibt ein Verhältnis von  $U_{Sin}/U_{Rect} = 1,21$ . Dieses Verhältnis kann jedoch nicht als fester Wert angesehen werden. Innerhalb der Stichprobe variierten die Verhältnisse von 1 bis 1,5. Weitere Untersuchungen an den anderen Prüflingsarten mit monopolarer Rechteckspannung bestätigten dieses Verhalten. So traten bei gleicher Anstiegszeit und Pulsfolgefrequenz Verhältnisse von 1,1 bis 1,8 auf. Ähnliche Verhältnisse wurden in [Kau93, Kau94] beim Vergleich von pulsförmigen Be-
Die Ursache wird dort in der Vergrösserung der raumladungsbedingten lokalen Feldstärke im Fehlstellenbereich für kurze Anstiegszeiten vermutet. Näheres dazu wird im Abschnitt 4.2.6 erläutert.

Ein weiterer Vergleichsparameter ist die scheinbare Ladung  $Q_S$ . Die ermittelten Werte lagen alle in der Grössenordnung der im Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Messergebnisse. Dieses Ergebnis bestätigt die Aussage in [Kur93], dass die Fehlstellengeometrie und das beteiligte Dielektrikum die maximale scheinbare Ladung einer Teilentladung bestimmen. Lediglich feststellbar war, dass die Beträge der scheinbare Ladung  $Q_S$  eher den Bereich der größeren Werte des angegeben Intervalls einnahmen.

#### 4.3.3 Interpretation der Ergebnisse

Es bestätigte sich das Ergebnis aus Abschnitt 4.2.3, dass der Teilentladungseinsatz unabhängig davon ist, ob eine bipolare oder monopolare Spannungsbeanspruchung vorliegt. Der Spannungshub  $\Delta U_{PD/inc}$  ist der entscheidende Parameter. Für die Erklärung dieses Phänomens wird auf den entsprechenden Abschnitt 4.2.3 verwiesen.

Des Weiteren ist ein signifikanter Unterschied in der Höhe der TE- Einsetzspannung  $U_{PD/inc}$  für Belastungen mit sinusförmiger bzw. pulsförmiger Spannung ersichtlich. Der Grund dieses Verhaltens ist der ungleiche heteropolare Aufladevorgang durch die stark divergenten Anstiegszeiten  $t_R$ , der bereits in Abschnitt 4.2.6 ausführlich betrachtet wurde.

## Kapitel 5

### Zusammenfassung und Ausblick

Die Teilentladungsmesstechnik hat sich in der Vergangenheit als geeignetes Verfahren herauskristallisiert, Baugruppen der elektrischen Isoliertechnik zerstörungsfrei zu untersuchen und aussagekräftig zu diagnostizieren. Nach DIN VDE 0434 werden zu prüfende Isolierungen hierbei mit sinusförmigen Wechselspannungen beaufschlagt.

Der zunehmende Einsatz von Leistungselektronik in der elektrischen Energietechnik führte jedoch zu grundsätzlich anders gearteten Spannungsbelastungen. Diese stellen nachweislich eine höhere elektrische Belastung für Isoliersysteme dar. Für den sicheren Betrieb von Betriebsmitteln mit pulsförmiger Spannungsbeanspruchung ist es notwendig, Teilentladungen unter Betriebsbedingungen zu detektieren. Somit ergab sich die Fragestellung, inwiefern die gewonnenen Erkenntnisse aus Teilentladungsuntersuchungen mit sinusförmigen Spannungen auf pulsförmige Belastungen übertragbar sind.

Die vorliegende Arbeit umfasst die theoretischen Betrachtungen und experimentellen Untersuchungen von Teilentladungen an Modellisolierungen bei typischen Spannungsformen der Leistungselektronik, den pulsförmigen Rechteckspannungen. Hierzu wurden verschiedene Parameter der Pulsspannung, wie Pulsfolgefrequenz oder Anstiegszeit variiert und deren Einfluss auf eine wichtige Grösse, die Teilentladungseinsetzspannung, herausgearbeitet.

Wesentliche Punkte waren dabei die Wahl geeigneter Messtechnik und das Erstellen von reproduzierbaren Isolieranordnungen. Den Ausgangspunkt stellt die Zusammenfassung der physikalischen Grundlagen der allgemeinen Gasentladung und insbesondere der Teilentladungen in Feststoffen dar.

# Aufbau eines Teilentladungsmesssystems für Pulsspannungsbelastungen

Experimentelle Grundvoraussetzung für eine aussagekräftige Untersuchung war eine Spannungsquelle, welche verschiedenartige Modellisolierungen zulässt. Im Gegensatz zu Arbeiten mit ähnlicher Thematik wurde kein Frequenzumrichter verwendet, um die pulsförmige Spannung zu erzeugen. Ein System aus Gleichspannungsquelle, Frequenzgenerator und Hochspannungsschalter stellte die Spannungsamplitude bereit und ermöglichte umfangreiche Variation in den Untersuchungen. Es kamen einzelne kommerzielle Komponenten zum Einsatz, was eine unproblematische Reproduzierbarkeit und Anwendbarkeit gestattet. Das System liefert eine Ausgangsspannung bis 10 kV bei Pulsfolgefrequenzen bis 10 kHz und variabler Pulsbreite. Prinzipiell ist eine Ansteuerung mit pulsweitenmodulierten Signalen ebenso möglich. Durch die begrenzte Leistung des Hochspannungsschalters ist die Verwendung ohne Einschränkungen jedoch nur für Isolieranordnungen mit Kapazitäten im pF- Bereich möglich. Für zukünftige Arbeiten wäre die Übertragbarkeit der gewonnen Ergebnisse auf eingesetzte Isoliersysteme zu untersuchen. Da in der Praxis verwandte Stromrichterverschienungen, Stator- bzw. Rotorwicklungen elektrischer Maschinen etc. meist grosse Kapazitäten und hohe Teilentladungseinsetzspannungen besitzen, ist eine grössere Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Pulsstromfähigkeit des Hochspannungsschalters notwendig. Somit wären auch für Kapazitäten im nF Bereich kleine Anstiegszeiten der Pulsspannung realisier-

Ein zentrales Thema dieser Arbeit war die Detektion von Teilentladungen bei pulsförmigen Spannungsbeanspruchungen. In Anlehnung an die Vorgaben nach DIN VDE 0434 für sinusförmige Wechselspannungen wurde eine geeignete Messanordnung für die Untersuchung an Modellisolierungen erstellt.

bar.

Wesentlicher Unterschied zur Detektion von Teilentladungen bei technischen Wechselspannungen besteht darin, dass die eigentliche Nutzinformation durch ein stärkeres Störspektrum überlagert wird. Diese Störungen werden durch grössere Anstiegsgeschwindigkeiten dU/dt der pulsförmigen Spannungsbeanspruchung hervorgerufen. Die dabei entstehenden Verschiebungsströme

 $i = C_P \cdot dU/dt$  beim Laden bzw. Entladen der Prüflingskapazität erreichen ein Vielfaches der Amplitude der Teilentladungsströme und erschweren die Detektion. Lösungsmöglichkeiten bieten hier analoge und digitale Filter, wobei in dieser Arbeit Ersterer zur Anwendung kam.

Um Nutz- und Sörsignal voneinander zu trennen wurde ein analoges Hochpassfilter 5. Ordnung mit Butterworth- Charakteristik eingesetzt. Es liefert eine gute Separation der beiden Signale, sodass der zeitliche Verlauf des TE-Signals mit guter Genauigkeit abgebildet werden konnte. Die digitalisierten Daten von Pulsspannung und TE- Signal aus einem Oszilloskop wurden mit einem PC ausgelesen und standen für weitere Auswertungen zur Verfügung. Vergleichsmessungen des eigenen Filtersystems bei sinusförmiger Spannungsbeanspruchung mit 50 Hz mit dem konventionellen System zeigte gleiche Empfindlichkeiten bei der Teilentladungsdetektion.

Zukünftig wäre eine Verbesserung der messtechnischen Seite anzustreben. Sowohl die Messanordnung als auch das Filtersystem ist für den Einsatz an Modellisolierungen mit kleinen Prüflingskapazitäten ausgelegt. Hier wäre eine universellere Applikation sinnvoll, die auch Messungen an Prüflingen mit grossen Kapazitäten (z.B. Verschienungen, Statorwicklungen) in beliebiger Schaltungstopologie, vorzugsweise unter Betriebsbedingungen, zulässt. Ein Ansatz hierzu wäre eine kapazitive Auskopplung des TE- Signals mit anschliessender Verarbeitung mittels digitale Filter, welche die periodischen Störungen des Ladeund Entladevorganges der Prüflinge besser filtern können.

Die Datenaufzeichnung und -auswertung nutzt, begrenzt durch die Leistungsfähigkeit der Oszilloskope, derzeit nur eine geringe Anzahl von Informationen. Der Ausbau zu einem leitungsfähigeren Online- System könnte den Zeitaufwand verringern und den Informationsgewinn erhöhen. Entsprechend leistungsfähige Analog- Digital- Wandler und digitale Signalverarbeitungshardware sind inzwischen im Handel erhältlich.

Einen wichtigen Punkt stellt dabei die Ermittlung der Vergleichsgrösse

"Scheinbare Ladung" dar, was eine direkte Korrelation mit den üblich ermittelten Werten aus den Teilentladungsmessungen bei sinusförmiger Wechselspannung zulässt.

Ein wichtiger Punkt der Arbeit stellte die Entwicklung und Herstellung reproduzierbarer Modellisolierungen dar, welche innere Teilentladungen im Bereich bis 10 kV bei pulsförmiger Spannungsbeanspruchung zeigen sollten.

Abweichend von bisherigen Arbeiten, die weitestgehend an Lackdrähten bzw. Kunststofffolien stattfanden, wurden vollständig umschlossene Fehlstellen in Isolierstoffen untersucht. Somit wurden mögliche Beeinflussungen des Gasentladungsprozesses in der Fehlstelle, wie Druck- und Temperaturausgleich mit der Umwelt, ausgeschlossen. Mit dem beschriebenen Verfahren gelingt es mit guter Stabilität und akzeptablen Abweichungen die TE- Einsetzspannungen zu reproduzieren. Die Gestaltung der 4 Typen der Modellisolierung sollte dabei möglichst realistische Fehlstellenmöglichkeiten wiedergeben.

Technologisch scheint der Verbesserung der Mass- und Fertigungsgenauigkeiten das grösste Potential innezuwohnen. Die Qualität der verwendeten Maschinen und Werkzeuge entspricht dem Stand der Technik und kann mit vertretbarem Aufwand nur in industriellen Fertigungen verbessert werden. Somit könnte beispielsweise die Positionierung und Oberflächengüte der Fehlstellen verbessert werden, welche derzeit manuell gefertigt sind.

Experimentell ergeben sich weitere Aspekte durch Variation der verwendeten Dielektrika und Fehlstellengeometrien. Verschiedenste Epoxydharze und Gasfüllungen mit variierenden Drücken könnten untersucht werden, um die gewonnenen Erkenntnisse zu hinterlegen. Gerade im Hinblick auf ständig verbesserte Herstellungsprozesse für physikalische Isolieranordnungen und die fortschreitende Miniaturisierung erscheint es sinnvoll, Mikrofehlstellen zu untersuchen. Mit dem beschriebenen Gesamtsystem sind umfangreiche Messreihen zu Teilentladungen bei Pulsspannungen mit verschiedensten Parametern realisiert worden. Untersucht wurde im Wesentlichen die Teilentladungseinsetzspannung unter Variation der Parameter

- 1. Gleichanteil
- 2. Pulsbreite
- 3. Pulsfolgefrequenz
- 4. Anstiegszeit der Pulsspannung.

Darüber hinaus ist der Einfluss von Impulsen auf die Teilentladungseinsetzspannung herausgearbeitet worden. Ziel war es, eventuelle Einflüsse dieser Parameter zu untersuchen, physikalisch zu erklären und in das Verhältnis zu Messungen bei sinusförmiger Spannung zu setzen.

#### Einfluss des Gleichanteils der Pulsspannung

Ein Einfluss durch Veränderung des Gleichanteils der Pulsspannung auf die TE- Einsetzspannung konnte nicht festgestellt werden. Dabei entsprach der Bereich der Gleichspannung (Variation von - 4 kV bis + 4 kV) der Amplitude der aufgesetzten Pulsspannung. Es bestätigte sich, dass der Spannungshub, also der Spitze-Spitze-Wert der Pulsspannung, den Teilentladungseinsatz bestimmt. Das zeigte sich in konstanten Mittelwerten der Messreihen jeder Prüflingsart, welche unabhängig von der Überlagerung der Pulsspannung mit einem Gleichanteil waren. Eine Erklärung für dieses Verhalten ist der Aufbau eines Raumladungsfeldes innerhalb der Fehlstelle, was für unterschiedliche äussere Spannungen nahezu identische Feldverläufe in der Fehlstelle hervorruft.

Daraus lässt sich ableiten, dass für die vorliegenden Untersuchungen von inneren Teilentladungen keine Notwendigkeit bestand, einen Gleichanteil der Pulsspannung zu überlagern. Der Gleichanteil veränderte den Teilentladungseinsatz nicht signifikant. Folglich wurden für alle Folgeversuche Pulsspannungen ohne Gleichanteil verwendet.

Dieses Ergebnis sollte durch weitere Messungen untermauert und der Grenzbereich zur Gleichspannungsteilentladung ermittelt werden. Bestätigt sich das Ergebnis, ist es zukünftig für einen Grossteil der Anwendungsfälle ausreichend, mit monopolaren Pulsspannungen zu untersuchen.

#### Einfluss der Pulsbreite der Pulsspannung

Die Veränderung der Pulsbreite im Bereich von  $10\mu s$  bis  $700\mu s$  zeigte einen signifikanten Einfluss auf die TE- Einsetzspannung. Je nach Modellisolierungstyp konnten um bis zu 20 % erhöhte TE- Einsetzspannungswerte bis in den Pulsbreitenbereich  $\approx 300\mu s$  gemessen werden. Für grössere Pulsbreiten sank die TE- Einsetzspannung auf konstante Werte. Daraus kann geschlossen werden, dass für die untersuchten Modellisolierungen die elektrische Festigkeit des Gasraums in der Fehlstelle bei Pulsen bis  $\approx 300\mu s$  wesentlich erhöht wurde.

Dieses Verhalten ist bisher von Isolieranordnungen bei transienter Beanspruchung mit Stossspannungen bekannt und bereits im Zeit-Flächen- Gesetz beschrieben worden. Jeder Beanspruchungsdauer kann eine Mindestamplitude zugewiesen werden, die notwendig ist eine Lawine aufzubauen und damit den Durchschlag des Gaskanals einzuleiten. Diese Spannungs- Zeit-Fläche betrug ca.  $F \approx 0, 3...0, 5kV \cdot \mu s$  und lag damit im Bereich üblicher Werte nach [Kin58]. Wird die Amplitude bei gleicher Beanspruchungsdauer weiter gesteigert, verkürzt sich der Zündverzug. Es ergeben sich Kennlinien, die den aus der Literatur bekannten Stosskennlinien entsprechen.

#### Einfluss der Pulsfolgefrequenz der Pulsspannung

Ähnlich deutliche Ergebnisse wie der Einfluss der Pulsbreite zeigten die Messungen zum Einfluss der Pulsfolgefrequenz bei konstanter Pulsbreite. Zunächst verlief die TE- Einsetzspannung konstant, um dann im Bereich von 2 kHz -4 kHz anzusteigen. Die Amplitude nahm dabei um ca. 20% zu. Ab dem angesprochenen Bereich ist die Pausendauer kürzer als die Pulsdauer der Pulsspannung. Die sich verkürzende Pausendauer bestimmt folglich ebenfalls den Teilentladungseinsatz. In [Kau94, Poh01] konnte dieser Anstieg nicht festgestellt werden, da vermutlich die Pulsfolgefrequenz zu gering gewählt worden ist.

Mit Hilfe des Raumladungsfeldes in der Fehlstelle können diese Messergebnisse erklärt werden. Für eine Pulspause sinkt die Spannung an der Fehlstelle und es verbleibt das Raumladungsfeld, welches bis dahin die äussere Spannung kompensiert hat. Ist das Raumladungsfeld ausreichend stark, kann die Durchschlagfeldstärke in Gegenrichtung erreicht und eine Gasentladung einleitet werden. Dazu muss ebenfalls das Spannungs- Zeit- Kriterium erfüllt sein, was für eine kurze Pausendauer eine grössere Amplitudenänderung zur Folge hat. Veränderte man mit der Pulsfolgefrequenz auch die Pulsbreite, sodass Pulsdauer und Pausendauer stets gleich gross waren, konnte kein Einfluss auf die TE- Einsetzspannung festgestellt werden. Sie verlief konstant über den gesamten untersuchten Frequenzbereich.

Die einzig sinnvolle Erklärung dieser Stetigkeit liefert der Ansatz der Erhöhung der Leitfähigkeit der Fehlstellengrenzen, da für kurze Pulsdauern die TE- Einsetzspannung steigen müsste. Die erhöhte Leitfähigkeit hat zur Folge, dass Oberflächenladungen schneller abfliessen und die Feldschwächung abnimmt. Hier besteht allerdings noch Bedarf an Untersuchungen, um eine hinreichend gesicherte Erklärung zu finden.

#### Einfluss der Anstiegszeit der Pulsspannung

Eine eindeutige Abhängigkeit der TE- Einsetzspannung von der Anstiegszeit ergab sich zunächst für Pulsfolgefrequenzen von 1 kHz bzw. 10 kHz nicht, da sich die gewählte Änderung der Anstiegszeit als zu gering erwies. Die Untersuchung für eine Pulsspannung mit 50 Hz bei Anstiegszeiten von 150ns....2ms zeigte einen Anstieg der TE- Einsetzspannung um ca. 20% auf. Letztendlich wurden Amplitudenwerte erreicht, die den Spitze- Spitze- Werten bei technischen Wechselspannungen entsprachen. Das lässt die Vermutung zu, dass nicht die Signalform, sondern die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit massgeblich den Teilentladungseinsatz bestimmt.

Diese unterschiedlich hohen Einsetzspannungen werden wahrscheinlich durch die Akkumulation von Ladungsträgern an den Grenzflächen der Fehlstelle erzielt. Dieser Vorgang ist eine Funktion der Zeit, sodass eine stärkere Feldschwächung und somit eine höhere Einsetzspannung für grössere Anstiegszeiten erzielt werden.

Grosse Anstiegszeiten tragen somit zur elektrischen Festigkeit des Gasraums der Fehlstelle bei. Äquivalente Ergebnisse zeigten sich in [Gue89, Kau94, Poh01].

Die Messungen mit Impulsen zeigten durch alle Messreihen gleiche Tendenzen. Für kurze Impulsbreiten ergaben sich ebenso höhere TE- Einsetzspannungen, wie die charakteristische Abflachung ab den entsprechenden Grenzpulsbreiten aus den Messungen für Pulsspannungen bei variablen Pulsbreiten.

Bedingt durch den weniger ausgeprägten Akkumulationsvorgang durch die fehlende dauerhafte Spannungsbeanspruchung der Fehlstelle im Vergleich zu Pulsspannungen konnte sich nur ein schwaches Feld aus Raumladungen ausbilden und das ursprüngliche Feld der Pulsspannung absenken. Die Messungen bestätigten diesen Ansatz, da für die TE- Einsetzspannungen geringere Werte ermittelt wurden, als für vergleichbare Pulsbreiten bei Pulsspannungsbelastung.

Ziel der vorliegenden Arbeit sollte der Vergleich und eine eventuelle Ubertragbarkeit der Ergebnisse von Untersuchungen mit technischen Wechselspannungen auf Untersuchungen mit Pulsspannungen sein. Die Ergebnisse der Messungen bei Variation verschiedenster Parameter der Pulsspannung deuten bereits darauf hin, dass ein direkter Transfer nicht möglich sein wird.

Das bestätigte sich durch den Vergleich der Spitze- Spitze- Werte bei sinusförmiger Wechselspannung und monopolarer bzw. bipolarer Pulsspannung mit 50 Hz. Die TE- Einsetzspannungen für sinusförmige Wechselspannungen waren im Durchschnitt um ca. 20% höher als die bei beiden Pulsspannungen. Das kann im Wesentlichen auf den signifikanten Unterschied in den Anstiegszeiten beider Spannungsbeanspruchungen zurückgeführt werden. Demzufolge bauen sich unterschiedlich starke Raumladungsfelder in den Fehlstellen auf. Diese Ergebnisse bestätigen die Untersuchungen in [Gue89, Kau93, Kau94, Wad03], welche allerdings mit Lackdrähten durchgeführt worden sind. Die eigenen Messungen zeigten, dass sich für jede Stichprobe einer Modellisolierung ein individuelles Verhältnis der TE- Einsetzspannungen von Puls- zu Sinusspannung einstellte. Somit ist eine direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse aus beiden Spannungsbeanspruchungen nicht gegeben, was eine Ermittlung der TE- Einsetzspannung für Betriebsmittel mit Pulsspannungsbelastung unter Betriebsbedingungen notwendig macht.

# Kapitel 6

## Verzeichnis der Formelzeichen

### Formelzeichen (Lateinische Buchstaben)

A	Fläche, bezogene Aufbaufläche	$m^2$
a	Tastgrad	
$b_e$	Beweglichkeit der Elektronen	$\frac{cm^2}{Ve}$
$C_{\nu}$	Konstante	13
D	Verschiebungsdichte	$\frac{As}{m^2}$
d	Durchmesser	m
E	Elektrische Feldstärke	$\frac{V}{m}$
$E_A$	Feldstärke zwischen Elektroden	$\frac{V}{m}$
$E_D$	Durchschlagfeldstärke	$\frac{V}{m}$
$E_G$	Elektrische Feldstärke des Grundfeldes / Laplace- Feld	$\frac{V}{m}$
$E_I$	Feldstärke in Fehlstelle	$\frac{V}{m}$
$E_L$	Elektrische Feldstärke des Raumladungsfeldes / Poisson- Feld	$\frac{V}{m}$
$E_Z$	Zünd- bzw. Einsetzfeldstärke	$\frac{V}{m}$
f	Frequenz	Hz
$f_W$	Pulsfolgefrequenz	Hz
F	Spannungs - Zeit - Fläche	Vs
G	Übertragungsfunktion	
h	Plancksches Wirkungsquantum	Js
$h_{Fehl}$	Fehlstellenhöhe	m
$I_{PD}$	Teilentladungstrom	A
J	Stromdichte	$\frac{A}{m^2}$
k	Geometriefaktor der Fehlstelle	
$k_B$	Bolzmann- Konstante	$\frac{J}{K}$
$K_{Diff}$	Diffusionskonstante	$\frac{m^2}{s}$
$K_G$	Durchschlagskriterium für Lawinendurchschlag	0
$K_{St}$	Durchschlagskriterium für Kanaldurchschlag	
$k_T$	Töplerkonstante	$\frac{Vs}{m}$
$m_e$	Elektronenmasse	$\ddot{kg}$
$m_{Ion}$	Ionenmasse	kg

### Formelzeichen (Lateinische Buchstaben)

$N_{cr}$	kritische Anzahl an Elektronen	
$N_e$	Elektronenanzahl	
$N_{e0}$	Startelektronenanzahl	
$N_{eSek}$	${ m Sekund} { m \ddot{a}relektronenanzahl}$	
$\dot{n}_0$	${\it Startelektronenbildungs}$ rate	$\frac{1}{a mm^3}$
$N_{+}$	Ionenanzahl	s·mm*
n	Anzahl	
p	Druck	bar
$P_{PD}$	TE- Wahrscheinlichkeit	
q	Ladung	As
$\overline{q}_e$	Elementarladung	As
$Q_{ein}$	Eingeschlossene Ladung	As
$Q_S$	Scheinbare Ladung	As
$r_{Fehl}$	Fehlstellenradius	m
$r_{Kugel}$	Kugelradius	m
$r_L$	Lawinenkopfradius	m
s	Elektrodenabstand, Schlagweite	m
$T_W$	Periodendauer	s
t	Zeit	s
$t_A$	Lawinenaufbauzeit	s
$t_D$	Zündverzug	s
$t_{EV}$	Entladeverzugszeit	s
$t_F$	Funkenaufbauzeit	s
$t_{Grenz}$	notwendige Pulsbreite zum Erfüllen des	s
	Spannungs- Zeit- Flächen- Kriteriums	
$t_P$	Pulsbreite	s
$t_R$	Anstiegszeit	s
$t_S$	Statistische Streuzeit	s
$t_0$	Verzug bis zum Erreichen der statischen Ansprechspannung	s

### Formelzeichen (Lateinische Buchstaben)

u	Relative Überspannung	
u(t)	Zeitliche Verlauf der Spannung U	V
$U_D$	Durchschlagspannung	V
$U_{Impuls}$	Impulsspannung	V
$U_M$	Messspannung	V
$U_{Offset}$	Gleichspannungsanteil der Pulsspannung	V
$U_{PD}$	${ m Teilentladungsspannung}$	V
$U_{PD/inc}$	${ m Teilentladung seinsetzspannung}$	V
$U_{PD/ext}$	${ m Teilentladung sauss etz spannung}$	V
$U_{Puls}$	Pulsspannung	V
$U_Z$	Zünd- bzw. Einsetzspannung	V
$U_0$	Statische Ansprechspannung	V
v	$\operatorname{Geschwindigkeit}$	$\frac{m}{s}$
$v_e$	Geschwindigkeit eines Elektrons	$\frac{\breve{m}}{s}$
$W_A$	1. Anregungsarbeit	$ {eV}$
$W_a$	${ m Elektronenaustritts} arbeit$	eV
$W_B$	Molekulare Bindungsenergie	eV
$W_E$	Energie einer Elektronenlawine	eV
$W_I$	1. Ionisationsarbeit	eV
$W_{PD}$	Energieumsatz während einer Teilentladung	eV
$W_{Ph}$	Photonenenergie	eV
$W_{UV}$	$\operatorname{Strahlungsenergie}$	eV
x	Abstand, Wegstrecke	m
$x_{cr}$	Kritische Wegstrecke	m

Formelzeichen	Griechische	Buchstaben)	)
		Ducinstant	/

$\alpha$	1. Townsendscher Stossionisierungskoeffizient	
$\alpha_{eff}$	Effektiver Ionisierungskoeffizient	
$\beta$ .	Feldänderungsfaktor infolge einer Teilentladung	
δ	Korrekturfaktor	
$\delta_{UV}$	Anregungskoeffizient	
$\epsilon_r$	Relative Dielektrizitätszahl	
$\epsilon_0$	Dielektrizitätszahl des freien Raumes	$\frac{As}{Vm}$
$\gamma$	2. Townsendsche Ionisationskoeffizient	VIII
$\gamma_S$	Winkel	
$\eta$	Anlagerungskoeffizient	
$\eta_{Ph}$	Photoionisationskoeffizient	
$\eta_S$	Schwaigerscher Ausnutzungskoeffizient	
$\lambda$	Wellenlänge	m
$\lambda_e$	Mittlere freie Weglänge eines Elektrons	m
$\mu$	Mittelwert	nach Anw.
$\vartheta$	Temperatur	K
ho	spezifischer Widerstand	$\Omega m$
$\sigma$	$\operatorname{Standardabweichung}$	nach Anw.
$\sigma$	Oberflächenladungsdichte	$\frac{As}{m^2}$
$ au_{A/PD}$	Anstiegszeitkonstante des TE- Signals	s
$ au_M$	${ m Messkreiszeitkonstante}$	s
$ au_{\sigma}$	Zeitkonstante des Akkumulationsvorgangs	S
ξ	Stossfaktor	

## Kapitel 7

### Literaturverzeichnis

[Abr72] M. Abramowitz, I. Stegun; Handbook of Mathematical Functions Dover Publications, 1972

[Ari00] W.G. Ariastina, T.R. Blackburn;
Distribution of Partial Discharges in Oil- Impregnated
Insulation
Australasian Universities Power Engineering Conference AUPEC, 2000

[Bar87] R. Bartnikas;
A Commentary on Partial Discharge Measurement and Detection
IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 22, 1987

[Bey86] M. Beyer, W.Boeck, K. Möller, W. Zaengl; Hochspannungstechnik Springer Verlag Berlin, 1986

[Bla91] G. Blaise, C. Le Gressus;
Charging and flashover induced by surface polarization relaxation process
Journal of Applied Physics 69, 1991

[Ble00] H.J.M. Blennow, M.L-A. Sjoberg, M.A.S. Leijon, S.M. Gubanski; Electric Field Reduction Due to Charge Accumulation in a Dielectric-Covered Electrode System IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 7 No. 3, 2000

[Bro98] T. Brosche; Erweitertes Teilentladungsmeßverfahren durch Erfassung neuer Impulsparameter Dissertation, Shaker Verlag, 1998 [Bro99] T. Brosche, W. Hiller, E. Fauser, W. Pfeiffer;
Novel Characterization of PD Signals by Real- Time
Measurement of Pulse Parameters
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1999

[Bru91] R.J. Van Brunt;
Stochastic Properties of partial- discharge Phenomena
IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 26 No. 5, 1991

[Bru94] R.J. Van Brunt;
Physics and chemistry of partial discharge and corona- Recent advances and future challenges
IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 1 No. 5, 1994

[Cam00] S. Campbell, G.Stone;

Examples of Stator Winding Partial Discharge due to Inverter Drives

IEEE International Symposium Electrical Insulation, 2000

[Car90] G. Carrara, W. Hauschild; Statistical evaluation of dielectric test results Electra Nr. 133, 1990

[Cav05] A. Cavallini, F. Ciani, G.C. Montanari; **The Effect of Space Charge on Phenomenology of Partial Discharges in Insulation Cavaties** Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena

Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2005

[Caz96] J. Cazaux;
 The Electric Image Effects at Dielectric Surfaces
 IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 3 No. 1, 1996

[Cen00] L. Centurioni, G. Coletti, F. Gustavino;

A Study About the Influence of the Rise- Time of Quasi- Square Voltages on the Aging by Partial Discharges of aPolymeric Film IEEE International Symposium Electrical Insulation, 2000

[Cha62] A. Chapiro; Radiation Chemistry of Polymeric Systems Interscience Publishers, 1962

[Cos39] H. Costa;
Über die Nachlieferungselektronen durch Photoeffekt in einer unselbständigen Wasserstoffentladung
Zeitschrift für Physik Band 113, 1939

[Chr89] G.C. Chrichton, P.W. Karlsson, A. Pedersen; **Partial Discharges in Ellipsoidal and Spheroidal Voids** IEEE Transaction on Electrical Insulation, Vol. 24, 1989

[Das90] D.K. Das- Grupta;

**Decay of Electrical Charges on Organic Synthetic Polymer Surfaces** IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 25 No. 3, 1990

[Dev84] J.C. Devins; **The Physics of Partial Discharges in Solid Dielectrics** IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 19 No. 5, 1984

[Eli91] B. Eliasson, U. Kogelschatz;Modeling and Applications of Silent Discharge PlasmasIEEE Transaction on Plasma Science Vol. 19 No. 2, 1991

[Fab01] D. Fabiani, G.C. Montanari, A. Contin;

Aging Acceleration of Insulating Materials for Electrical Machine Windings supplied by PWM in the Presence and in the Absence of Partial Discharges

IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 2001

[Fan96] Z. Fang, R.A. Fouracre, O. Farish;
Investigations of Surface Charging of DC Insulator Spacers
IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1996

[Fic03] T. Ficker; Electron Avalanches I-Statistics of Partial Microdischarges in Their Pre-streamer Stage

IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulations Vol. 10 No. 4, 2003

[Fou93] N. Foulon-Belkacemi, M. Goldman, A. Goldman, H. Dejean, J. Amouroux;

The mechanism of degradation of polymers under corona streamers: relative humidity influence

International Conference on Partial Discharge, 1993

[Fro95] U. Fromm;
Interpretation of Partial Discharges at dc Voltages
IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulations Vol. 2 No. 5, 1995

[Fro64] L. Frommhold;

Über verzögerte Elektronen in Elektronenlawinen, insbesondere in Sauerstoff und Luft, durch Bildung und Zerfall negativer Ionen Fortschritt der Physik Band 12, 1964 [Fuj89] H. Fujinami, T. Takuma, M. Yashima, T. Kawoto;
Mechanism and Effect of DC Charge Accumulation on SF6 Gas Insulated Spacers
IEEE Transactions on Power Delivery Vol.4 No. 3, 1989

[Gem32] A. Gemant, W. von Philippoff; **Die Funkenstrecke mit Vorkondensator** Zeitschrift für technische Physik Vol. 13, 1932

[Gän53] B. Gänger; **Der elektrische Durchschlag von Gasen** Springer- Verlag Berlin, 1953

[Gol95] M. Goldman, A. Goldman, J. Gatellet;
Physical and chemical aspects of partial discharges and their effects on materials
IEE Proceedings- Science, Measurement and Technology, Volume 142, 1995

[Göt92] S. Göttlich, G. Krause, K. Möller, R. Neubert, R. Pietsch; **Dielektrisches Alterungsmodell hochpolymerer Isolierstoffe** ETG- Fachbericht 40,VDE- Verlag, 1992

[Gue89] A. Guerra;

Langzeitverhalten der Windungsisolierung von Niederspannungs- Asynchronmaschinen bei komplexer thermischer und elektrischer Belastung mit Impulsspannung Dissertation TU Dresden, 1989

[Gut95] F. Gutfleisch, L. Niemeyer; Measurement and Simulation of PD in Epoxy Voids IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 2 No. 5, 1995

[Hal54] H.C. Hall, R.M. Russek;
Discharge Inception and Extinction in Dielectric Voids
IEE Proceedings 101 (Pt. II- Measurement Section), 1953

[Har02] P. Hartherz;
Anwendung der Teilladungsmeßtechnik zur Fehleranalyse in festen Isolierungen unter periodischer
Impulsspannungsbelastung
Dissertation, Shaker Verlag, 2002

[Hau84] W. Hauschild, W. Mosch; Statistik für Elektrotechniker VEB Verlag Technik Berlin, 1984 [Hod91] C. Hudon, R. Bartnikas, M.R. Wertheimer;

Analysis of Degradation Products on Epoxy Surfaces Subjected to Pulse and Glow- type Discharge

IEEE Annual Report- Conference on Electrical Insulation and Dielectrics Phenomena, 1991

[Hod93] C. Hudon, R. Bartnikas, M.R. Wertheimer;
Spark to glow Discharge Transition Due to Increase Surface Conductivity on Epoxy Resin Specimens
IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 28, 1993

[Hoo97] M. Hoof; Impulsfolgen- Analyse: Ein neues Verfahren der Teilentladungsdiagnostik Dissertation, Universität Siegen, 1997

[Hun90] R. Hund, W. Pfeiffer, H. Reinhard, F. Scheurer;
Partial Discharge Testing of Components for Low- Voltage Equipment at High Frequencies
Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1990

[Hun93] R. Hund, W. Pfeiffer; Insulations of Low- Voltage Equipment at High Frequencies Conference Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1993

[Ize85] N. Izeki;

A Proposal on Mechanism of Partial Discharges Detoriation of Organic Insulating Materials ETG- Fachberichte 16, VDE- Verlag, 1985

[Joh70] B. John; Einführung in die Technische Statistik Deutsche Gesellschaft für Qualität (ASQ) beim AWF e.V., 1970

[Kär76] S. Kärkkäinen; Internal Partial Discharges - Pulse Distributions, Physical Mechanisms and Effects on Insulations Dissertation TU Helsinki, 1976

[Kah89] M. Kahle; Elektrische Isoliertechnik Springer Verlag, 1989 [Kau93] M. Kaufhold, G. Börner, M. Eberhardt; Endurance of Winding Insulations of Induction Machines allying frequency inverters 8. International Symposium on High Voltage Engineering, 1993

[Kau94] M. Kaufhold; Elektrisches Verhalten der Windungsisolierung von Niederspannungsmaschinen bei Speisung durch Pulsumrichter Dissertation TU Dresden, 1994

[Kin58] D. Kind; Die Aufbaufläche bei Stoßbeanspruchungen technischer Elektrodenanordnungen in Luft Dissertation, TH München, 1958

[Kön81] D. Königstein; Ladungsverteilung auf Isolierstoff- Oberflächen bei elektrostatischer Aufladung in Luft Dissertation, Hochschule der Bundeswehr Hamburg, 1981

[Kog02] U. Kogelschatz; Filamentary, Patterned and Diffuse Barrier Discharges IEEE Transactions on Plasma Science Vol. 30 No. 4, 2002

[Kol54] R. Kollath; Sekundärelektronen- Emission fester Körper bei Bestrahlung mit Elektronen

Handbuch der Physik Bd. 21, Springer Verlag, 1954

[Kor98] R. Kories, H. Schmidt- Walter; Taschenbuch der Elektrotechnik Verlag Harri Deutsch, 1998

[Kra75] H.G. Kranz; Grundsätzliche Untersuchungen des Teilentladungsverhaltens von hochpolymeren Isolierstoffen im Bereich der Einsetz- Wechselspannung Dissertation RWTH Aachen, 1975

[Kur92a] M. Kurrat; **Energy Considerations for Partial Discharges in Voids** ETEP Vol. 2, No. 1, 1992

[Kur92b] M. Kurrat, A. Schnettler;

A New Computer- Aided Measuring System For Fundamental PD-Studies

Proceedings of the 4. th International Conference on Conductors and Breakdown on Solid Dielectrics, 1992

[Kur93] M. Kurrat;

Modellierung und Messung von Teilentladungen in Hohlräumen zur Bestimmung schädigungsrelevanter Energien

Dissertation, Universität Dortmund, 1993

[Küc96] A. Küchler; **Hochspannungstechnik** VDI- Verlag, 1996

[Küp73] K. Küpfmüller; Einführung in die theoretische Elektrotechnik Springer Verlag, 1973

[Leb98] T. Lebey;
A Theoretical Approach of Partial Discharges under Square Voltage Wave Forms
IEEE International Symposium on Electrical Insulations, 1998

[Leh04] G. Lehner; Elektromagnetische Feldtheorie Springer Verlag, 2004

[Löb65] L.B. Löb;Electrical Coronas- Their Basic Physical Mechanism University of California Press, 1965

[Mas78] J.H. Mason; Discharges IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 24 No. 4, 1978

[May76] C.J. Mayoux; Partial- Discharge Phenomena and the Effect of their Constituents on Polyethylene IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 11 No. 4, 1976

[Mee40] J.M. Meek; A Theory of Spark Discharge Physical Review 57, 1940 [Mee78] J.M. Meek, J.D. Craggs; Electrical Breakdown of Gases John Wiley & Sons, 1978

[Mel97] M. Melfi, J. Sung, S. Bell, G. Skibinski;
Effect of Surge Voltage Risetime on the Insulation of Low Voltage Machines fed by PWM Converters
Industry Applications Conference, 1997

[Mes02] D. Meschede; Gerthsen Physik Springer Verlag, 2002

[Mie72] G. Mierdel; Elektrophysik Dr. Alfred Hüthig Verkag, 1972

[Mor93] P.H.F. Morshuis; Partial Discharge Mechanisms PhD- Thesis, Delft University of Technology, 1993

[Mül73] H.P. Müller, P. Neumann, R. Storm; **Tafeln der mathematischen Statistik** VEB Fachbuchverlag, 1973

[Mül03] K. Müller; Entwicklung und Anwendung eines Messsystemes zur Erfassung von Teilentladungen bei an Frequenzumrichtern betriebenen elektrischen Maschinen Dissertation Universität Duisburg- Essen, 2003

[Müh99] P. Mühlbeyer; Untersuchungen zur elektrostatischen Trennbarkeit von Kunststoffen Dissertation Universität Stuttgart, 1999

[Mül00] K. Müller, R. Busch, S. Hilfert;
An Approach for Measuring Partial Discharges in PWM Inerter Driven Induction Machines
IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 2000

[Nem03] E. Nemeth; Triboelektrische Aufladung von Kunststoffen Dissertation TU Bergakademie Freiberg, 2003 [Nev96] A. Neves, H. Martins; Surface Charging and Charge Decay in Solid Dielectrics IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 1996

[Nie93] L. Niemeyer;The physics of partial dischargesInternational Conference on Partial Discharge, 1993

[Nie95] L. Niemeyer;
A Generalized Approach to partial Discharge Modeling
IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 2 No. 5, 1995

[Nov95] J.P. Novak, R. Bartnikas; Ionisation and Excitation Behavior in a Microcavity IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 2 No. 5, 1995

[Nov00] J.P. Novak, R. Bartnikas;

Effect of Dielectric Surfaces on the Nature of Partial Discharges IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 7 No. 1, 2000

[Ped89] A. Pedersen;

On the electrodynamics of partial discharges in voids in solid dielectrics

Proceedings of the 3rd International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics, 1989

[Ped91] A. Pedersen, G.C. Crichton, I.W. McAllister;
The Theory and Measurement of Partial Discharge Transients
IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 26 No. 3, 1991

[Ped95a] A. Pedersen, G.C. Crichton, I.W. McAllister;Partial discharge detection: theroretical and practical aspectsIEE Proceedings- Science, Measurement and Technology, Volume 142, 1995

[Ped95b] A. Pedersen, G.C. Crichton, I.W. McAllister;The Functional Relation between Partial Discharges and Induced Charge

IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. 2 No. 4, 1995

[Pfe91] W. Pfeiffer;High- frequency Voltage Stress of InsulationIEEE Transactions on Electrical Insulation, 1991

[Pfe99] W. Pfeiffer, M. Paede;

About the Influence of the Frequency on Partial Discharge Characteristics of Enamelled Wires

Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing & Coil Winding Conference, 1999

[Ple94] R. Plessow, W. Pfeiffer; Influence of the Frequency on the Partial Discharge Inception Voltage Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 1994

[Poh01] F. Pohlmann;

Isoliersysteme für Drehstrom- Niederspannungsmotoren, die von Pulsfrequenzumrichtern angesteuert werden Dissertation Universität Essen, 2001

[Pri69] H. Prinz; Hochspannungsfelder R. Oldenbourg Verlag München, 1969

[Rät64] H. Räther; Electron Avalanches and Breakdown in Gases Butherworths, 1964

[Sac78] L. Sachs; Angewandte Statistik Springer Verlag, 1978

[Sch85] W. Schmidt, T. Hibma, P.Pfluger;
Zur elektrischen Festigkeit und Alterung von Epoxid- Isoliermaterialien
ETG- Fachberichte 16, VDE- Verlag, 1985

[Schm89] P. Schmiegel;

Zum Einfluss von Oberflächenladungen auf die Teilentladungszündung an Isolierstoffgrenzflächen in Luft bei Gleichspannungsbelastung

Dissertation, Technische Universität Dresden, 1989

[Schw81] A.J. Schwab; Hochspannungsmesstechnik Springer - Verlag, 1981 [Schw40] W. Schwieker; Über die ultraviolette Strahlung einer unselbständigen Gasentladung

Zeitschrift für Physik Band 116, 1940

[Sjö00] M.L.-A. Sjöberg, H.J.M. Blennow, S.M. Gubanski, M.A.S. Leijon; On discharge phenomena in a covered electrode system in air Electrical Insulations, 2000

[Sjö01] M.L.-A. Sjöberg, C. Rein, S.M. Gubanski, M.A.S. Leijon; Surface charge accumulation in a dielectric-covered electrode system in air Electrical Insulating Materials, 2001

[Sti90] K. Stimper;Isolationskoordination in NiederspannungsanlagenVDE Verlag, 1990

[Sto92] G. Stone, H. Sedding, N. Fujimoto, J. Braun; Practical Implementation of Ultrawideband Partial Discharge Detectors IEEE Transactions on Electrical Insulation, 1992

[Sto97] G. Stone, S. Campbell;

Development of an On- Line Monitor to measure Motor Voltage Surges

Electrical Insulation, Manufacturing & Coil Winding Conference, 1997

[Sto99a] G. Stone, S. Campbell, H. Sedding;
Adjustable Speed Drive Surges: How they affect Motor Stator Windings
International Conference Electric Machines and Drives, 1999

[Sto99b] G. Stone, S. Campbell, M. Susnik;
New Tools to determine the Vulnerability of Stator
Windings to Voltage Surges from IFDs
Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing & Coil Winding
Conference, 1999

[Sto00] G. Stone;Importance of Bandwidth in PD Measurement of Operating Motors and GeneratorsIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2000 [Tei67] T. Teich;Emission gasionisierender Strahlung aus ElektronenlawinenZeitschrift für Physik Band 199, 1967

[Tow10] J.S. Townsend; **The Theory of Ionization of Gases by Collision** Constable & Co. Ltd. London, 1910

[Wad03] K. Wada, T. Tsuji, H. Muto:

Partial Discharge Inception Voltage for two Insulating Materials (PVC and PE) under Inverter Surge Voltage

7th International Conference: Properties and Applications of Dielectric Materials, 2003

[Win03] A. Winter;

Elektrische Ladungen auf Isolierstoffoberflächen und deren Wirkung auf die Durchschlagspannung von Elektrodenanordnungen

Dissertation TU Dresden, 2003

[Wer00] P. Werle, K. Hackemack, E. Gockenbach, H. Borsi; The Breakdown Behavior of Impulse Stressed Polyethylene in Dependence on the Parameters Characterizing Lightning Impulses

IEEE International Symposium Electrical Insulation, 2000

[Yah98] K.B. Yahia; Experimentelle und theoretische Untersuchungen zu Durchschlagsspannungen Diplomarbeit Universität Karlsruhe, 1998